PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-331936

(43) Date of publication of application: 30.11.2001

(51)Int.Cl.

7/0045 G11B

5/26 B41M

G11B 7/24

(21)Application number: 2000-139953

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEMICALS CORP

(22)Date of filing:

12.05.2000

(72)Inventor: NOBUKUNI NATSUKO

HORIE MICHIKAZU

(30)Priority

Priority number: 11138067

Priority date: 19.05.1999

Priority country: JP

2000076514

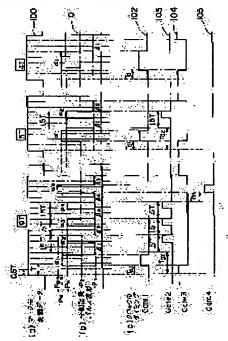
17.03.2000

(54) OPTICAL RECORDING METHOD AND OPTICAL RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical recording method using the pulse dividing method such that the satisfied recording of the mark length modulation is performable.

SOLUTION: In the case the mark length modulated information is recorded on a recording medium by the plural recording mark lengths, (i) the time-wise length nT of the recording mark is divided in order of $\eta 1T$, $\alpha 1T$, β 1T, α 2T, β 2T,..., α iT, β iT,..., α mT, β mT, η 2T, and the arrangement is made so that the irradiation of the recording light having the recording power Pwi is made thereon in the time of βiT (1≤i≤m), and the irradiation of the recording light having the bias power Pbi such as Pbi<Pwi and Pbi<Pwi+1 is made in the time of βiT (1≤i≤ m), then (ii) in accordance with n of the time-wise length nT of the recording mark, m, αi, βi, η1, η2, Pwi, Pbi are made variable, and for the time-wise length of at least one recording mark, the above pulse divided number m is settled ≥2, and also expression n/m≥1.25 is satisfied for the time-wise lengths of all recording marks.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.02.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3899779

[Date of registration]

12.01.2007

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-331936 (P2001-331936A)

(43)公開日 平成13年11月30日(2001.11.30)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		5	f-73-ト*(参考)	
G11B	7/0045		G11B	7/0045	Α	2H111	
B41M	5/26			7/24	511 '	5 D O 2 9	
G11B	7/24	5 1 1	B 4 1 M	5/26	х	5 D O 9 O	

審査請求 未請求 請求項の数32 OL (全 39 頁)

(21)出廢番号	特顧2000-139953(P2000-139953)	(71)出顧人	000005968
(00) (LIES 17	74-41077 F 1310 I3 (0000 F 10)		三菱化学株式会社
(22)出顧日	平成12年5月12日(2000.5.12)	(70) 50 HH 46	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
		(72)発明者	信國 奈津子
(31)優先権主張番号	特願平11-138067		神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地
(32)優先日	平成11年5月19日(1999.5.19)		三菱化学株式会社横浜総合研究所内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	堀江 通和
(31)優先権主張番号	特願2000-76514(P2000-76514)		神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地
(32)優先日	平成12年3月17日(2000.3.17)		三菱化学株式会社横浜総合研究所内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(74)代理人	100103997
			弁理士 長谷川 曉司
			最終頁に続く
		1	DUTE STILL TO

(54) 【発明の名称】 光記録方法及び光記録媒体

(57)【要約】

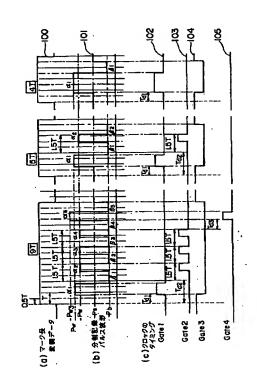
(修正有)

【課題】 良好なマーク長変調記録が行えるようなパルス分割法を用いた光記録方法を提供する。

【解決手段】 記録媒体にマーク長変調された情報を複数の記録マーク長により記録するにあたり

(i) 記録マークの時間的長さnTを、

 η_1 T、 α_1 T、 β_1 T、 α_2 T、 β_2 T、 \cdots 、 α_n T、 β_n T、 η_2 T の順に分割し、 α_i T ($1 \le i \le m$) の時間内においては記録パワーP w_i の記録光を照射し、 β_i T ($1 \le i \le m$) の時間内においては、P b_i < P w_i かつP b_i < P w_i かつP b_i < P w_i かつP b_i るがイアスパワーP b_i の記録光を照射するものとし、(i i) 上記記録マークの時間的長されてのれに応じてm、 α_i 、 β_i 、 η_1 、 η_2 、P w_i 、P b_i を可変とし、少なくとも一つの記録マークの時間的長さについては上記パルス分割数mを 2 以上とし、かつ、全ての記録マークの時間的長さについて $n/m \ge 1$ 、2 5 5 を満たすようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 記録媒体に光を照射することによってマーク長変調された情報を複数の記録マーク長により記録するにあたり、一つの記録マークの時間的な長さをnTとしたとき(Tは基準クロック周期であって25ns以下である。nは2以上の自然数である。)、記録マークの時間的長さnTを、

【数1】

 η_i T、 α_i T、 β_i T、 α_2 T、 β_2 T、 \cdots 、 α_i T、 β_i T、 \cdots 、 α_n T、 β_n T、 η_2 T (mはパルス分割数である。 Σ_i (α_i + β_i) + η_1 + η_2 = η である。 α_i ($1 \le i \le m$) は0より大きい実数であり、 β_i ($1 \le i \le m-1$) は0より大きい実数であり、 β_n は0以上の実数である。 η_1 及び η_2 は それぞれ-2以上2以下の実数である。) の順に分割し

 α : T ($1 \le i \le m$) の時間内においては記録パワーP w: の記録光を照射し、

 β ; T (1 \leq i \leq m - 1) の時間内においては、P b; < P w; かつP b; < P w; なるバイアスパワーP b 20; の記録光を照射し、

少なくとも一つの記録マークの時間的長さについては上記パルス分割数mを2以上とし、かつ、全ての記録マークの時間的長さについてn/m≥1.25を満たすことを特徴とする光記録方法。

【請求項2】 β_i (1 \leq i \leq m - 1) は0. 5 \sim 2. 5 である請求項1 に記載の光記録方法。

【請求項3】 全ての記録マークの時間的長さについて、 α_i T $(1 \le i \le m)$ の平均値が3ナノ秒以上で、かつ β_i T $(1 \le i \le m-1)$ の平均値が3ナノ秒以上 30 である請求項1または2に記載の光記録方法。

【請求項4】 全ての記録マークの時間的長さについて、それぞれのiに対して α , T \geq 3ナノ秒($1\leq$ i \leq m)で、かつ β , T \geq 3ナノ秒($1\leq$ i \leq m−1)である請求項1乃至3のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項5】 全ての記録マークの時間的長さについて、n/m≥1.5を満たす請求項1乃至4のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項6】 $\alpha_i + \beta_i$ (2 \leq i \leq m - 1) あるいは、 $\beta_{i-1} + \alpha_i$ (2 \leq i \leq m - 1) が、1.5、2、あるい 40 は2.5のいずれかの値をとる請求項1乃至5のいずれか1つに記載の光記録方法。

【請求項7】 nの異なる少なくとも2つの記録マークについて、同一のパルス分割数mを用い、前記少なくとも2つの記録マークにおいて、 α_i ($1 \le i \le m$)、 β_i ($1 \le i \le m-1$)、 η_i 、 η_2 、 Pw_i ($1 \le i \le m$) 及びPb_i ($1 \le i \le m-1$) の少なくとも1つが相互に異なる請求項1乃至6のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項8】 マーク長がnT=2LT(ただし、Lは 50

2以上の整数)で表される場合、マークを分割数m=L 個の区間に分割し、記録パルス区間 α : T及びオフパルス区間 β : Tにおける α : 及び β : (これらはLの値に応じて変化し得る)を下記のように定め、

【数2】 $\alpha_1 + \beta_1 = 2 + \delta_1$

 $\alpha_i + \beta_i = 2$ $(2 \le i \le m-1)$

 $\alpha_0 + \beta_0 = 2 + \delta_2$

(ただし、 δ_1 及び δ_2 は、それぞれ順に、 $-0.5 \le \delta_1 \le 0.5$ 、及び $-1 \le \delta_2 \le 1$ を満足する実数である。 10 また、L=2の場合には、 α_1 、 β_1 、 α_2 及び β_2 のみが存在するものとする。)

マーク長が n T = (2L+1) T で表される場合、マークを分割数m = L 個の区間に分割し、記録パルス区間 α , α : α , α : α

【数3】 α_1 ' + β_1 ' = 2. 5 + δ_1 ' α_i ' + β_i ' = 2 (2 ≤ i ≤ m - 1) α_n ' + β_n ' = 2. 5 + δ_2 '

0 (ただし、 δ_1 '及び δ_2 'は、それぞれ順に、-0.5 $\leq \delta_1$ ' ≤ 0.5 、及び $-1 \leq \delta_2$ ' ≤ 1 を満足する実数 である。また、L=2 の場合には、 α_1 '、 β_1 '、 α_* '及び β_* 'のみが存在するものとする。) 且つ、 α_1 、 β_1 、 α_* 、 β_* 、 α_1 '、 α_* '、 α_* "、 α_* " 、 α_* "

【数4】

 $\alpha_1 + \beta_1 + \alpha_2 + \beta_2 + \Delta = \alpha_1' + \beta_1' + \alpha_2' + \beta_2'$ (CCT, $\Delta = 0$. $8 \sim 1$. 2 Tbd)

【請求項9】 α_1 、 β_1 、 α_1 '及び β_1 'が下記式を満足する請求項8に記載の光記録方法。

【数5】 $\alpha_1 + \beta_1 + \Delta_1 = \alpha_1' + \beta_1'$

(ただし、 $\Delta_1 = 0$. 4~0. 6)

【請求項10】 マーク長がnT=2LT(ただし、Lは2以上の整数)で表される場合、マークを分割数m=L個の区間に分割し、記録パルス区間 α_i T及びオフパルス区間 β_i Tにおける α_i 及び β_i (これらはLの値に応じて変化し得る)を下記のように定め、

【数6】 $T_{d1} + \alpha_1 = 2 + \varepsilon_1$

 $\beta_{i-1} + \alpha_i = 2$ $(2 \le i \le m)$

一方、マーク長がnT=(2L+1) Tで表される場合、マークを分割数m=L個に分割し、記録パルス区間 α ', T及びオフパルス区間 β ', Tにおける α ', 及び β ', (これらはLの値に応じて変化し得る)を下記のように定め、

【数7】 T_{41} ' $+ \alpha_1$ ' $= 2 + \epsilon_1$ '

 $\beta_1' + \alpha_2' = 2.5 + \varepsilon_2'$

 β_{i-1} ' $+\alpha_i$ ' = 2 (3 \leq i \leq m-1)

 $\beta_{\bullet 1}$ ' $+\alpha_{\bullet}$ ' = 2. $5+\epsilon_{3}$ '

(ただし、L=2の場合には、 β_1 ' $+\alpha_2$ ' =2. 5+

(3)

40

 ϵ_2 '、あるいは、 β_1 ' + α_2 ' = 3 + ϵ_2 ' とする。また、 T_{al} 、 T_{al} 'は - 2以上2以下なるしによらないほぼ一定の実数値とする。さらに、 ϵ_1 、 ϵ_1 '、 ϵ_2 '、 ϵ_3 'は - 1以上1以下の実数とする。)かつ、 β_1 、 α_2 、 β_{el} 、 α_{el} 、 β_{el} 。

3

【数8】 $\beta_1 + \alpha_2 + \beta_{=1} + \alpha_1 + \Delta_2 = \beta_1' + \alpha_2' + \beta_{=1}' + \alpha_1'$

 $(22 \text{ Ce}, \Delta_2 = 0.8 \sim 1.2 \text{ ess } 3.$

請求項7に記載の光記録方法。

【請求項11】 3以上のLに対して、 β_1 '= β_1 +約 0.5、 $\beta_{\bullet 1}$ '= $\beta_{\bullet 1}$ +約 0.5、であり、 α_1 = 0.8 α_1 ' \sim 1.2 α_1 '、 α_{\bullet} =0.8 α_{\bullet} ' \sim 1.2 α_{\bullet} "、 β_{\bullet} =0.8 β_{\bullet} " \sim 1.2 β_{\bullet} " とする請求項10に記載の光記録方法。

【請求項12】 マーク長nT=2T又は3Tのマークの記録に際して、m=1個の区間に分割する請求項8乃至11のいずれか1つに記載の光記録方法。

【請求項13】 Lが3以上の場合に、 $2 \le i \le m-1$ なるiに対して、 $\alpha_i = \alpha_c$ で一定とし、かつ、 $\alpha_i' = 20$ α_i' で一定とする請求項8乃至11のいずれか1つに 記載の光記録方法。

【請求項14】 Lが3以上の場合に、αc及びαc'がLによらず一定である請求項13に記載の光記録方法。

【請求項15】 しが3以上の場合に、 $\alpha c = \alpha c$ 'とする請求項13又は14に記載の光記録方法。

【請求項16】 Lが3以上の場合に、 T_{ai} , T_{ai} , α_{1} 、 α_{1} 、 β_{1} 、及び β_{1} , がそれぞれ一定の値をとる請求項8乃至15のいずれか1つに記載の光記録方法。 【請求項17】 Lが3以上の場合に、 α_{\bullet} 、 α_{\bullet} 、 β_{\bullet} 、及び β_{\bullet} 、がそれぞれ一定の値をとる請求項8乃至は15のいずれか一つに記載の光記録方法。

【請求項18】 周期Tの第1の基準クロック1と周期Tで第1の基準クロックに対して0.5 Tだけずれた周期Tの第2の基準クロック2とを用いて、基準クロック1を分周して得られる周期2Tの基準クロック3に同期させて、 α_i (1 \leq i \leq m)を発生させ、基準クロック2を分周して得られる周期2Tの基準クロック4に同期させて、 α_i (2 \leq i \leq m−1)を発生させる請求項8乃至17のいずれか1つに記載の光記録方法。

【請求項19】 すべてのLに対して、記録パルス α , T及び α , Tの立ち上がりに、記録すべきマーク長の前端に対する遅延時間Ta を設け、

記録トラック上に所定の位置に形成されたクロックマークに対応した基準時間 T.smc を発生させ、

基準時間T_{srac} を起点として、各マーク長及びマーク間に対応した変調信号を発生させ、

基準時間 T_{syne} を起点として遅延時間 T_{dl} をもって発生された、周期 2 T の基準クロック 1 a と、該基準クロッ 50

ク1 a に対して 0.5 T 先行した周期 2 T の基準クロック 2 a と、該基準クロック 1 a に対して 1 T 先行した周期 2 T の基準クロック 1 b と該基準クロック 1 a に対して 1.5 T 先行した周期 2 T の基準クロック 2 b との 4 種の基準クロックを発生し、

n T = 2 L T なるマークの記録に際して、基準クロック <math>1 a 及び 1 b のいずれかに同期させて、 $\alpha_1 T$ 、 $\alpha_1 T$ ($2 \le i \le m-1$)、 $\alpha_n T$ の発生区間に対応したタイミングのゲートの一群 G 1 a 及び G 1 b を発生させ、

10 nT = (2L+1) Tなるマークの記録に際して、基準 クロック 2a 及び 2b のいずれかに同期させて α_1 , T、 α_i , T ($2 \le i \le m-1$)、 α_n , T に対応したタイミングのゲートの一群 G 2a 及び G 2b を発生させ、

n が偶数である場合には、n T \forall = 1

20 基準時間 T_{sync} を起点として n T マークの前端までの経 過時間を、基準クロックTの個数として計数し、

該経過時間が基準クロックTの偶数倍であれば、nが偶数であるか奇数であるかに応じてゲート信号群G1a又はG2bを選択し、

該経過時間が基準クロックTの奇数倍であれば、nが偶数であるか奇数であるかに応じてゲート信号群G1b又はG2aを選択し、

G3及びG4のいずれもがオフである場合、消去パワー Peの記録光を照射し、

0 G3及びG4のいずれかがオンである場合、バイアスパワーPbの記録光を照射し、

G3とG1aとが同時にオンである場合、G1aオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、

G3とG1bとが同時にオンである場合、G1bオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、

G4とG2aとが同時にオンである場合、G2aオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、且つG4とG2bとが同時にオンである場合、G2bオン区間に対応して記録パワーPwの記録光が照射される請求項8に記載の光記録方法。

【請求項20】 すべてのLに対して、記録パルス α_1 及び α_1 , Tの立ち上がりに、記録すべきマーク長の前端に対する遅延時間 T_a 又は T_a , を設け、

記録トラック上に所定の位置に形成されたクロックマークに対応した基準時間Tsync を発生させ、

基準時間T_{syn} を起点として、各マーク長及びマーク間 に対応した変調信号を発生させ、

基準時間 T_{sme} を起点として発生された、周期 2 T の基準クロック 1 a と該基準クロック 1 a に対して 0.5 T 先行した周期 2 T の基準クロック 2 a と、該基準クロッ

30

ク1 a に対して1 T 先行した周期2 T の基準クロック1 b と該基準クロック1 a に対して1.5 T 先行した周期2 T の基準クロック2 b との4種の基準クロックを発生し、

n が奇数である場合には、n Tマークの前端を基準として遅延時間 T。'の経過後、 Σ (α ;'+ β ;') T なるゲート G 4 を発生させ、

基準時間T_{smc} を起点としてnTマークの前端までの経過時間を、基準クロックTの個数として計数し、

該経過時間が基準クロックTの偶数倍であれば、nが偶数であるか奇数であるかに応じてゲート信号群G1a又はG2bを選択し、

該経過時間が基準クロックTの奇数倍であれば、nが偶数であるか奇数であるかに応じてゲート信号群G1b又はG2aを選択し、

G3及びG4のいずれもがオフである場合、消去パワー Peの記録光を照射し、

G3及びG4のいずれかがオンである場合、バイアスパワーPbの記録光を照射し、

G3とG1aが同時にオンである場合、G1aオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、

G3とG1bが同時にオンである場合、G1bオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、

G4とG2aが同時にオンである場合、G2aオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、

G4とG2bが同時にオンである場合、G2bオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射する請求項10に記載の光記録方法。

【請求項21】 同一の記録媒体に対して、v×Tが一 40 定の複数の線速度vでマーク長変調方式による記録を行うに際し、

2以上のLにおいて、 $2 \le i \le m-1$ における($\alpha_i + \beta_i$) T、及び(α_i ' $+\beta_i$ ') Tの周期を線速によらず一定に保ち、さらに各 i におけるP w_i ,P b_i 、及びP e も線速度によらずほぼ一定に保ち、且つ低線速度ほど α_i 及び α_i '($2 \le i \le m$)を減少させる請求項8に記載の光記録方法。

【請求項22】 同一の記録媒体に対して、v×Tが一 定の複数の線速度vでマーク長変調方式による記録を行 50 うに際し、

2以上のLにおいて、 $2 \le i \le m$ における(β_{in} + α_i) T、及び(β_{in} ' $+ \alpha_i$ ') Tの周期を線速によらず一定に保ち、さらに各 i における P w $_i$, P b $_i$ 、及び P e も線速度によらずほぼ一定に保ち、且つ低線速度ほど α_i 及び α_i '($2 \le i \le m$)を減少させる請求項 1 0 に記載の光記録方法。

6

【請求項23】 α_i T、及び α_i ' T($2 \le i \le m-1$)を線速度によらずほぼ一定とする請求項21 又は2 2に記載の光記録方法。

【請求項24】 マーク間の時間において、 $Pb_i \le Pe \le Pw_i$ ($1 \le i \le m$) なる消去パワーPe を照射する請求項1万至は23のいずれか一つに記載の光記録方法。

【請求項25】 記録媒体が、結晶状態を未記録・消去 状態とし、非晶質状態を記録マークとする相変化型の光 記録媒体である請求項1乃至24のいずれか一つに記載 の光記録方法。

【請求項26】 全ての記録マークの時間的長さについ 0 て、 $4 \ge n / m \ge 1$. 5、 Σ_i (α_i) < 0. 6 n、か つ、P b_i / P e ≤ 0 . 2 を満たす請求項1乃至25のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項27】 記録時の線速度が10m/s以上であって、最短マーク長が0.8μm未満である請求項1乃 至26のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項28】 記録光の波長が500nm未満であり、記録光を集束させるためのレンズの開口数が0.6以上であり、かつ、最短マーク長が0.3 μm未満である請求項1乃至27のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項29】 マーク長変調方式が、8-16変調方式もしくは(1,7)-RLL-NRZI変調方式である請求項1乃至28のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項30】 マーク長変調方式がEFM変調方式であり、記録時の線速度をCDの基準線速度1.2m/s ~1.4m/sの10倍速以上として、記録線密度を一定としながら記録を行う請求項1乃至29のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項31】 マーク長変調方式がEFM変調方式であり、記録時の線速度をDVDの基準線速度3.49m/sの2倍速以上として、記録線密度を一定としながら記録を行う請求項1乃至30のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項32】 請求項1乃至31のいずれかに記載の 光記録方法により記録を行うための相変化型光記録媒体 であって、M. Ge, (Sb. Tein) $_{17}$ - 合金(た だし、 $0 \le z \le 0$. 1、 $0 < y \le 0$. 3、0. $8 \le x$ 。 Mは、In、Ga、Si、Sn、Pb、Pd、Pt、Zn、Au、Ag、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Co、Mo、Mn、Bi、O、N、Sから選ばれる少な くとも一種)からなる記録層を有することを特徴とする

光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光記録方法及び光記録媒体に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、情報量の増大に伴い高密度でかつ 高速に大量のデータの記録・再生ができる記録媒体が求 められているが、光ディスクはまさにこうした用途に応 えるものとして期待されている。光ディスクには一度だ け記録が可能な追記型と、記録・消去が何度でも可能な 書き換え型がある。書き換え型光ディスクとしては、光 磁気効果を利用した光磁気記録媒体や、可逆的な結晶状 態の変化に伴う反射率変化を利用した相変化型記録媒体 があげられる。

【0003】光ディスクの記録原理は、穴あけや変形を利用したライトワンス媒体、キュリー点近傍での磁化の反転を利用した光磁気媒体、記録層の非晶質と結晶間の相転移を利用した相変化媒体のいずれにおいても、記録層を記録パワーの照射により所定の臨界温度以上に昇温させ、物理的もしくは化学的変化を生じせしめて記録を行う。

【0004】また、1ビームオーバーライト(消去と同時に記録を行う)可能であるという相変化型記録媒体の特徴を生かして、CD、DVDと互換性を持った書換え可能なコンパクトディスク(CD-ReWritable、CD-RW)や、書換え可能なDVD等も開発されている。さて、これらの光記録媒体への記録方式には近年では、ほとんどすべて、高密度化に適したマーク長記録が採用されている。

【0005】マーク長記録はマーク部とマーク間部の両方の長さを変化させてデータを記録する方法で、マーク間部の長さのみを変化させるマーク位置記録に比べて記録密度を上げることに適しており、1.5倍以上も高密度化できる。しかし、正確にデータを再生するためにはマークの時間的長さの検出が厳密になるため、マークエッジの形状の正確な制御が必要となる。さらに、短いマークから長いマークまで長さの異なる複数種類のマークを形成しなくてはならない困難性もある。

【0006】以下の説明においては、マークの空間的長 40 さをマーク長、マークの時間的長さをマーク時間長と称する。基準クロック周期が定まれば、マーク長とマーク時間長は一対一で対応する。マーク長記録においてnTマーク(nTなる時間的長さを有するマーク。ただしTはデータの基準クロック周期、nは自然数)を記録するときに、単に時間的長さnTもしくはその長さを微調節しただけの方形波状の記録パワーを照射するだけでは、マークの前端と後端で温度分布が異なり、特に、後端部に熱が蓄積してマークが広がった非対称な形状のマークが形成され、マーク長の正確な制御やマークエッジのゆ 50

らぎの抑制に支障をきたす。

(5)

30

【0007】このため短マークから長マークまで一様にマーク形状を整えるための、記録パルス分割やオフパルスの採用などの工夫がなされてきている。例えば相変化媒体で次のような技術が利用されている。即ち、非晶質マークの形状を整えるため記録パルスを分割することが行われている(特開昭62-259229号公報、特開昭63-266632号公報など)。この考え方はオーバーライトされないライトワンス媒体にも存在する。また、マーク形状の補償方法としてオフパルスの利用が広く行われている(特開昭63-22439号公報など)。

【0008】さらに、マーク長及びマーク時間長を整えるために記録パルスの立ち下がり波形を故意に鈍らせて記録する(特開平7-37252号公報)、記録パルスの出射時間をシフトさせる(特開平8-287465号公報)、マルチパルス記録方式を用いる場合にマーク記録時のバイアスパワーの値を、マーク間記録時又は消去時のバイアスパワーの値と異ならせる(特開平7-37251号公報)、線速度に応じて冷却時間を制御する(特開平9-7176号公報等)なども提案されている。

【0009】上記のようなパルス分割方式による記録方 法の考え方は、光磁気方式の光記録媒体や、ライトワン スタイプの光記録媒体でも利用されており、光磁気方式 やライトワンスタイプでは、熱が一部に溜まるのを防止 する効果を目的とし、相変化方式では、それに再結晶化 防止という目的も加わっている。ところで、マーク長変 調記録の例としては、EFM(Eight-Fourteen Modulat ion)変調方式を用いたCD互換媒体、8-16変調方 式の一種であるEFM+(プラス)変調方式を用いたD VD互換媒体、(1、7)-RLL-NRZI (Ruu -Length Limited Non-retur n to zero inverted)変調方式を用 いた光磁気記録媒体などが一般的である。EFM変調で は3Tから11Tまでのマークが、EFM+変調では3 **Tから14Tまでのマークが、(1、7)-RLL-N** RZI変調方式では2Tから8Tまでのマークが設けら れる。この中で、EFM+変調及び(1、7)-RLL -NRZI変調方式は、特に高密度のマーク長変調記録 用の変調方式として知られている。

【0010】これらCDなどのマーク長変調記録媒体に対する記録パルス分割方式による記録方法として、次の方式が広く用いられている。即ち、記録マークには、記録マークの時間的な長さをnT(Tは基準クロック周期、nは2以上の自然数)としたとき、時間 $(n-\eta)$ Tを

[0011]

【数9】 α_1 T、 β_1 T、 α_2 T、 β_2 T、····、 α_n T、 β_n T、

(ただし、 $\Sigma \alpha_i + \Sigma \beta_i = n - \eta$ とする。 η は0 - 2までの実数。mはm = n - kを満たす数。kは1または2。)と分割し、記録パルス区間としての α_i T($1 \le i \le m$)なる時間においては、記録パワーPwの記録光を照射し、オフパルス区間としての β_i T($1 \le i \le m$)なる時間においては、P b < P w となるバイアスパワーP b の記録光を照射する。

【0012】図2は、この記録方法における記録光のパ ワーパターンを示す模式図である。図2(a)に示す長 さのマークを形成するために、図2(b)に示すパター 10 ンを用いる。長さnT(Tは基準クロック周期、nはマ ーク長変調記録において取りうるマーク長であり、整数 値である) にマーク長変調されたマークを形成する際、 $(n-\eta)$ Tを、m=n-k (kは1又は2) 個の記録 パルスに分割(図2(b)ではk=1、 $\eta=0.5$) し、個々の記録パルス幅をα: T(1≤i≤m)とし、 個々の記録パルスに β : T ($1 \le i \le m$) なる時間のオ フパルス区間が付随する。記録の際 α i T (1 \leq i \leq m) においては、記録パワーPwの記録光を照射し、 β i T (1 ≤ i ≤ m) なる時間においては、Pb < Pwと 20 なるバイアスパワーPbの記録光を照射する。この際、 マーク長を検出した際に、正確なnTマークが得られる ように、 $\Sigma \alpha_i + \Sigma \beta_i$ はnよりも若干小さくしてもよ $\langle \sum \alpha_i + \sum \beta_i = n - \eta \pmod{\eta}$ なる実数)とする。

【0013】つまり、従来技術においては、nTマーク形成時に照射する記録光をパルス分割するにあたり、nから一律にkを差し引いたm個(m=n-k、ただしkは1または2)に分割(特開平9-282661号公報に記載あり)し、記録パルスの分割数mを一定数減ずる 30ことでマーク時間長を正確に制御していた(以下ではこのようなパルス分割方式を「n-k分割」方式と呼ぶこととする)。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】一般に、高密度化あるいは高速化により上記基準クロック周期Tは短くなる。例えばTは次のような時に短くなる。

(1) 記録を高密度化し記録容量を上げる場合 マーク長及びマーク時間長を短縮すればより高密度にな るが、この場合、クロック周波数を高周波化して基準ク ロック周期Tを小さくする必要がある。

【0015】(2)記録線速度を上げデータ転送レートを高める場合

記録可能CDやDVDの高倍速記録などでも、クロック周波数が高周波化されて基準クロック周期Tが短くなる。例えば書換え型コンパクトディスクなどのCD系媒体では1倍速(線速1.2~1.4m/s)での基準クロック周期Tは231ナノ秒であるが、10倍速では23.1ナノ秒と非常に短くなる。同じくDVD系媒体では1倍速(3.5m/s)で基準クロック周期Tは3

8. 2ナノ秒であるが、2倍速では19. 1ナノ秒とな ス

【0016】上記(1)、(2)から分かるように、より大容量の光ディスクやデータ転送レートの高いCD、DVD等においては基準クロック周期Tが非常に短くなる。これに伴い、記録パルス区間 α ; Tやオフパルス区間 β ; Tも短くなる傾向にある。このとき以下のような問題が発生する。

(問題 a) 記録パルス区間 a: Tが短すぎて照射する 光、特にレーザーの立ち上がり/立ち下がり速度が追い つかないという問題がある。立ち上がり時間とはレーザ 一等の光の出射パワーが設定値に達するまでの時間、立 ち下がり時間とはレーザー等の光の出射パワーが設定値 から落ちきるまでの時間である。現在、レーザー等の立 ち上がりや立ち下がりにはそれぞれ最低2~3ナノ秒の 時間を必要とするため、例えばパルス幅が15ナノ秒未 満だと実際に所定パワーを出射する時間は数ナノ秒とな る。さらにパルス幅が5ナノ秒未満になると、出射パワ ーが設定値に到達する前に下がり始めてしまうため、記 録層の昇温が不十分で規定のマークサイズを得ることが できなくなってしまう。これら信号源やレーザービーム の応答速度の限界の問題は、光源波長や基板入射/膜面 入射などの入射方式やその他の記録方式の改良ではカバ ーしきれない問題である。

(問題 b) オフパルス区間 β; Tが狭いと、記録媒体にとって十分な冷却時間が得られなくなってしまい、オフパルス区間を設けているにもかかわらずオフパルス機能(冷却速度制御機能)が働かず、マーク後端部に熱が蓄積されてしまいマーク形状が正確に形成できなくなるという問題がある。特に、この問題はマークの長さが長いほど深刻である。

【0017】この問題点を、相変化媒体を例に説明する。現行の相変化媒体は通常、結晶状態の部分を未記録状態・消去状態とし非晶質の部分を記録状態とする。非晶質マークを形成する際は、記録層の微小な領域にレーザーを照射し、その微小部分を溶融させた後にこれを急冷することにより非晶質マークを形成する。

【0018】例えば、図3(a)に示すようにオフパルス区間をまったく設けない方形波上の記録パワー波形で、長いマーク(例えばCDフォーマットのEFM変調方式の記録マークで概ね5T以上のマーク)を記録した場合、図3(b)に示すように、後端が細った非晶質マークが形成され、同図(c)に示すような歪んだ再生波形が観測される。これは、長いマークでは特にマーク後端において、前方からの熱拡散で蓄熱が起こり溶融領域が太るが、一方で、冷却速度が著しく低下して、再凝固時に再結晶化してしまうためである。この傾向は、記録時の線速が低いほど著しい。低線速ほど記録層の冷却速度は低下するためである。

【0019】逆に、再結晶化がほとんど無視できるほど

50

(7)

20

12

冷却速度が速い場合には、長いマークを記録した場合、図3(d)に示すように、むしろ後端が太った非晶質マークが形成され、同図(e)に示すような歪んだ再生波形が観測される。これは、長いマークでは特にマーク後端において、前方からの熱拡散で蓄熱されて溶融領域が太るが、全体に冷却速度が高めに維持されているためこの溶融領域の形が比較的正確に非晶質マークとなるからである。

11

【0020】マーク長全体に複数のオフバルス区間を分散させて、適正に使用しない場合には、程度の差こそあ 10 れ図3(b)及び(d)のように、マークのどこかで再結晶化が著しくなり、良好な非晶質の長マーク形成が阻害され、再生波形に歪を生じる。オフパルス区間を入れることで、長マークの先端から後端までにわたって記録層の時間的な温度変化が急冷的になり、記録時の再結晶化によるマークの劣化を抑えることができる。

【0021】しかし、前述のように高密度化や高速化のために基準クロック周期Tが短くなっていくと、従来のようなオフパルス区間を設けても急冷されにくくなりマーク前半部分が再結晶化してしまうようになる。例えば、相変化型の書換え型コンパクトディスクであるCD-RWで時間的長さ4Tのマークを従来のn-k分割方式(ただし、k=1)で記録する場合、非晶質マークの形成時には以下のパルスが照射される。

[0022]

【数10】

 α_1 T、 β_1 T、 α_2 T、 β_2 T、 α_3 T、 β_3 T このときマークの始端部は、記録パルス α_1 T照射により溶融後、後続の記録パルス α_2 T、 α_3 T照射による熱がマーク後方から伝導する。図4はマーク始端部での 30温度履歴の模式図で、図4 (a)は低線速の場合、図4 (b)は高線速の場合であるが、いずれも α_1 T、 α_2 T、 α_3 Tによる3度の昇温過程と β_1 T、 β_2 T、 β_3 Tによる冷却過程が見られる。

【0023】低線速の場合には図4 (a) に示すように β ₁ T、 β ₂ Tでの冷却時間が十分にあるため、その都 度記録層の温度が結晶化温度以下にまで下がることがで きるが、高線速の場合には、基準クロック周期Tが線速 に反比例して小さくなるために、図4 (b) のように α L Tで溶融した記録層が結晶化温度領域よりも冷却され 40 ることがないまま、次のα2 Tで昇温され、さらにα3 Tで昇温される。結晶化温度領域に保たれる時間が、低 線速のT: +T: +T; に比べて高線速のT:+T; + T。ではずっと長くなるため、再結晶化が起こりやすく なることが分かる。なお、相変化記録層として使用され るSbTe共晶組成付近の合金は非晶質/結晶の境界か ら結晶成長が起こりやすいので、マークの外側部分で再 結晶化しやすい。ここで、低倍速とは例えば10倍速未 満(T=23.1ナノ秒未満)、高倍速とは10倍速以 上程度を言う。

【0024】上記のように、相変化型媒体においては、 高密度化や高速化のために基準クロック周期Tが短くな ると、従来のパルス分割法では再結晶化が起こりやす く、長マークの中央部で変調度が出なくなるという深刻 な問題が発生する。なお、結晶領域に非晶質マークをオ ーバーライト記録する相変化媒体においては、高線速時 には一般に冷却速度は確保されやすく非晶質を形成しや すいが、一方で結晶化のための結晶化時間を確保するこ とが難しいため、結晶化しやすい傾向にある。即ち、再 結晶化しやすい組成の記録層を用いることが多い。従っ て、オフパルス区間をより広くとって冷却効果を大きく することが重要になるにもかかわらず、高線速時には逆 にオフパルス区間が短くなってしまう。

【0025】相変化媒体の高密度化のために、レーザー 光源を短波長化したり開口数を大きくし、ビーム径を小 さくしたときにも同じ問題が生ずる。例えば、波長78 0nm、開口数NA=0.50のレーザーを波長400 nm、開口数NA0.65に変更した場合には、ビーム 径は約1/2に絞られる。このときビーム内のエネルギー分布が急峻になるため加熱部分は冷却されやすくなり 非晶質マークは形成されやすくなるが、逆に結晶化しに くく消去しにくくなるため、やはり冷却効果はより大き くする必要がある。

【0026】本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、高密度記録や高速記録に適した短いクロック周期でのマーク長記録においても、良好な記録が行えるような光記録方法とそれに適した光記録媒体を提供することにある。

[0027]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的は、パルス分割方式における分割数mを従来よりも少なくすることによって達成されることを見出し、本発明を完成した。本発明の要旨は、記録媒体に光を照射することによってマーク長変調された情報を複数の記録マーク長により記録するにあたり、一つの記録マークの時間的な長さをnTとしたとき(Tは基準クロック周期であって25ns以下である。nは2以上の自然数である。)、記録マークの時間的長さnTを、

[0028]

[数11] η_1 T、 α_1 T、 β_1 T、 α_2 T、 β_2 T、 \cdots 、 α_i T、 β_i T、 \cdots 、 α_n T、 β_n T、 η_2 T

 $(mはパルス分割数である。<math>\Sigma_i$ $(\alpha_i + \beta_i) + \eta_1 + \eta_2 = n$ である。 α_i $(1 \le i \le m)$ は0より大きい 実数であり、 β_i $(1 \le i \le m-1)$ は0より大きい実数であり、 β_i は0以上の実数である。 η_1 及び η_2 は それぞれ-2以上2以下の実数である。)の順に分割し、 α_i T $(1 \le i \le m)$ の時間内においては記録パワーPw_i の記録光を照射し、 β_i T $(1 \le i \le m-1)$ 50 の時間内においては、 Pb_i $< Pw_i$ かつ Pb_i < Pw

(8)

… なるバイアスパワーPb: の記録光を照射し、少なくとも一つの記録マークの時間的長さについては上記パルス分割数mを2以上とし、かつ、全ての記録マークの時間的長さについてn/m≥1.25を満たすことを特徴とする光記録方法に存する。

13

【0029】また、本発明の別の要旨は、上記光記録方法に用いる相変化型光記録媒体であって、M. Ge, (Sb. Te_{1-1}) $_{1-2}$ 合金(ただし、 $0 \le z \le 0$. 1、 $0 < y \le 0$. 3、0. $8 \le x$ 。Mは、In、Ga、Si、Sn、Pb、Pd、Pt、Zn 、Au 、Ag、Z 10 r 、Hf 、V 、Nb 、Ta 、Cr 、Co 、Mo 、Mn 、Bi 、O 、N 、Sho B 選ばれる少なくとも一種)からなる記録層を有することを特徴とする光記録媒体に存する。

[0030]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明する。本発明の光記録方法は、パルス分割方式による分割数mを少なくする、即ち記録光の各パルスを長くすることによって、光記録媒体の光照射部分の加熱時間をレーザーパルスの応答速度に対して十分長くとること、お20よび光照射部分の冷却時間を十分長くとるものである。その結果、25ns以下という短いクロック周期においても良好なマーク長記録が行なえる。

【0031】具体的には、記録マークの時間的な長さを n T としたとき (T は基準クロック周期であり 25 n s 以下である。n は 2 以上の自然数である。)、該記録マークの時間的長さ n T を、

[0032]

【数12】 η_1 T、 α_1 T、 β_1 T、 α_2 T、 β_2 T、···、 α_i T、 β_i T、···、 α_n T、 β_n T、 η_2 T

(mはパルス分割数である。 Σ_i ($\alpha_i + \beta_i$) $+\eta_1 + \eta_2 = n$ である。 α_i ($1 \le i \le m$) は0より大きい実数であり、 β_i ($1 \le i \le m-1$) は0より大きい実数であり、 β_i ($1 \le i \le m-1$) は0より大きい実数であり、 β_i は0以上の実数である。 η_i 及び η_2 は、それぞれ通常-2以上、好ましくは0以上、また通常2以下好ましくは1以下の実数である。) の順に分割し、 α_i T ($1 \le i \le m$) の時間内においては記録パワーPwi の記録光を照射し、 β_i T ($1 \le i \le m$) の時間内においては、Pbi <Pwi かつPbi <Pwi なるバイアスパワーPbi の記録光を照射し、少なくとも一つの記録マークの時間的長さについては上記パルス分割数mを2以上とし、かつ、全ての記録マークの時間的長さについて $n/m \ge 1$. 25とする。

【0033】すなわち、従来のn-k分割方式によればパルス分割数mをn-k個(kは1または2)としたが、本発明ではmを別の観点から規定する。本発明においては、少なくとも一つの記録マークの時間的長さについては上記パルス分割数mを2以上とする。ただし、必ずしも全てのnTマーク(nTなる時間的長さを有する50

マーク。ただしては基準クロック周期、nは2以上の自然数)についてパルス分割を行う必要はない。特に2 T、3 Tや4 Tなどの短いマークにおいては熱の蓄積の問題が比較的小さく、パルスの応答速度が追いつかないとの問題のほうが影響が大きいため、記録パワーPwの記録光を1パルス照射するだけ、或いは記録パワーPwの記録光を1パルスとバイアスパワーPbの記録光を1パルス照射する方が好ましい。

【0034】本発明においては、全ての記録マークの時間的長さについて $n/m \ge 1$. 25 とする。仮に η_1 、 η_2 を共に0 とすると、 Σ_i ($\alpha_i + \beta_i$) /m = n/mであるから、n/mは ($\alpha_i + \beta_i$) の平均的な長さに対応する値であり、 (n/m) Tは分割パルスの平均的な周期に対応する値となる。

【0035】従来のn-k分割方式ではm=n-kであって、kは1または2に固定されているから、n/m=n/(n-1) 又はn/m=n/(n-2) である。この値は、nが大きいほど小さいから、最長のマーク時間長をn エとするとn においてn/mは最小となる。即ち、分割パルスの平均的周期は最短マークで最も長く最長マークで最も短いから、 α : T、 β : Tは最長マークで最も短い。

【0036】例えば、EFM変調方式ではn=3~1 1、k=2であるから

(num /m) = 11/(11-2) = 1.22、 同様にEFM+変調方式ではn=3~14、k=2であるから

 $(n_m$ /m) = 14/ (14-2) = 1.16、 (1、7) -RLL-NRZI変調では $n = 2 \sim 8$ 、k 30 = 1なので

 $(n_{max} /m) = 8/(8-1) = 1.14$ 程度となる。

【0037】上記から明らかなように、従来ではn/mは1.22、1.16、1.14程度である。基準クロック周期Tがおよそ25ナノ秒を切ると、概ね最長マークにおいて分割パルスの平均周期が25ナノ秒を切り、記録パルス区間 α : Tの平均値もしくはオフパルス区間 β : Tの平均値が12.5ナノ秒未満となる。これは少なくとも一つのiに対して、 α : Tもしくは β : Tのいずれかが12.5ナノ秒未満になることを示す。さらに、クロック周期Tが約20ナノ秒以下となると、 α : Tもしくは β : Tのいずれかがさらに小さくなってしまう。

【0038】なお、上記の説明においてどれか特定の α はしくは β が平均値より長くなったとしても、それは他方別の α もしくは β がさらに短くなることを意味しているから、やはり α Tもしくは β Tのいずれかが小さくなることに変わりはない。また正確には、n-k分割方式では Σ (α + β) は必らずしもnと等しくなく、 $n-\eta$ ($\eta=0\sim2$) となっていてもよい

20

40

が、この場合は α : や β : の平均値はさらに短くなるの で、むしろ問題は一層深刻となる。

15

【0039】本発明の光記録方法においては、短マーク から長マークまで全ての記録マークの時間的長さについ てn/m≥1.25を満たすようにmを設定する。その 結果、α: Tとβ: Tの長さを十分なものとする。例え ば、記録パルス区間 α i T、オフパルス区間 β i Tを概 ね0.5 Tより長めに取ることができ、記録層の加熱を 十分に行う一方、後続パルスによる熱の供給を抑えて十 分な冷却効果を得ることができる。

【0040】特にマークが長い場合には熱蓄積によるマ ーク形状が歪みやすいため、好ましくは時間的長さ7T 以上のマークに対してはn/mは1.5以上とする。勿 論、6 T以下の短マークについてもn/mは1.5以上 とするのが好ましい。より好ましくはn/mは1.8以 上とする。ただし、n/mの値が大きすぎると熱蓄積が 大きくなるため、n/mは通常4以下とし、特に3以下 とするのが好ましい。

【0041】本発明の光記録方法は基準クロック周期T が短いほど効果が大きく、25 n s 以下、好ましくは2 0 n s以下、さらに好ましくは15 n s以下とする。た だし、あまりに短いクロック周期は実用上得にくいので 通常0.1ns以上、好ましくは1ns以上、さらに好 ましくは3ns以上とする。クロック周期Tが小さいほ ど、n/mの最小値を大きくするのが好ましい。

【0042】本発明における記録マークとは、通常、記 録媒体中に連続的に形成された、他の部分と光学的に区 別しうる物理的マークとして認識される。即ち、n/m ≥1.25を満足する、従来のn-k分割方式の2T、 3 T及び4 Tマークを再生系の処理によってつなぎ合わ せて長いマークとみなすものではない。ただし、本発明 においては、再生光の光学分解能以下の範囲において、 記録マークが複数の物理的マークから形成されていても よい。再生光の集束用の対物レンズの開口数をNA、再 生光波長を1とするとき、物理的マークが概ね0.2 (1/NA) よりも離れていると、これらの物理的マー クは光学的に分離して区別できる。従って、記録マーク を複数の物理的マークから形成する場合には、それらの 間隔を0.2(11/NA)よりも小さくするのが好まし ١١°

【0043】本発明において、 α_i 、 β_i 、 η_i 、 η_2 、Pw、Pb等の分割パルスに関するパラメータは、マーク長 やiに応じて適宜変化させることができる。また、本発 明においては、記録パルス区間 α : T ($1 \le i \le m$) の 平均値およびオフパルス区間 β 、T ($1 \le i \le m-1$) の平均値をともに3ナノ秒以上、特に5ナノ秒以上、さ らに10ナノ秒以上とするのが照射する光の追従性を確 保する意味で好ましい。より好ましくは、個々のα: T $(1 \le i \le m)$ および β_i T $(1 \le i \le m-1)$ を3ナ ノ秒以上、特に5ナノ秒以上、さらに10ナノ秒以上と 50 い。具体的には、(α : $+\beta$:)T(ただし $2 \le i \le m$

する。なお、記録の際に通常使用するレーザー光のパワ ーの立ち上がり時間や立ち下がり時間は、最小の α: T (1≦ i ≦ m) 及びβ; T (1≦ i ≦ m) の50%以下 とするのが好ましい。

【0044】本発明においては、β。を0として最後の オフパルス区間であるβ. Tに光を照射しなくてもよい が、マーク後端部の熱蓄積の問題が大きい場合はβ. T を設けるのが好ましい。その場合はβ. Tも通常3ナノ 秒以上、特に5ナノ秒以上とし、より好ましくは10ナ ノ秒以上とする。記録パルス区間α, T (1≤ i≤m) が3ナノ秒以上、特に5ナノ秒以上あれば、記録光の立 ち上がり/立ち下がりの問題はあるものの、記録パワー Pwiを上げることで記録に必要な照射エネルギーを確 保できる。

【0045】一方オフパルス区間 β_i T (1 ≤ i ≤ m -1) も3ナノ秒以上、特に5ナノ秒以上あれば、バイア スパワーPbを再生光パワーPrと同程度、あるいはト ラッキングサーボなど他に支障の無い限り0まで下げる ことで冷却効果が確保できる。さらに大きな冷却効果を 得るためには、全ての記録マークの時間的長さについて Σ_i (α_i) は0.6 nよりも小さくする、特に0.5 nよりも小さくするのが好ましい。より好ましくは Σ_i (α_i) は 0.4 n 以下とする。すなわち、記録パルス 区間の総和 Σ : $(\alpha$: T) を Σ : $(\beta$: T) より短くし て、各マーク内でオフパルス区間が長くなるようにす る。特に好ましくは、 $i=2\sim m-1$ の全てのiに対し てα: T≦β: Tとし、少なくとも2番目以降の記録パ ルス列においてβ: Tのほうを長くする。

【0046】本発明の記録方法において、 α_i ($1 \leq i$ \leq m) 及び β i ($1 \leq i \leq m-1$) の値は、記録パルス 区間 α , T (1 \leq i \leq m) やオフパルス区間 β , T (1 \leq i ≤m-1) 等の値によって適宜設定されるが、それぞ れ通常0.01以上、好ましくは0.05以上であり、 通常5以下、好ましくは3以下である。特に、 β : (1 ≦ i ≦m-1) については、あまりに小さいと冷却効果 が不十分になることがあるので好ましくは0.5以上、 特に1以上であり、一方あまりに大きいと冷却されすぎ て記録マークが光学的に分離されてしまうことがあるの で、好ましくは2.5、特に2以下とする。この効果 は、マーク先端の形状に大きな影響を与える最初のオフ パルス区間β₁Tにおいて特に大きい。

【0047】また、同様に、マーク後端の形状に大きな 影響を与える最後のオフパルス区間 β. Tについても、 上記同様のことが言えるので、β.は、通常0.1以 上、好ましくは0.5以上、特に1以上であり、好まし くは2.5、特に2以下である。先頭パルス区間α、T と最後尾パルス区間 α. Tとの間の中間パルス区間 (群) α : $T(2 \le i \le m-1)$ の切り替え周期は、こ れを一定値とするのが、回路を簡便化する上で好まし

-1)または(α_i + β_{ii}) T(ただし $2 \le i \le m-1$)は、1.5T、2T又は2.5Tとするのが好ましい。本発明においては、オフパルス区間 β_i T ($1 \le i \le m-1$) に照射する記録光のパワーP b_i は、記録パルス区間 α_i T及び α_{ii} Tに照射する記録光のパワーP w_i 及び P w_{ii} よりも小さくする。大きな冷却効果を得るためには、全ての記録マークの時間的長さについて P b_i < P w_i ≥ 0.5 であり、さらに好ましくは P b_i / P w_i ≤ 0.5 であり、さらに好ましくは P b_i / P v_i ≤ 0.5 である。また、バイアスパワーP v_i v_i v

17

【0048】特定の一つの記録マークの時間的長さに対 して、iに応じてPb:及び/又はPw:として異なる 2以上の値を用いてもよい。特に、先頭の記録パルス区 間 α 、 T及び最後尾の記録パルス区間 α 、 Tにおける記 録パワーPwi 及びPw を、中間の記録パルス区間 a i T (2≤i≤m-1) における記録パワーPwi と異 なる値とすることで、マークの始端部・終端部のマーク 形状を正確に制御することができる。ただし、中間の記 録パルス区間 α : $T(2 \le i \le m-1)$ における記録パ ワーPwiは、できるだけ全て同じパワー値にするの が、分割パルス回路の設定が簡便となり好ましい。オフ パルス区間 β : T $(1 \le i \le m-1)$ におけるバイアス パワーPb。についても同様に、特に理由がない限りで きるだけ全て同じパワー値にするのが好ましい。また異 なるnを有する少なくとも2つの記録マークの間で、同 じiに対して異なるPw。及び/又はPb。の値として もよい。

【0049】本発明においては、記録マークを形成しないマーク間にどのようなパワーの光を照射するか限定されないが、好ましくはPb。 \leq Pe < Pw。なるパワーPeの光を照射する。書換え型記録媒体であれば、パワーPe は記録済みマークを消去するための消去パワーとする。この場合、 $(n-(\eta_1+\eta_2))$ T区間には、バイアスパワーPb。以上、消去パワーPe以下の光を照射するのが好ましい。バイアスパワーPb。と同じか、消去パワーPeと同じとすれば、分割パルス回路の設定が簡便となる。なお、 η_1 Tなる区間においてバイアスパワーPbの光を照射する場合、先頭の記録パルス区間 α_1 Tに先行してバイアスパワーPbの光を照射することとなるので、先行する記録マークからの余熱の影響を小さくすることができる。

【0050】記録パワーPw及びバイアスパワーPb、または消去パワーPeについては、使用される光記録媒体 m)のタイプによって、それぞれの物理的機能は異なってくる。例えば、光磁気媒体の場合、PwあるいはPeは記録層の温度を少なくともキュリー温度近傍より高くし、なる磁化の反転を起こしやすくするための昇温に必要なパワ 50 る。

ーである。いわゆる光変調オーバーライト可能な光磁気 媒体では、PwはPeよりも大きく、キュリー点の異な る複数の磁性層のいずれかのキュリー点温度より、磁性 層の温度を高めるためのパワーである。

【0051】相変化媒体の場合、結晶化による記録を行う場合には、Pwは記録層を結晶化温度より高い温度に昇温するためのパワーである。あるいは、非晶質化よる記録を行う場合には、少なくとも記録層をその融点より高い温度まで昇温するためのパワーである。非晶質化記録、結晶化消去によってオーバーライトを行う場合には、Peは記録層を少なくとも結晶化温度以上に昇温せしめるパワーである。

【0052】金属や有機物記録層の穴あけや、変形により記録を行うライトワンス媒体では、Pwは記録層を軟化させたり、溶融させたり、蒸発させたり、分解したり、化学反応を誘起する温度まで昇温するに必要なパワーである。使用する記録媒体の種類によって、記録パワーPw及びバイアスパワーPbの値は異なるが、例えば書き換え型の相変化媒体の場合、通常記録パワーPwは1~100mW程度、バイアスパワーPbは0.01~10mW程度である。

【0053】いずれの媒体を使用した場合でも、記録パワーPwは記録層になんらかの光学的変化を誘起するに必要な温度まで記録層を昇温し、場合によってはその温度を保持するに必要なレーザー光パワーである。一方、バイアスパワーPbは少なくとも記録パワーPwより低いパワーである。通常は、記録パワーPw及び消去パワーPeよりも低く、記録層になんら物理的変化を誘発しないような低いパワーである。

30 【0054】以上説明したような熱蓄積の問題は、相変化型、光磁気型、ライトワンス型光記録媒体など広くマーク長変調記録を行う光ディスクに共通である。しかし中でも、オーバーライト可能な相変化媒体は記録層の昇温と冷却速度という2つの温度パラメータを正確に制御することでマーク記録とマーク消去を同時に行うため、オフパルスによる記録層の冷却機能は他のライトワンス媒体や光磁気媒体よりもいっそう重要な意味を持つ。従って、本発明は相変化型の記録媒体に対して特に有効である。

19

【0056】分割数mはnの値の大小とは無関係に並ん でいても良いが、好ましくは長いマークほど、つまりn が大きいほどmを単調に大きく(等しい場合も含む)す る。以下に、本発明のパルス分割方式の具体例を示す。

(分割方式例1) 例えば、3Tから11Tまでのマーク を設けるEFM変調方式で、n=3においてはm=1と し、n≥4 (4、5、6、7、8、9、10、11) に おいてmを増やす。即ち、n=3、4、5、6、7、 8、9、10、11に対して順にm=1、2、2、3、 4、5、6、7、8のように分割する。

【0057】このときn=11においてn/mは最小で 1. 38であり、n=3においてn/mは最大で3であ る。

(分割方式例2) 同じくEFM変調方式で、n=3、 4、5、6、7、8、9、10、11に対して、順にm = 1、2、2、3、4、5、6、6、6のように分割す る。

【0058】このときn=9においてn/mは最小で 1. 5、n=3においてn/mは最大で3である。 (分割方式例3) 同じくEFM変調方式で、n=3、 4、5、6、7、8、9、10、11に対して、順にm =1、2、2、3、3、4、5、5、5のように分割す

【0059】このときn=9においてn/mは最小で 1. $8 \times n = 3$ においてn/mは最大で3である。nの 異なる少なくとも2つの記録マークについて、同一のパ ルス分割数mを用いる場合には、例えば、パルス周期τ $i = \alpha_i + \beta_i$ やデューティー比($\alpha_i \neq \alpha_i$ β:)) を変更すればよいが、この具体例を以下に示

(分割方式例4)最も単純な分割方式は、m≥2の場合 にパルス周期 t; を t; = n T/mとなるよう等分割す ることである。

【0060】しかしながら、単純にnTを等分割すれ ば、τιは基準クロック周期Tのタイミングや長さとは 全く無関係の中途半端な値となることがある。

(分割方式例5) パルス周期τ: は、基準クロック周期 Tもしくはその整数分の1(1/2T、1/4T、1/ 5T、1/10T等が好ましい)に同期しているほう が、一つのベースクロックを基準にしてパルスの立ち上 40 がり/立ち下がりを制御できて好ましい。一方で、この 際、 Σ_i (τ_i) = Σ_i ($\alpha_i + \beta_i$) は必ずしもnと 一致せず余剰の時間が発生するためパルス長を補正する が、パルス照射時間の合計はnより小さくするのが好ま しい。nより大きくするとマーク長さが長くなりすぎる ためである。

[0061] \mathcal{L} \mathcal{L} $_{2}$) = n (η_{1} \ η_{2} はそれぞれ $0 \leq \eta_{1}$ \ $0 \leq \eta_{2}$ な る実数)となるような区間 η ι Τ、 η ι Τを設け、これ

ぞれで変化させる。 n. T、n2 Tの区間には例えばバ イアスパワーPbの光を照射すればよい。このとき、O $\leq (\eta_1 + \eta_2) \leq 1$ とするのが好ましい。

【0062】上記 n, 、n, は、該マークに先行及び/ 又は後続する他のマークからの余熱効果を補正するため にも利用できる。この場合は、先行及び/又は後続する マークのマーク長及び/又はマーク間スペース長に応じ て、n: T、n2 Tの時間的長さを可変とする。分割し たパルスの先頭のη1 T及び最後尾のη2 Tはいずれか 10 一方のみ配置し他方を0としてもよいし、0≦(η, + n2) ≤1となる範囲で、両方配置しても良い。また、 区間 η_1 T、 η_2 Tには、バイアスパワーPbとは異な るパワーの光を照射して、マーク長を整えたり先行及び /又は後続するマークからの余熱効果をより厳密に制御 することも可能である。

(分割方式例6) 上記分割パルス周期 τ; やデューティ 一比 $(\alpha_i / (\alpha_i + \beta_i))$ を、 i により可変とす る。この方法によって、マーク長記録で重要となるマー クの前後端でのジッタ(ゆらぎ)を改善することもでき

【0063】具体的には、先頭の記録パルス周期τ、及 び/又は最後尾の記録パルス周期 τ。とをそれぞれ中間 部分の記録パルス周期 t; (2≤i≤m-1)とは異な るものとする。この際、先行及び/又は後続するマーク 長もしくはスペース長に応じて、先頭及び/又は最後尾 O_{τ_1} 、 α_1 、 β_1 、 τ_{\bullet} 、 α_{\bullet} 、 β_{\bullet} を若干調整する ことも可能である。

【0064】なお、先頭の記録パルス区間 a. Tは後続 の記録パルス区間 α 2 T、・・・、 α . Tのいずれの値 よりも大きくするのが好ましい。また、記録パルス区間 αιTにおける記録パワーPwiを後続の記録パルス区 間α2 T、···、α。Tにおける記録パワーPwi よ り高くするのが好ましい。これらの方法は、後述する再 生信号のアシンメトリー値を良好にするために有効であ

【0065】時間的長さ3Tや4Tのような短いマーク では熱の蓄積効果が小さいため比較的マークが短めに形 成されやすい。このような場合、記録パルス区間 a 、 T をある程度長くするか記録パルス区間α. Tにおける記 録パワーPwiの値を大きめにしてマーク時間長を厳密 に制御することもできる。上記のような、先頭パルス又 は最後尾パルスを変化させる方法は、相変化媒体の結晶 領域に非晶質マークをオーバーライト記録する場合に特 に有効である。

【0066】先頭記録パルス区間α: Tを変化させるこ とで、相変化媒体の記録層が最初に溶融する領域の幅を 制御することができる。最後尾オフパルス区間β. Tは 相変化媒体の記録層の再結晶化の抑制に重要であり、か つ、どの領域までを非晶質状態とするかを決める重要な らを同じ分割数mの2つの異なる長さの記録マークそれ 50 パルスである。非晶質マークが形成される場合には、マ

20

ークの最も終端部においては、一旦溶融した領域が再結晶化し、溶融領域よりも実際に形成される非晶質マークは小さくなる。ここでオフパルス区間を長くする、すなわち冷却時間を長く取ることで、再結晶化を防ぎ、非晶質部分を長くすることが可能である。従って、最後尾オフパルス区間 β 。 Tの長さを変えることでマーク終端部が結晶化時間に保たれる時間を変化させ、マーク長をかなり大きく変化させることが出来る。

21

【0067】なお、上記とは逆に、 τ_1 、 α_1 、 β_1 、 τ_0 、 α_0 、 β_0 を変化させず、間の τ_1 、 α_1 、 β_1 (2 \leq i \leq m=1) を変えることで、マークエッジに影響させずに変調度の出方を制御することもできる。以上のような分割方式を実現する分割記録パルス発生方法について以下に述べる。

【0068】基本的には、各マーク時間長nTに対する分割方法をプログラマブルとし、ROMチップに組み込んで記録してしまえば上記パルス分割は実現できる。しかし、あまりに多様な柔軟性を同一のパルス発生回路に付加するのは回路が複雑になるため、例えば、以下の2つのパルス発生方法を用いるのが好ましい。その結果、ほとんどすべての媒体に適応できるパルスを簡便に提供できる。

(分割記録パルス発生方法1)図1 (a)のようなEFM変調されたマーク長変調データ100に対して、図1(b)で示す分割方式101を適用する。即ち、n=3、4、5、6、7、8、9、10、11に対してm=1、1、2、3、3、4、5、5、5のように分割する。このとき、図1(c)に示すタイミングでクロックを発生する回路Gate1、Gate2、Gate3、Gate4を組み合せることで図1(b)の分割方式を実現することができる。

【0069】図1 (c) において、符号102で示すG a telは先頭記録パルスαι Tを遅延時間Tu 後に発 生させる。符号103で示すGate2は2番目以降の 中間記録パルス群 a: Tを遅延時間 Ta 後に発生させ る。符号104で示すGate3は、バイアスパワーP b をもつパルスとパワーPeをもつパルスの発生を司 る。即ち、Gate1、Gate2及びGate4で記 録パルス群が発生していない場合、低いレベルのときに はバイアスパワーΡЬをもつオフパルス群β、Tを発生 させ、高いレベルのときにはパワーPeをもつパルスを 発生させる。Gate3及びTaにより($n-(\eta_1+$ η₂)) Tが定まる。符号105で示すGate4は中 間記録パルス群α: Tが発生し終わった後、遅延時間T u 後に最終記録パルスα、Tを発生させる。Gete3 が低いレベルにある区間内では、記録パルス群が高いレ ベルにあればオフパルスに優先する。

区間では、記録パワーPw」を発生し、Gate2内での中間パルス群 α 。 Tでは記録パワーPw」を発生し、Gate4で発生する α 。 T区間では、記録パワーPw」を発生させれば、先頭パルス区間と中間パルス区間群及び最後尾パルス区間とで、記録パワーを独立に制御できる。

【0071】先頭と最後尾の記録パルス幅及び記録パワーを独立して制御するために、中間パルス群の周期は、 T_{α} を起点として $\gamma_i = \alpha_i + \beta_{i-1}$ ($2 \le i \le m-1$) で規定し、概ね $\gamma_i = 1 \sim 3$ で一定としており、この場合 β_i は自動的に決まる。図1 では $\gamma_i = 1$. 5 とした。ただし、 β_i には $T_{\alpha} - (T_{\alpha_i} + \alpha_i T)$ の補正をするよう T_{α_i} を定義しており、 β_i は独立したパラメータとして扱える。

【0072】いずれの場合においても、Gateonsyle Gateonsyle Gateonsylva Gateonsylv

(分割記録パルス発生方法2)以下の方法は、基準クロック周期Tを分周して得られる、周期2Tのクロック信号をベースとする分割記録パルス発生方法であり、分割記録パルス発生方法1より制限が多いが、より規則正しいルールに基づいて論理回路の設計が可能となる利点がある。

【0074】パルス発生方法2は、nTマークのnのとり得る値が奇数であるか偶数であるかにわけて考える点に特徴がある。即ち、<math>nが偶数、つまりマーク長がnT=2LT(ただし、Lは2以上の整数)のマークの記録に際しては、分割数m=L個の区間に分割し、記録パルス区間 α : T及びオフパルス区間 β : Tにおける α : Dび β : D0 を下記のように定める。

[0075]

【数13】 $\alpha_1 + \beta_1 = 2 + \delta_1$ $\alpha_i + \beta_i = 2 \qquad (2 \le i \le m-1)$ $\alpha_n + \beta_n = 2 + \delta_2$

(ただし、 δ_1 及び δ_2 は、それぞれ順に、 $-0.5 \leq \delta$ $_1 \le 0$. 5、及び−1 $\le \delta_2 \le 1$ を満足する実数である。 また、L=2の場合には、 α_1 、 β_1 、 α_n 及び β_n のみが 存在するものとする。)

一方、nが奇数、つまりマーク長がnT=(2L+1) Tのマークの記録に際しては、分割数m=L個の区間に 10 分割し、記録パルス区間 α₁, T及びオフパルス区間 β_i , Tにおける α_i , 及び β_i , を下記のように定め

[0076]

【数14】 α_1 '+ β_1 '=2.5+ δ_1 ' $\alpha_i' + \beta_i' = 2 \quad (2 \leq i \leq m-1)$ $\alpha_{\bullet}' + \beta_{\bullet}' = 2 \cdot 5 + \delta_{2}'$

(ただし、 δ_1) 及び δ_2) は、それぞれ順に、-0.5 $\leq \delta_1$ ' ≤ 0 . 5、及び $-1 \leq \delta_2$ ' ≤ 1 を満足する実数 である。また、L=2の場合には、 α_1 '、 β_1 '、 α , 及び β , のみが存在するものとする。) そして、バルス発生方法2においては、さらに下記式を 満足させる。

[0077]

【数15】

 $\alpha_1 + \beta_1 + \alpha_2 + \beta_2 + \Delta = \alpha_1' + \beta_1' + \alpha_2' + \beta_2'$ $(227, \Delta = 0.8 \sim 1.2753)$ なお、上記パルス発生方法2では、 α_i 、 β_i 、 α_i 、 β_1 , δ_1 , δ_2 , δ_1 , δ_2 , δ_3 , に応じて変化していてもよい。パルス発生方法2におい 30 Tは、n=2 L及びn=(2L+1) の記録マークの形 成に際しては、同じ分割数し個の記録パルスに分割して 記録を行う。つまり、nが順に2,3,4,5,6, 7, 8, 9、・・・・の場合、それぞれ、分割数mを順 に1, 1, 2, 2、3, 3, 4, 4, ・・・とする。 具 体的には、EFM変調信号では、n=3、4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11に対して、分割数mを順にm= 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 et a. etc. E FM+信号では、n=14が加わるが、その場合には分 割数mは7とする。(1, 7) RLL-NRZI変調で は、n=2の場合があるが、この場合分割数mは1とす る。

【0078】パルス発生方法2においては、同じ分割数 m=Lの2つの長さの異なる記録マークの間では、先頭 のパルス周期 $(\alpha_1 + \beta_1)$ Tと最後端の周期 $(\alpha_1 + \beta_2)$ β 。) Tとのみが異なっている。すなわち、 $(\alpha_1 + \beta_1)$ $+\alpha \cdot +\beta \cdot \cdot$ に対して $(\alpha_1' +\beta_1' +\alpha \cdot \cdot' +\beta \cdot \cdot')$ を、 Δ (ここで、 $\Delta=0$. 8 \sim 1. 2である) だけ大き くする。 Δ は通常 1 であるが、前後の記録マークとの熱 干渉の影響を考慮して0.8~1.2程度の範囲で変化 50 値とするのが好ましい。即ち、中間のパルスが存在しう

させることができる。

【0079】 δ_1 及び δ_2 並びに δ_1 , 及び δ_2 , は、それ ぞれ、各マーク長が正確にnTになるため、及び、マー ク端のジッタを低減するために調整され、通常-0.5 $\leq \delta_1 \leq 0$. $\delta_2 = 0$. $\delta_3 \leq \delta_4 \leq 0$. $\delta_3 = 1 \leq \delta_2$ ≤ 1 及び $-1 \leq \delta_1$ ' ≤ 1 である。好ましくは前端と後 端とでその補正量をほぼ同程度とする、つまり、 | δ₂ $/\delta_1$ |、及び | δ_2 ' $/\delta_1$ ' | がそれぞれ 0. 8~ 1. 2であることが好ましい。

24

【0080】また、同じ分割数の2つの記録マークのマ ーク長の差1Tは、前端側で約0.5T、後端側で約 0. 5 T分それぞれ差をつけることによって形成するの が好ましい。即ち、

[0081]

【数16】 $\alpha_1 + \beta_1 + \Delta_1 = \alpha_1' + \beta_1'$ $(\hbar k l) \Delta_1 = 0.4 \sim 0.6$ とするのが好ましい。この場合、後端側は通常、

[0082]

20

【数 1 7 】 $\alpha_1 + \beta_2 + \Delta_2 = \alpha_1' + \beta_1'$

(ただし、 $\Delta_2 = 0$. 4~0. 6であって、 $\Delta_1 + \Delta_2 =$ Δ) となる。

【0083】この中でも、特に、 δ₁ =約0及び δ₁' = 約0とすると、マーク前端に同期して各分割パルスを発 生させるような回路が使用できるので特に好ましい。マ ーク前端の位置はほぼ α₁ Tにおける記録パワーレーザ 一光の立ち上がりで決まり、そのジッタは、 α , と β , の デューティー比や α_1 , と β_1 , のデューティー比で決ま るので、この方法において $\delta_1 = 0$ 、 δ_1 ' = 0. 5とし てもマーク前端位置及びそのジッタは良好に制御するこ とができる。

【0084】マーク後端位置は、δ₂(及びδ₂')即 ち、マーク最後端の分割パルス周期 (α₀ + β₁) T (及 び $(\alpha_{\bullet}' + \beta_{\bullet}')$ T) の値にも、 α_{\bullet} と β_{\bullet} のデューテ ィー比(及び α _a'と β _a'のデューティー比)の値にも 依存する。また、マーク後端位置は、最後端の記録パル ス α _• T (及び α _•'T) の立下り位置や、その前後での 記録層温度の冷却過程にも依存する。特に、非晶質マー クを形成する相変化媒体においては、記録層の冷却速度 に大きな影響を与える最後端のオフパルス区間β.T

(及び β ・'T) の値に依存する。従って、最後端の分 割パルスの周期 $(\alpha_+ + \beta_+)$ Tは、必ずしも、0.5T や1 Tになる必要はなく、0.1 T好ましくは0.05 Tより好ましくは0.025T程度の分解能で微調整を することができる。

【0085】パルス発生方法2においては、 α ; と β ; と のデューティー比 α_i / $(\alpha_i + \beta_i)$ は、それぞれのマ ーク長でそれぞれ最適化することができるが、パルス発 生回路の簡便化のために、先頭のパルス及び最後尾のパ ルスの間にある中間のパルスにおいては、これらを一定

る L \geq 3 の場合、同じ分割数m = L o 2 種類の記録マークにおける 2 以上(m - 1)以下の全ての i に対して、 $\alpha_i = \alpha c$ (一定値)及び α_i ' = αc '(一定値)とするのが好ましい。 さらに、L が 3 以上の場合に、 α c 及び α c 'をともにLによらない一定値、特に α c = α c 'としてLによらない一定値とすると、回路がさらに簡略化できて好ましい。

25

【0086】パルス発生方法2におけるパルス発生回路の簡便化のために、nが偶数の記録マークにおいて、 α ,及び β ,が、3以上のすべてのLに対してそれぞれ一定 10の値をとるのが好ましい。特に、2以上のすべてのLに対して、 α , + β , を2とすると、1から(m-1)のすべての i に対して、周期(α , + β ,) Tが2 Tとなるので、特に好ましい。

【0089】前述のように、パルス発生方法2においては、特に $\delta_1 = \delta_1$ '=0とするのが好ましい。この場合、周期Tを有する第1基準クロック1と第1の基準クロックに対して0.5 Tだけずれた同じ周期Tを有する第2基準クロック2とを用いて、第1基準クロック1を分周して得られる周期2Tの分周第1基準クロック3に同期させて α_i ($1 \le i \le m$)を発生させ、第2基準クロック2を分周して得られる周期2Tの分周第2基準クロック4に同期させて α_i '($2 \le i \le m$)を発生させるとともに、 α_1 'を α_2 'の立ち上がりに2.5 T先行して立ち上がるようにパルス発生回路を制御するのが好ましい。この複数の基準クロックを用いる方法によって、パルス発生回路を簡便化することができる。

【0090】なお、αι及びαι'の立ち上がりを、記録すべきマーク長に従って変調された方形波の立ち上がりまたは立下りに対して、遅延あるいは先行させる必要がある場合があるが、この場合、マーク間の長さを一定にするために同一の遅延時間Tωを付加することが好まし 50

【0091】図12において、200は周期Tの基準クロックをあらわす。図12(a)は、長さnTの記録マークに対応したパルス波形であり、符号201が長さ2LTの記録マークの長さ、符号202が(2L+1)Tの記録マークの長さに対応する。図12(a)においては、L=5の場合が示してある。図12(b)は、n=2L(=10)の場合の分割記録パルスの波形であり、図12(c)は、n=2L+1(=11)の場合の分割記録パルスの波形である。

【0092】図12(b)において、周期2Tの分周第1基準クロック205は、周期Tを有する基準クロック200に対して位相の遅れが0である第1基準クロック203を分周して得られる。 $\alpha_i + \beta_i = 2$ であるため、各記録パルス区間 α_i T(1 $\leq i \leq m$)の立ち上がりは、周期2Tの分周第1基準クロック205に同期している。この分周第1基準クロック205に同期している。この分周第1基準クロック205に同期して、 α_i と β_i のデューティー比を調節して、記録パルス波形207を得る。

【0093】一方、図12(c)においては、周期2Tの分周第2基準クロック206は、基準クロック200に対して0.5Tの位相のずれを有する周期Tの第2基準クロック204を分周して得られる。各記録パルス区間 α_i T(2 \le i \le m)の立ち上がりは、周期2Tの分周第2基準クロック206に同期している。 α_i + β_i = 2.5であるため、 α_i Tのみが0.5T先行して立ち上がる。この分周第2基準クロック206に同期して、 α_i と β_i のデューティー比を調節して、記録パルス波形208を得る。

【0094】ここで、図12においては、マーク長2L Tと(2L+1) Tとを、そのマーク後端がT2及びT 4において一致するように描いているので、周期2Tの 基準クロック205及び206の関係は(b)及び (c)の2通りしかないが、実際に2T周期の基準クロックを用いた場合、各マーク長の前端位置は、その位相

に関して1T分のずれが生じうる。また、nが偶数か奇数であるかに応じて、図13(a)、(b), (c)、

(d)に示すように4通りの関係がありうる。そこで、

(15)

これに対応するゲート発生方法として、以下のような方 法を採用するのが好ましい。

27

【0095】図13は、上記ゲート発生方法を説明する ためのタイミングチャートである。図13のゲート発生 方法は、(1)記録トラック上に所定の位置に形成され たクロックマークに対応した基準時間 Tsync を発生さ せ、(2) 基準時間 Tsmc を起点として遅延時間 Tal を もって発生された周期2Tの基準クロック1aと、該基 準クロック1aに対して0.5Tの先行した周期2Tの 基準クロック2aと、該基準クロック1aに対して1T 先行した周期2Tの基準クロック1bと、該基準クロッ ク1aに対して1.5T先行した周期2Tの基準クロッ ク2bとの4種の基準クロックを発生させるとともに、 (3) nT = 2LTなるマークの記録に際しては、基準 クロック1a及び1bのいずれかに同期させて、α i T、αi T (2 ≤ i ≤m-1)、α. Tの発生区間に対 応したタイミングのゲートの一群Gla、Glbを発生 させ、(4) nT=(2L+1) Tなるマークの記録に 際しては、基準クロック2a及び2bのいずれかに同期 させて α_i ' T、 α_i ' T ($2 \le i \le m-1$)、 α_i ' T に対応したタイミングのゲートの一群G2a、G2bを 発生させる方法である。

【0096】図13において、符号300は、周期下の基準クロック(データの基準クロック)である。通常記録システムは、記録媒体の特定のアドレスにデータを記録するために、アドレスの最小単位ごとに媒体上に配置されたクロックマークで発生された同期信号 Tsme (例えば、媒体上に凹凸ピット列として形成され、セクタごとに配置されたVF〇等の同期信号や、媒体上に溝蛇行として形成されたATIPフレーム(1/75秒)ごとに配置された同期パターン)と、あらかじめ生成した周期Tの基準クロックとを位相比較して同期を達成する。

【0097】図13に、マークの前端が、T_{sync} を基準としてTの偶数周期分経過した場合の例として、nが偶数の偶数マーク長301(図13(a))と、nが奇数の奇数マーク長304(図13(d))とを示す。一方、T_{sync} を基準としてTの奇数周期分経過した場合の例として、nが偶数の偶数マーク長302(図13

(b) と、nが奇数の奇数マーク長303 (図13

(c))とを示す図13の(a)~(d)のそれぞれの場合で、図12の説明と同様の、位相が0.5ずつずれた基準クロックを発生させると、それぞれ、符号305、符号306、符号307及び符号308で示される4つのクロック系列が生まれる。即ち、基準クロック305を基準として、それから0.5Tずれたクロック307、1Tずれたクロック306、1.5Tずれたクロック308がベースとなる。これらのクロックは、すべてT_{sme}を起点とする周期Tの基準クロックを分周した後、0.5Tずつ位相をずらして形成される。

【0098】そして、図13 (a) の場合には、周期P 50 はG2aを選択する。その結果、4種の0.5 Tずつ位

1a、P2a、P3a、P4a、及びP5aのそれぞれに同期して、記録パルス区間 α_1 T, α_2 T, α_3 T, α_4 T, α_5 Tに対応するゲート群G1a を生成する。図13 (b) の場合には、周期P1b、P2b、P3b、P4b、及びP5bのそれぞれに同期して、記録パルス α_1 T, α_2 T, α_3 T, α_4 T, α_5 Tに対応するゲート群G1b を生成する。

【0099】図13 (c) の場合には、周期R1a、R2a、R3a、R4a、及びR5aのそれぞれに同期して、記録パルス α_1 ' T, α_2 ' T, α_3 ' T, α_4 ' T, α_5 ' Tに対応するゲート群G2aを生成する。さらに、図13 (d) の場合には、周期R1b、R2b、R3b、R4b、及びR5bのそれぞれに同期して、記録パルス α_1 ' T, α_2 ' T, α_3 ' T, α_4 ' T, α_5 ' Tに対応するゲート群G2bを生成する。

【0100】ここで、これらの記録パルス発生用のゲート群G1a、G1b、G2a、及びG2bは、図1において、Gate1、2及び4を合成したものと同等である。即ち、ゲート群G1a 及びG1b を生成するにあたり、図1において、先頭パルス α : T を生成するGate1、中間パルス群 α : T ($2 \le i \le m-1$) 生成するGate2、および最後尾のパルス α . T を生成するGate4 を別々に生成し、これを合成する。また、ゲート群G2a 及びG2b を生成するにあたり、図1において、先頭パルス α : T 、中間パルス群 α : T ($2 \le i \le m-1$)、および最後尾のパルス α . T を別々に生成し、これを合成する。

【0102】各ゲート群G1a、G1b、G2a、及びG2bは、下記のように選択される。まず、Tsync を基準として、周期Tの基準クロック300の時間の起点を定め、周期Tのクロックが偶数周期あるいは奇数周期のいずれかを経過してからマーク長nTが立ち上がるかを判定する。具体的には、例えば、Tsync でリセットされた、1ビットの加算器を利用して、1周期ごとに1を加算し、結果が0ならば偶数周期、結果が1ならば奇数周期と判定する。即ち、基準時間Tsync からnTマークの前端までの経過時間がTの偶数倍であれば、nが偶数であるか奇数であるかに応じてゲート信号群G1aもしくはG2bを選択し、基準時間Tsync からnTマークの前端までのの経過時間がTの奇数倍であれば、nが偶数であるか奇数であるかに応じてゲート信号群G1bもしくけG2aを選択する。その結果 4種の0.5Tずつ位

相の異なる周期2Tの基準クロック群の組み合わせで、 T。を起点として生成される一連のnTマークのすべて の記録パルスを生成できる。

【0103】一方、オフパルス区間との長さと消去パワ ーPeの光を照射する区間とを決定するためには、マー ク最後尾のオフパルス区間β.Tに留意する必要があ る。即ち、マーク後端の周期を2Tではなくこれに±1 T程度の範囲の任意性をもたせるのが好ましいが、この 場合には、最終のオフパルスβ もしくはβ 'のタイミ ングを、例外的に規定すればよい。そのためには、図1 のGate3に相当するゲート信号を発生させるのが好 ましい。例えば、nTマークの前端を基準として、nが 偶数であるか奇数であるかに応じて、nが偶数の場合に は T_a の遅延後 Σ ($\alpha_i + \beta_i$) なるゲートG3を発生さ せるか、n が奇数の場合には T_a の遅延後 Σ (α_i) + β_i) なるゲートG4を発生させ、nTマークの前端 位置が、(1) G3ないしはG4のいずれもがオフであ る期間はパワーPeの光が照射し、(2) G3ないしは G4のいずれかがオンである場合にはパワーPbの光が 照射され、かつ、(3) G3とG1aとが同時にオンで 20 ある場合には、G1aオン区間に対応してPwのパワー の光を照射し、(4) G3とG1bとが同時にオンであ る場合には、G1bオン区間に対応してパワーPwの光 を照射し、(5) G4とG2aとが同時にオンである場 合には、G2aオン区間に対応してパワーPwの光を照 射し、(6) G4とG2bとが同時にオンである場合に は、G2bオン区間に対応してパワーPwの光が照射さ れるようにする。

【0104】このようなゲートの優先関係は、ゲートの オン/オフを論理的な0,1レベルに対応させて、各ゲ ート制御の論理信号の和演算を行うことによって達成さ れる。なお、図12及び13においては、簡略化のた め、最前端の記録パルス α_1 T、 α_1 Tの立ち上がり は、nTマークの前端、すなわち、記録すべきnTマー クの前端に対して同時である場合を示した。もしも遅延 を有する場合は、すべてのしのとり得る値に対して、記 録パワーのパルス α_1 T及び α_1 'Tの立ち上がりが同一の 遅延時間Talを有するようにするのが、マーク間長を所 望の長さに保つ上で好ましい。

(分割記録パルス発生方法3)以下の方法は、基準クロ 40 ック周期Tを分周して得られる、周期2Tのクロック信 号をベースとする分割記録パルス発生方法のもう一つの 例であり、やはり分割記録パルス発生方法1より規則正 しいルールに基づいて、論理回路の設計が可能となる方 法である。

【0105】具体的には、パルス発生方法2と同様に、 n Tマークのnのとり得る値が奇数であるか偶数である かに分けて考える。分割記録パルス発生方法2において は、分割数が同じ偶数長マークと奇数長マークのマーク 分散して割り当てたが、パルス発生方法3においては、 マーク長1Tの補正を中間分割記録パルス群のオフパル ス長 β : T (2 \leq i \leq m - 1) の調整にて行う。

【0106】即ち、nが偶数、つまりマーク長がnT= 2 L T (ただし、Lは2以上の整数) のマークの記録に 際して、分割数m=L個の区間に分割し、記録パルス区 間 α , T及びオフパルス区間 β , Tにおける α , 及び β , を 下記のように定める。

[0107]

【数18】 $T_{4i} + \alpha_1 = 2 + \epsilon_1$

 $\beta_{i-1} + \alpha_i = 2$ $(2 \le i \le m)$ 一方、nが奇数、つまりマーク長がnT= (2L+1) Tのマークの記録に際して、分割数m=L個の区間に分 割し、記録パルス区間 α '、T及びオフパルス区間 β '、

Tにおける α' ,及び β' ,を下記のように定める。

[0108]

【数19】 $T_{a1}' + \alpha_1' = 2 + \varepsilon_1'$

 $\beta_1' + \alpha_2' = 2. 5 + \epsilon_2'$

 β_{i-1} ' + α_i ' = 2 (3 \leq i \leq m-1)

 $\beta_{\bullet 1}$ ' $+\alpha_{\bullet}$ ' = 2. $5+\epsilon_3$ '

(ただし、L=2の場合には、 β_1 '+ α_2 '=2.5+ ϵ_2 ', ϵ_3 ', ϵ_4 ', ϵ_5 ', ϵ_6 ', ϵ_7 ', ϵ_8 \mathcal{L} \mathcal{L} β₋₁ '、及びα₋'が下記式を満足する。

[0109]

【数20】 $\beta_1 + \alpha_2 + \beta_{-1} + \alpha_1 + \Delta_2 = \beta_1' + \alpha_2'$ $+\beta=1'+\alpha=$

 $(227, \Delta_2 = 0.8^2 \cdot 1.2753.)$

 $\Xi\Xi C$, α_i , β_i , α_i , β_i , T_{di} , T_{di} , ει、ει'、ε2'及びε3'の値は、Lに応じて変わり うる。

【0110】Ta 及びTa 'は、マーク長変調された元 信号におけるnTマークの始端から、先頭の記録パルス αιTが立ち上がるまでの先行もしくは遅延時間であ り、通常-2以上2以下の実数である。 Tai 及びTai ' が正の値ならば、遅延を意味する。 Tai 及びTai 'は、 Lによらずほぼ一定とするのが好ましい。α_i、β_i、αi'、及びβi'は、それぞれ通常 0 以上 2 以下の実数で あり、好ましくはそれぞれ0.5以上1.5以下であ る。

 $\{0111\}_{\epsilon_1,\epsilon_1',\epsilon_2',\mathcal{B}}$ 、及び ϵ_3' は、いずれ も通常-1以上1以下の実数であり、より好ましくはい ずれも-0.5以上0.5以下である。これらは、周期 2 Tを形成する分割パルス周期 (β_{i}) $+ \alpha_{i}$) Tにおい て、正確なマーク長あるいはスペース長を実現するため の補正値として必要に応じて用られる。パルス発生方法 3においては、Lが等しいn=2LT及びn=(2L+ 1) Tに対応する2つのマークに対しては、等しい分割 数しの記録パルスに分割して記録を行う。つまり、n= 長差1 Tの補正を、先頭及び最後尾の記録パルス周期に 50 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9、・・・・、に対し

20

31

て、それぞれ、記録パルスの数を1, 1, 2, 2、3, 3, 4, 4, 5, 5、・・・とする。例えば、EFM変調信号では、n=3、4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11に対して、分割数mを順に1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5とする。EFM+信号では、これにn=14が加わるが、その場合には分割数mを7とする。(1, 7)RLL-NRZI変調では、n=2の場合もm=1とする。

【0112】同一分割数でn=2L及び2L+1の2種類のマーク長を記録するために、周期($\beta_1+\alpha_2$) T、及び周期($\beta_{\bullet + 1}+\alpha_{\bullet}$) Tをそれぞれ0.5 Tずつ増減して長さを調整する。マーク長記録において重要なのは、マーク前後端の波形で決まるマーク端の位置とジッタであり、マークの中間部分は振幅のみ得られていれば、マーク端のジッタには大きな影響がない。上記の調整方法は、マークが光学的に分割されて見えない限り、マーク中間部での記録パルス周期を0.5 T伸縮させても、その分、マーク長が伸縮変化するのみで、マーク端でのジッタには大きくは影響しないことを利用している。

【0113】パルス発生方法3においては、記録パルス の周期はいずれのマーク長でも2Tをベースとする。 α ;とβ;のデューティー比は、各マーク長ごと或いはiご とにそれぞれ最適化できるが、記録パルス発生回路の簡 便化のために以下のような制限を設けておくことがより 好ましい。まず、マーク前端に関しては、α₁、β₁、α1'及びβ1'は、3以上のLに対して、Lによらずそれ ぞれ一定とするのが好ましい。より好ましくは、α.' $=0.8\alpha_1 \sim 1.2\alpha_1$ 、及び $\beta_1'=\beta_1+約0.5$ と する。 さらに好ましくは、 $\beta_1' = \beta_1 + 0.5$ 、 $\alpha_1 =$ α_1 、且の $\beta_1 = \beta_1$ とする。マーク前端の位置はほ ぼ先頭の記録光の立ち上がりで決まる。つまり、α,Τ $=\alpha_1$ Tの立ち上がり位置を、マーク長nTの始端に 対して、一定の遅延時間Talとしておけば、実際のマー クの前端の位置はほぼ一義的に決まる。一方、マーク前 端のジッタは、 α , Tが α , $^{\prime}$ Tとほぼ同じとしても、 β 1 Tがある程度(実際上0.5T)以上の長さであれ ば、 β_1 , β_2 , β_3 , β_4 , β_3 , β_4 よらず良好な値が得られる。

は一定の時間差をもって同期することが望ましい。マーク後端の位置は、最後端の記録パルス α 。T(もしくは α 。'T)の立下り位置のみならず、その前後での記録層温度の冷却過程にも依存する。特に非晶質マークを形成する相変化媒体では、最後端のオフパルス区間 β 。T(もしくは β 。'T)によって制御される記録層温度の冷却速度に依存する。従って、 α 。T及び α 。'Tが α T マークの後端に対して、一定の時間だけずれており、 β 。'= β 。であれば、マーク後端位置はほぼ一義的に決まる。

【0117】 さらなるパルス発生回路の簡便化のために、Lが3以上の場合には、 $2 \le i \le m-1$ なるiに対して、 α_i 、 α_i 'をそれぞれiによらず一定値とする、つまり、

[0118]

【数21】 $\alpha_2 = \alpha_3 = \cdots = \alpha_{r-1}$ $\alpha_2' = \alpha_3' = \cdots = \alpha_{r-1}$

ひとするのが好ましい。ここで、Lが3以上とは、分割数が3以上であり、マーク先頭と最後尾の分割パルスを除いて、1以上の中間分割記録パルスが存在するための条件である。

β1, と同じ値を用いることが好ましい。

【0121】このような分割記録パルスは、0≦T』≦ 2、0≦Tai ′≦2の場合、例えば以下のようにして生 成することができる。まず、(1)周期Tの第1の基準 クロックに同期して、元になるマーク長変調信号が生成 されているものとする。マーク長変調信号のnTマーク の始端を基準としてTal (あるいはTal) 遅延して、 先頭記録パルス α_1 T(あるいは α_1) T)を生成し、

33

(2) 次いで、n Tマークの後端と ɛ₃ (あるいは ٤3')時間差をおいてたち下がりが一致するによう に、最後尾記録パルス α T (α T) を生成する。そ して、(3) Lが3以上の場合に存在する中間分割記録 パルスである、 α_i T、 β_i T(2 \leq i \leq m-1)は、n が偶数 (n=2L) の場合には、nTマークの始端から、4 T後に α_2 Tがたち下がり、以後、 $\alpha_i + \beta_{ii}$ が 2 T 周期となるように生成させ、(4) n が奇数(n= 2L+1) の場合には、nTマークの始端から、4.5 T後に α_2 , Tがたち下がり、以後 α_i , + β_{i-1} , が2 T周期となるように生成する。

【0122】上記の例では、ει、ει'、ει'、εз'、εз' がそれぞれ0でない場合にも、少なくとも中間分割記録 パルス群の α_2 Tあるいは α_2 Tの立ち下がりが、正確 にnTマークの始端から、4Tあるいは4.5Tのいず れかの遅延時間をおいて発生させている。このため、少 なくとも中間分割記録パルス群は、あらかじめ周期Tの 基準データクロックを分周して生成された周期2Tの基 準クロックに同期して生成できる。

【0123】図24は、かかる周期2Tの複数の基準ク ロックの組み合わせで、本記録パルス分割方法を実施す る場合の、各記録パルスの関係を示した図である。図2 4では、簡便化のために、記録パルス区間に照射する光 の記録パワーPwや、オフパルス区間に照射する光のバ イアスパワーРЬ、及びそれら以外の区間で照射する光 の消去パワーPeは、それぞれいずれのiでも一定とし て描いており、且つある。Pb<Pe<Pwとして描い ているが、これらの値は、nやiに応じて異なる値にで きる。特に α_1 T、 α_1 Tにおける記録パワーPw₁、及 $T(i=2\sim m-1)$ における記録パワー Pw_i とは異 なる値に設定されることがある。

【0124】また、図24ではやはり、簡便化のため に、 $\epsilon_1 = \epsilon_1' = \epsilon_2' = \epsilon_3' = 0$ とし、記録すべき n Tマークの前端に対して2T後に最先端の記録パルスα $_{1}$ T、及び α_{1} Tがたち下がるとし、また、 α_{n} T, α、Tの立下りがnTマークの後端と一致するとして 描いている。図24において、220は周期Tの基準ク ロックをあらわす。

【0125】図24 (a) は元になるマーク長変調信号 のnTマークに対応した方形波の波形であり、221が 長さ2LT、222が(2L+1) Tのマークに対応す 50 応するゲート群G1aを生成し、(1b)の場合には、

る。ここでは、具体的にL=5に対応するの2種類の場 合が記載されているが、Lが1増減するごとに、中間の $2 \le i \le m-1$ に対応する、周期 2 T を差し引きすれ ば、他の場合も同様に扱うことができる。

34

【0126】図24 (b) は、n=2L=10の場合の 分割記録パルスの波形であり、図24(c)はn=2L +1=11の場合の分割記録パルスの波形である。図2 4 (b) では、周期2Tの基準クロック225は周期T の基準クロック220に対して位相の遅れが0である周 期Tの基準クロック223を分周して得られる。Tu+ $\alpha_1 = 2$ である場合、各記録パルス α_i T $(1 \le i \le m)$ の立ち下がりは、周期2Tの基準クロック225に同期 している。かかる周期2Tのクロック225に同期し て、 α , β , のデューティー比を調節して、記録パルス 波形227が得られる。

【0127】図24 (c) では、周期2Tの基準クロッ ク226は周期Tの基準クロック220に対して0.5 Tの位相のずれを有する周期Tの基準クロック224を 分周して得られる。各記録パルスα; T (2≦i≦ m) の立ち下がりは、周期2Tの基準クロック226に 同期している。基準クロック226に同期して、β:-1 とα; のデューティー比を調節して、記録パルス波形2 28が得られる。

【0128】このように、周期Tの第1の基準クロック 1 (223) と、及び周期Tで第1の基準クロックに対 して0.5Tだけずれた周期Tの第2の基準クロック2 (224) とを用いて、基準クロック1を分周して得ら れる周期2Tの基準クロック3(225)に同期させ T、 α i (1 \leq i \leq m) を発生させ、基準クロック2を 分周して得られる周期2Tの基準クロック4(226) に同期させて、 α_i '(2 \leq i \leq m-1)を発生させる ことによって、2L及び2L+1に対応した分割記録パ ルスを容易に生成できる。

【0129】図24では、マーク長2LTと(2L+1) Tとを、そのマーク後端がT2及びT4において一致す るように描いているので、周期2Tの基準クロック22 5及び226の関係は(b)及び(c)の2通りしかな いが、実際に2T周期の基準クロックを用いた場合、各 マーク長の前端位置は、2 T周期に同期はしていても位 40 相に関しては、1 Tのずれが生じうる。従って、さらに nが偶数か奇数であるかに応じて、分割記録パルス発生 方法2において図13(a)、(b), (c)、(d) に示すしたように4通りの関係がありうることを考慮し なければならないことは、分割記録発生方法3において も同様である。

【0130】そして、図13の周期2Tのクロック4系 列を利用して、(1a)の場合には、周期P1a, P2 a, P3a, P4a, P5aのそれぞれに同期して、記 録パルス区間 α_1 T, α_2 T, α_3 T, α_4 T, α_5 Tに対

30

40

35

周期P1b, P2b, P3b, P4b, P5bのそれぞ れに同期して、記録パルス α_1 T, α_2 T, α_3 T, α T, αs Tに対応するゲート群G1bを生成し、(2) a) の場合には、周期Rla, Rla, Rla, Rla, Rla a, R5aのそれぞれに同期して、記録パルスα」 T, α_2 ' T, α_3 ' T, α_4 ' T, α_5 ' Tに対応するゲ ート群G2aを生成し、(2b)の場合には、周期Q1 b, Q2b, Q3b, Q4b, Q5bのそれぞれに同期 して、記録パルス α_1 'T, α_2 'T, α_3 'T, α_4 ' Τ, αs' Τに対応するゲート群G2bを生成する。 【0131】ここで、これらの記録パルス発生用ゲート 群Gla, Glb, G2a, G2bは、図1において、 Gate1、2、4を合成したものと同等であることも 分割記録発生方法2の場合と同様である。つまり、G1 a及びG1bを生成するにあたり、図1のように、先頭 パルスα, Tを生成するGate1、中間パルス群α, T (2≤ i ≤m-1) 生成するGate 2、および最後尾 のパルスα. Tを生成するGate4を別々に生成し、 これを合成する。あるいは、G2a及びG2bを生成す るにあたり、図1のように、先頭パルスα1'Τ、中間 パルス群αi'T (2≦i≦m-1)、および最後尾の パルス α 。' Tを別々に生成し、これを合成する。 ϵ ₁、 ει'、ε2'、ε3'が0でない場合は、先頭記録パル スα₁T, α₁'Tに対して周期Pla, Qla, Pl b、Q1bのいずれかで所定の時間差を加えて発生さ せ、最後尾記録パルス α . T, α . Tに対して周期P5 a, P5b, Q5a, Q5bのいずれかで所定の時間差 を加えて発生させればよい。

【0132】一方、オフパルス区間とPe照射区間とを 決定するためには、マーク最後尾のβ_•Tが変則的であ ることに留意する必要がある。すなわちマーク後端の周 期が必ずしも2Tとはならず、かつ、2T±1T程度の 任意性をもたせる必要があるが、これは、最終のオフパ ルスβ。もしくはβ。'を例外的に規定すればよい。その ためには、図1のGate3に相当するゲート信号を発

【0133】すなわち、nが偶数である場合は、nTマ ークの前端を基準として、遅延時間Ta の経過後、Σ $(\alpha_i + \beta_i)$ TなるゲートG3を発生させ、nが奇数で ある場合には、nTマークの前端を基準として、遅延時 間 T_{ai} ′ の経過後、 Σ (α_i ′ + β_i ′) T なるゲートG4を発生させる。そして、G3ないしはG4のいずれも がオフである場合は消去パワーPeの光を照射し、G3 ないしはG4のいずれかがオンである場合にはバイアス パワーPbの光を照射し、且つ、G3とG1aが同時に オンである場合には、Glaオン区間に対応して記録パ ワーPwの光を照射し、G3とG1bが同時にオンであ る場合には、G1bオン区間に対応して記録パワーPw の光を照射し、G4とG2aが同時にオンである場合に は、G2aオン区間に対応して記録パワーPwの光を照 50

射し、G4とG2bが同時にオンである場合には、G2 bオン区間に対応して記録パワーPwの光を照射する。 このようなゲートの優先関係は、ゲートのオン/オフを 論理的な0,1レベルに対応させて、各ゲート制御の論 理信号の和演算を行えばよい。

【0134】以上をまとめると、(1)記録トラック上 に所定の位置に形成されたクロックマークに対応した基 準時間 T sync を発生させ、(2) 基準時間 T sync を起点 として発生された、周期2Tの基準クロック1aと該基 10 準クロック1aに対して0.5Tの先行した周期2Tの 基準クロック2aと、該基準クロック1aに対して1T 先行した周期2Tの基準クロック1bと該基準クロック 1 a に対して1. 5 T 先行した周期 2 T の基準クロック 2 b との 4 種の基準クロックを発生させると共に、

(3) nT=2LTなるマークの記録に際して、基準ク ロック1a及び1bのいずれかに同期させて、α,T、 $\alpha_i T$ (2 $\leq i \leq m-1$)、 $\alpha_n T$ の発生区間に対応した タイミングのゲートの一群Gla及びGlbを発生さ せ、(4) nT=(2L+1) Tなるマークの記録に際 して、基準クロック2a及び2bのいずれかに同期させ $T\alpha_i$ ' T、 α_i ' T ($2 \le i \le m-1$)、 α_i ' Tに対 応したタイミングのゲートの一群G2a及びG2bを発 生させることで、記録パルス区間α; Tを発生するため のゲートのすべてを生成することができる。

【0135】各ゲート群Gla, Glb, Gla、Gl bは下記のようにして選択することができる。まず、基 準時間 Tsync を基準として、周期 Tのクロックが偶数周 期あるいは奇数周期のいずれかを経過してからマーク長 n Tが立ち上がるかを判定する。具体的には、例えば、 基準時間Tsync でリセットされた1ビットの加算器を利 用して、1周期ごとに1を加算し、結果が0ならば偶数 周期、結果が1ならば奇数周期と判定できる。 すなわ ち、基準時間Tsmc からnTマークの前端までの経過時 間がTの偶数倍であれば、nが偶数であるか奇数である かに応じてゲート信号群G1aもしくはG2bを選択 し、基準時間Tsync からnTマークの前端までのの経過 時間がTの奇数倍であれば、nが偶数であるか奇数であ るかに応じてゲート信号群G1bもしくはG2aを選択 する、このようにすれば、4種の0.5 Tずつ位相の異 なる周期2Tの基準クロック群の組み合わせで、Toを 起点として生成される一連のnTマークのすべての記録 パルスを生成できることになる。

【0136】以上の分割記録パルス発生方法1、2及び 3に従えば、少なくとも中間のパルス群の切り替え周期 $(\alpha_i + \beta_i)$ T又は $(\alpha_i + \beta_{i-1})$ T (ただし2 $\leq i \leq i$ m-1) は1T, 1.5T、2T、2.5Tいずれかで 一定とし、 α , と β , のデューティー比及び α , 'と β , ' のデューティー比を変化させることで、異なる特性を有 する媒体や、同一の媒体を異なる線速で使用した場合に も最適の分割記録パルスストラテジーを見出すことが容

易になる。

【0137】本発明の光記録方法は、特に結晶状態を未 記録・消去状態とし、非晶質マークを形成することで情 報のオーバーライトを行う相変化媒体において特に有効 である。本発明の光記録方法は、また、同一の媒体に対 して様々な線速で記録を行う場合にも有効である。一般 的に、複数の線速でクロック周期T及び線速vの積vT を一定として、線速によらず等密度の記録を行うことは 広く行われている。

【0138】例えば、同一の記録媒体に対して、v×T が一定の複数の線速度 v でマーク長変調方式による記録 を行う場合に、前記パルス発生方法2を用いる際、少な くとも2以上のLにおいて、2≦ i ≦m-1における $(\alpha_i + \beta_i)$ T、及び $(\alpha_i' + \beta_i')$ Tの周期を線速 によらず一定に保ち、さらに各 i における Pwi, P bi、及びPeも線速度によらずほぼ一定に保ち、且つ 低線速度ほどαi及びαi' (2≦i≦m)を減少させる (特開平9-7176号公報)。その結果、広い線速度 で良好なオーバーライトが可能となる。

【0139】また、同一の記録媒体に対して、v×Tが 一定の複数の線速度 v でマーク長変調方式による記録を 行う場合に、前記パルス発生方法3を用いる際、少なく とも2以上のLにおいて、2≦i≦mにおける(βin $+\alpha_i$) Tの周期及び(β_{i} , '+ α_i ') Tの周期を線 速によらず一定に保ち、さらに各iにおけるPwi, P bi、及びPeも線速によらずほぼ一定に保ち、低線速 ほど α :及び α : が単調に減少させる(特開平9-71 76号公報)のも有効である、この場合も、広い線速範 囲で良好なオーバーライトが可能となる。

【0140】上記2つの例において、Pwi, Pbi、及 びPeが線速度によらずほぼ一定であるとは、最小値が 最大値の概ね20%程度以内であることをいうが、より 好ましくは10%以内である。さらに好ましくは実質的 に全く線速によらず一定とすることである。上記2つの 例において、低線速ほど $(\alpha_i + \beta_i)$ Tにおける α_i を 減少させβ; を増加させたり、(α; + β;) Tにおけ るα:を減少させてβ: を増加させたりするのは、特に 相変化媒体において有効である。相変化媒体では、低線 速ほど記録層の冷却速度が遅くなるので、オフパルス区 間βιの比率を高めて、冷却効果を促進する必要がある からである。その場合、すべての使用線速度 v およびす べてのLに対して、で0. $5 < \beta_i$ 、 β_i ≤ 2 . 5、よ り好ましくは1 $\leq \beta_i$ 、 β_i ' \leq 2として、非晶質化のた めの冷却時間を確保することがより好ましい。

【0141】上記2つの例においては、さらに、すべて の線速度においてa: Tとa: 'T(2≤i≤m-1)と を一定とする、つまり、中間記録パルス群は記録パルス の絶対時間をほぼ一定とするのが好ましい。「ほぼ一 定」とは、各線速において±0.1 Tの範囲程度の幅を 有することを意味する。この場合、基準クロックTは線 50 の振幅(実際上11Tマークの振幅) 【11 を 1 いの で規

速が小さいほど大きくなるので、中間パルス群のαι、 α、' は必然的に単調減少する。先頭の記録パルス区間 微調整する。また、 β 、、 β 、' は、各線速ごとに微調整 を行うのが好ましい。この場合、 β 。、 β 。' 自体が一定 であるか、あるいは低線速になるほど大きくするのが好 ましい。

38

【0142】なお、以上の3つのパルス発生方法1、2 及び3において、記録可能DVDの1倍速(線速3.5 m/s、基準クロック周期Tは38.2ナノ秒)以上に 基準クロック周期Tが小さい場合には、さらに、先行及 び/又は後続マーク長もしくはスペース長に応じて、n - (n, + n,) や、先頭、最後尾パルスを制御するの が好ましい。

【0143】本発明が特に有効な具体的な場合としては 以下が挙げられる。まず、記録時の線速度が10m/s 以上と高速であって、かつ最短マーク長を0.8 μ m未 満と短くし、高密度に記録を行う場合である。なお、最 短マーク長は線速度をVとするとnT×Vで表されるか ら、最短マーク長が短いことは基準クロック周期Tを短 くすることに他ならない。

【0144】また、記録光の波長が500nm未満と短 く、記録光を集束させるためのレンズの開口数が0.6 以上と高く、記録光のビーム径が小さく、かつ、最短マ ーク長を 0. 3 μ m未満と短くし、高密度に記録を行う 場合も有効である。さらには、マーク長変調方式とし て、8-16変調方式もしくは(1、7)-RLL-N RZI変調方式といった、高密度記録用の変調方式を用 いた場合も有効である。

【0145】さらにまた、マーク長変調方式がEFM変 調方式であり、記録時の線速度をCDの基準線速度1. 2 m/s~1.4 m/s の10倍速以上と非常に高速と して、記録線密度を一定としながら記録を行う場合であ る。。さらにまた、マーク長変調方式をEFM+変調方 式という高密度記録用の方式とし、かつ、記録時の線速 度をDVDの基準線速度3.49m/sの2倍速以上の 高速として、記録線密度を一定としながら記録を行う場 合である。

【0146】次に、マーク長変調信号の品質について図 40 を用いて説明する。図5は、CD-RWをはじめとする CDファミリーで用いられるEFM変調信号の再生波形 (アイパターン)の模式図である。EFM変調では3T から11Tの長さの記録マーク長及びマーク間長をとり うるが、アイパターンには3Tから11Tのすべての非 晶質マークの再生波形が実質的にランダムに含まれてい る。なお、EFM+変調では、これにさらに14Tのマ ーク長及びマーク間長が含まれる。

【0147】アイパターンの上端 1 い を反射率に換算 したものが反射率の上端値R_{top} であり、アイパターン

格化たものが下記式で表される記録信号の変調度mmで ある。

* [0148] 【数22】

 $m_{11} = I_{11} / I_{10p} \times 100$ (%)

(1)

※比 (SN比) が低下してしまうため、下限は40%程度

m は40%以上80%以下とするのが好ましいが、特 に下限値40%以上とすることがより重要である。信号 振幅は大きいほうが好ましいが、大きすぎると信号再生 系のアンプのゲインが極端に飽和してしまうためmu 上 限は80%程度である。一方、小さすぎると信号体雑音※

【数23】

[0150]

As $y_m = (I_{alice} / I_{11} - 1/2)$ (%) (2)

【0149】さらに、下記式

0付近にあることが望ましい。

【0151】さらに再生信号の各マーク及びマーク間 (スペース) のジッタが基準クロック周期Tのおおむね 10%以下であり、かつマーク長及びマーク間がほぼ n T×V (Tはデータの基準クロック周期、nは3~11 までの整数、Vは再生時の線速度)の長さを有するのが 好ましい。これにより、通常の市販のCD-ROMドラ イブで低エラーレートで再生できることを意味する。一 方、EFM+変調方式を用いた記録可能なDVD媒体で は、 I 』を 14 Tマークの振幅 I 』に置き換えて(1) 式及び(2)式を定義する。また、ジッタは、アナログ 再生信号をイコライザを通して2値化した後の、いわゆ るエッジ・トゥ・クロックジッタとして測定する。この 場合、ジッタの値はクロック周期の13%以下、特に9 %以下とするのが好ましい。

【0152】次に、上記光記録方法を用いる際に好まし い光記録媒体について述べる。本発明による記録を行う 光記録媒体としては、色素系有機記録媒体、光磁気記録 媒体、相変化型記録媒体等各種の記録方式の媒体が採用 できる。また、ライトワンス型及び書き換え型いずれの 媒体にも採用できる。これらの中で特に顕著な効果が得 られるのは、相変化型記録媒体、特に結晶状態を未記録 状態として非晶質マークをオーバーライトする書き換え 型相変化型記録媒体である。

【0153】中でも、結晶化が結晶領域と溶融領域の境 界面から始まるタイプの記録層材料が好ましい。このよ うな、好ましい相変化媒体としては、SbTe共晶組成 にさらに過剰のSbを含有する記録層を有するものが挙 げられる。特に好ましくは、Sbn Ten 共晶点組成を 基本として過剰のSbを含み更にGeを含む組成であ る。この場合、特にSb/Te比は4以上とするのが好 ましく、またGe量は10原子%以下とするのが好まし い。具体的な記録層としては、M. Ge, (Sb. Te in)in 合金 (ただし、0≤z≤0.1、0<y≤ 0. 3, 0. 8 ≤ x, Mt, In, Ga, Si, Sn, Pb、Pd、Pt、Zn、Au、Ag、Zr、Hf、 V、Nb、Ta、Cr、Co、Mo、Mn、Bi、O、 N、Sから選ばれる少なくとも一種)組成を有する記録 層を有するものが挙げられる。

【0154】上記組成は、本合金は前述のように、Sb 50 【0157】一方で、この組成は、本発明において克服

で定義されるアシンメトリー値Asymは、できるだけ 10 70 Te∞ 共晶点に過剰のSbを含む 2 元合金が、経時安 定性やジッタの改善のためにGeを含有し、さらなるジ ッタの低減、線速依存性の改善、光学特性の改善等のた めにMで示される一群の元素のうち少なくとも1種を含 有したものである。或いは、Te量がO近傍の組成は、 Geis Sbs 共晶点近傍組成にTeもしくはM元素を添 加した系ともみなすこともできる。

> 【0155】上記組成において、Geは過剰Sbによる 高速結晶化機能を損ねることなく、非晶質マークの経時 安定性を高める作用を有する。結晶化温度を高めるとと もに、結晶化の活性化エネルギーを高める効果があると 考えられる。即ち、SbTe共晶組成をベースとした上 記のようなGeSbTeを主成分とする合金記録層は、 Geの存在により結晶核生成を抑制したまま、Sb/T e比を高めることで結晶成長速度を速めることができ る。一般に、結晶核生成は、結晶成長よりも低温で進行 するため、非晶質マークを形成する際の該マークの室温 付近での保存安定性にとっては好ましくない傾向にあ る。上記GeSbTeを主成分とする合金記録層は、融 点近傍での結晶成長が選択的に促進されているため、短 時間での消去が可能であると共に、室温での非晶質マー クの安定性に優れる。その点において、上記合金記録層 は、特に高線速記録に適している。上記組成における元 素MとしてはInやGa、特にInがジッタ低減、対応 線速マージンを拡大するのに効果が有る。より好ましい 相変化媒体の記録層の組成は、A'。A'。Ge。(Sb 合金(ただし、0≦a≦0.1、 d Te 1-d) 1-w-b-c $0 < b \le 0$. 1, 0. $0 \le c \le 0$. 3, 0. $8 \le d$. A' Id Zn, Pd, Pt, V, Nb, Ta, Cr, C o、Si、Sn、Pb、Bi、N、O、Sから選ばれる 少なくとも一種。A² はIn及び/又はGa)である。 【0156】これらの組成は従来のGeTe-Sb₂ T e。 擬似 2元合金の近傍の組成に比べ、未記録あるいは 消去状態の多結晶状態において、個々の微細結晶粒の反 射率の面方位依存性が小さく、ノイズを低減できる点で 好ましい。また、上記のSb/Te比が80/20より 高いSbTe系組成は、特にCD線速の12倍速(約1 4m/s)以上やDVD線速の4倍速(約14m/s) 以上のような高線速において高速消去が可能である点で 優れている。

41

すべき、基準クロック周期が25ns以下のような小さ い場合の問題点が特に大きい。その理由は下記のとおり である。上記組成における非晶質マークの消去は、実質 的に、非晶質マーク周辺の結晶領域との境界からの結晶 成長のみで支配されており、非晶質マーク内の結晶核生 成と該結晶核からの結晶成長過程とは、殆ど再結晶化過 程に寄与していない。線速度が高くなると(例えば線速 度10m/s以上)、消去パワーPeが照射される時間 が短くなるため、結晶成長に必要な融点近傍の高温に保 たれる時間が極めて短くなる。上記組成においては、非 10 晶質マーク周辺領域からの結晶成長を促進させるために は、Sbの含有量を増やせばよいが、その一方で、Sb 含有量の増加は、溶融された領域の再凝固時の結晶成長 速度をも増加させてしまう。従って、高線速記録におい て短時間で非晶質マークの消去を確実にするために、S b含有量を増やすと、良好な非晶質マークの形成が困難 になってしまう。即ち、非晶質マーク周辺からの再結晶 化速度をある程度以上増加させると、一方で、非晶質マ ーク記録のために形成した溶融領域の再凝固時に溶融領 域周辺部からの再結晶化も増加してしまうのである。

【0158】このように、上記組成においては、高線速 度記録に対応して高速消去しようとすると、非晶質マー クの形成が困難になるというジレンマがある。これに加 え、高線速度になると、クロック周期が短縮されるの で、それに伴いオフパルス区間も短くなって冷却効果が 損なわれるので、上記ジレンマは特に顕著となる。な お、このような上記組成における問題は、従来一般に使 用されてきたGeTe-Sb₂Te₃ 擬似 2元合金系組成 では、相対的にそれほど大きくないと考えられる。Ge Te-Sb₂Te₃擬似2元合金系組成においては、非晶 質マークの消去は非晶質マーク内の結晶核の生成が中心 で、結晶成長はあまり寄与していない。また、結晶核の 生成は結晶成長よりも低い温度で盛んとなる。従って、 上記GeTe-Sb₂Te₃擬似2元合金系組成において は、多数の結晶核を生成することで、結晶成長が比較的 遅くても再結晶化を達成できるのである。しかも、再凝 固時に融点以下に低下する過程では、結晶核生成が起き ない上に、結晶成長速度も比較的小さいので、比較的小 さな臨界冷却速度で非晶質化しやすいのである。

【0159】上記のような、SbTe共晶組成に過剰の Sbを含有する組成、特にさらにGeを含有する組成の 記録層は、結晶状態において、相分離を伴わない、実質 的に単一相からなる結晶状態であるのが好ましい。上記 結晶状態は、スパッタ等による製膜初期に得られる非晶 質状態の記録層を加熱し結晶化する初期化操作を行うこ とで得ることができる。実質的に単一相であるとは、単 一の結晶相からなっていてもよく、複数の結晶相からな っていてもよいが、複数の結晶相からなる場合、格子不 整合を有しないのが好ましい。単一の結晶層からなる場 合は、結晶相は同じで配向面のみが異なる多結晶層であ ってもよい。

【0160】このような実質的に単一相からなる記録層 では、ノイズを減少させる、保存安定性が向上する、高 速での結晶化が容易である等、特性を向上させることが できる。これは、Sb, Te、Sb₂Te₃等で知られ る、六方晶構造を有する結晶相やSb等の立方晶ではあ るが格子定数が大きく異なる結晶相、AgSbTez等 に対して知られる面心立方晶、さらには、その他の空間 群に属する他の結晶相が混在する場合、格子不整合の大 きな結晶粒界が形成される結果、マークの周辺形状が乱 れたり、光学的なノイズが発生したりすると考えられる のに対し、単一相からなる場合には、このような結晶粒 界が生じないためと考えられる。

【0161】記録層の結晶相の形態は、記録層の初期化 方法に大きく依存する。即ち、本発明において好ましい 上記結晶相を形成させるためには、記録層の初期化方法 を下記のように工夫するのが好ましい。記録層は通常ス パッタ法等の真空中の物理蒸着法で成膜されるが、成膜 直後のas-deposited状態では、通常非晶質 であるため、通常はこれを結晶化させて未記録消去状態 とする。この操作を初期化と称する。初期化操作として は、例えば、結晶化温度(通常150~300℃)以上 融点以下での固相でのオーブンアニールや、レーザー光 やフラッシュランプ光などの光エネルギー照射でのアニ ール、溶融初期化などの方法が挙げられるが、上記好ま しい結晶状態の記録層を得るためには、溶融初期化が好 ましい。固相でのアニールの場合は、熱平衡を達成する ための時間的余裕があるために、他の結晶相が形成され やすい。

【0162】溶融初期化においては、記録層を溶融させ て再凝固時に直接再結晶化させてもよく、また、再凝固 時にいったん非晶質状態とした後、融点近傍で固相再結 晶化させてもよい。この際、結晶化の速度が遅すぎると 熱平衡を達成するための時間的余裕があるために他の結 晶相が形成されることがあるので、ある程度冷却速度を 速めるのが好ましい。

【0163】例えば、融点以上に保持する時間は、通常 2μ s 以下、好ましくは1μ s 以下とすることが好まし い。また、溶融初期化には、レーザ光を用いるのが好ま しく、特に、走査方向にほぼ平行に短軸を有する楕円型 のレーザ光を用いて初期化を行う(以下この初期化方法 を「バルクイレーズ」と称することがある)のが好まし い。この場合、長軸の長さは、通常10~1000μm であり、短軸の長さは、通常0.1~10μmである。 なお、ここでいうビームの長軸及び短軸の長さは、ビー ム内の光エネルギー強度分布を測定した場合の半値幅か ら定義される。走査速度は、通常3~10m/s程度で ある。あるいは、少なくとも本発明相変化媒体のオーバ ーライト記録可能な最高使用線速度より高い速度で走査 した場合、初期化走査で一旦溶融した領域が非晶質化し

てしまうことがある。また、概ね最高使用線速度より30%以上低い速度で走査すると相分離が生じて単一相が得られにくい。特に、最高使用線速度の50~80%の走査速度が好ましい。なお、最高使用線速度そのものは、その線速度でPeを照射したときに、消去が完全に行われるような線速度の上限として定まる。

【0164】レーザ光源としては、半導体レーザ、ガス レーザ等各種のものが使用できる。レーザ光のパワーは 通常100mWから2W程度である。バルクイレーズに よる初期化の際、例えば円盤状の記録媒体を使用した 際、楕円ビームの短軸方向をほぼ円周方向と一致させ、 円盤を回転させて短軸方向に走査するとともに、1周 (1回転)ごとに長軸(半径)方向に移動させて、全面 の初期化を行うことができる。1回転あたりの半径方向 の移動距離は、ビーム長軸より短くしてオーバーラップ させ、同一半径が複数回レーザー光ビームで照射される ようにするのが好ましい。その結果、確実な初期化が可 能となると共に、ビーム半径方向のエネルギー分布(通 常10~20%) に由来する初期化状態の不均一を回避 することができる。一方、移動量が小さすぎると、かえ って前記他の好ましくない結晶相が形成されやすいの で、通常半径方向の移動量は、通常ビーム長軸の1/2 以上とする。

【0165】溶融初期化の際、2本のレーザビームを使用し、先行するビームで一旦記録層を溶融させ、後続する2番目のビームで再結晶化を行うことによって高融初期化を行うこともできる。ここで、各々のビーム間の距離が長ければ、先行ビームで溶融された領域は、いったん固化してから、2番目のビームで再結晶化される。溶融再結晶化を行ったかどうかは、実際の直径1 μ m程度の記録光で非晶質マークのオーバーライトを行った後の消去状態の反射率R1と、初期化後の未記録状態の反射率R2が実質的に等しいかどうかで判断できる。ここでR1の測定は、非晶質マークが断続的に記録されるような信号パターンを用いた場合、複数回のオーバーライト、通常は5から100回程度のオーバーライト後に行う。こうすることで、一回の記録だけでは未記録状態のまま残りうるマーク間の反射率の影響を除去する。

【0166】上記消去状態は、必ずしも記録用集束レーザー光を実際の記録パルス発生方法に従って変調しなくても、記録パワーを直流的に照射して記録層を溶融せしめ、再凝固させることによっても得られる。本発明の記録用媒体の場合、R1とR2の差は小さい方が好ましい。具体的には、R1とR2とで定義される下記値が10(%)以下、特には5(%)以下となるようにするのが好ましい。

[0167]

【数24】

2 | R1-R2 | / (R1+R2) × 100 (%) 例えば、R1が17%程度の相変化媒体では、概ねR2 50

が16~18%の範囲にあればよい。

【0168】かかる初期化状態を達成するためには、概 ね実際の記録条件と等しい熱履歴を初期化によって与え るのが好ましいこのような初期化方法で得られた単一結 晶相は、Sb/Te比が4.5程度より大きな場合に は、概ね六方晶となりやすく、4.5より小さい場合は 面心立方晶となりやすいが、必ずしもSb/Te比だけ に依存するものではない。特に、CD線速の16倍速以 上、DVD線速の4倍速以上の記録では、六方晶の単一 相からなる多結晶とするのが好ましい。本発明の相変化 媒体は、通常、基板上に、下部保護層、相変化型記録 層、上部保護層、反射層を設ける。中でも、いわゆる急 冷構造として、記録層の膜厚を10~30nmとし、上 部保護層の膜厚を15~50nmとし、かつ、反射層の 膜厚を30~300nmとしたものが好ましい。なお、 本発明の記録方法を上記の光記録媒体に適用する際に は、全ての記録マークの時間的長さについてn/mは 1. 5以上とすることが好ましい。更に、n/mは1. 8以上であるとより好ましい。 n/mの上限は、通常4 程度、好ましくは3程度とするが、記録パワーPwやバ イアスパワーPbなど他の条件にもより変化する。基本 的には、冷却に十分な所定の時間的長さが得られる範囲 であればよい。

【0169】なお、ライトランス型の媒体に本発明の光記録方法を用いる場合は、Pe=Pb=Pr(Prは再生光パワー)とすればよい。Pe>Prとして余熱効果を付与することもできる。また、本発明の記録方法は、記録媒体の層構成や光入射方式にも依存せず、基板/保護層/記録層/保護層/反射層という層構成で基板を介して記録再生用レーザー光ビームを入射する場合のみならず、基板/反射層/保護層/記録層/保護層という層構成で、基板とは反対側から記録再生用レーザー光ビームを入射する、いわゆる膜面入射タイプの光記録媒体にも利用できる。さらには、これらを組み合わせて記録層を多層化したような場合にも適用可能である。

【0170】反射層は、放熱を促進し、冷却速度を高める機能を有するため、本発明の記録媒体においては、その選択が重要である。具体的には、本発明においては、高い放熱効果を有する反射層を用いるのが好ましい。反射層の熱伝導率はその体積抵抗率におおむね反比例すると考えられる一方で、反射層による放熱効果は膜りに比例するので、結局反射層の放熱効果は概ね面積抵抗率に反比例すると考えられる。そこで、本発明においては、面積抵抗率0.5 Ω /□以下、特に0.4 Ω /□以下の反射層を使用するのが好ましい。また、体積抵抗率としては、20 π Ω ·m以上100 π Ω ·m以下程度が好ましい。体積抵抗率が小さすぎる材料は実用上得難い。一方、体積抵抗率が小さすぎると、放熱効果が不十分となる傾向にあるばかりでなく、記録感度が低下する傾向にある。

30

45

【0171】反射層材料としては、アルミニウム、銀、及びこれらを主成分とする合金を挙げることができる。反射層に使用できるアルミニウム合金としては、AlにTa、Ti、Co、Cr、Si、Sc、Hf、Pd、Pt、Mg、Zr、Mo及びMnからなる群から選ばれた少なくとも一種の添加元素を含有するAl合金が挙げられる。上記添加元素の含有量は、通常0.2原子%以上1原子%以下である。含有量が少なすぎると、耐ヒロック性は不十分になる傾向にあり、多すぎると、放熱効果が不十分になる傾向にある。

【0172】反射層に使用できる銀合金としては、AgにTi、V、Ta、Nb、W、Co、Cr、Si、Ge、Sn、Sc、Hf、Pd、Rh、Au、Pt、Mg、Zr、Mo及びMnからなる群から選ばれた少なくとも一種の添加元素を含有するAg合金が挙げられる。添加元素としては、経時安定性を高める点でTi、Mg、Pd及びCuからなる群から選ばれた少なくとも一種の金属元素が好ましい。上記添加元素の含有量は、通常0.2原子%以上3原子%以下である。含有量が少なすぎると、耐腐食性は不十分になる傾向にあり、多すぎると、放熱効果が不十分になる傾向にある。

【0173】なお、A1合金への添加元素の含有量やAg合金への添加元素の含有量にほぼ比例して、体積抵抗率は増加する。反射層は通常スパッタ法や真空蒸着法で形成されるが、成膜時に混入する水分や酸素量も含めて反射層中の全不純物量は2原子%以下とするのが好ましいので、製膜時に使用するプロセスチャンバの到達真空度は1×10³ Pa以下とすることが好ましい。また、不純物の混入量を低減するには、成膜レートを1nm/秒以上、特に10nm/秒以上とするのが好ましい。なお、、不純物の混入量は、スパッタに用いる合金ターゲットの製法やスパッタガス(例えばAr、Ne、及びXe等の希ガスが挙げられる)にも依存する。

【0174】反射層の放熱効果を高めるためには、反射層材料はできるだけアルミニウムや銀のみで構成するのが好ましい。放熱効果や媒体の信頼性を高めるため反射層を多層化することもできる。例えば、放熱効果が大きい銀を主体とする反射層を用い、該反射層と記録層との間に硫黄を含有する保護層を設けた場合、銀と硫黄との影響で、繰り返しオーバーライト特性や、高温高湿の加速試験環境下での耐食性に問題が生じることがあるため、これら2つの層の間に例えばアルミニウムを主体とする合金からなる界面層を設けて、アルミニウム層と銀層の2層の反射層とすることができる。この場合の界面層の厚さは、通常5nm以上100nm以下程度、好ましくは5nm以上50nm以下である。界面層が薄すぎると保護効果が不十分となる傾向にあり、厚すぎると放熱効果が悪化する傾向にある。

【0175】なお、反射層を多層化することは、所望の 膜厚で所望の面積抵抗率を得るためにも有効である。 [0176]

【実施例】以下実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は実施例に限定されるものではなく、その要旨を超えない限り適用可能である。

実施例1

1. 2 mm厚でトラッキング用の溝(トラックピッチ1. $6 \mu \text{m}$ 、溝幅約 $0.53 \mu \text{m}$ 、溝深さ約37 nm)を形成したポリカーボネイト基板上に(Z nS) $_{50}$ (SiO₂) $_{20}$ 保護層を70 nm、Ges Sb $_{77}$ Te $_{18}$ 記録層を17 nm、(Z nS) $_{55}$ (SiO₂) $_{15}$ 保護層を40 nm、Al $_{99,5}$ Ta $_{65}$ 合金を220 nm、それぞれ真空チャンバー内でスパッタにより成膜した。その上に紫外線硬化型保護コートを $4 \mu \text{m}$ 塗布し硬化して、相変化型の書き換え型光ディスクを作製した。

【0177】このディスクを、レーザー波長810nm、ビーム径約 108μ m× 1.5μ mのバルクイレーザで420mWのパワーで初期結晶化を行い、さらに、レーザー波長780nm、ピックアップの開口数NAが0.55の評価装置で、サーボをかけて、溝と溝間とを1回ずつ9.5mWのDC光で結晶化させ、結晶レベルのノイズを減らす作業を行った。

【0178】その後、このディスクに対して、レーザー 波長780nm、ピックアップの開口数NAO.55の評価装置にて、線速12m/s(CDの10倍速)、基本クロック周波数43.1MHz、基準クロック周期T23.1ナノ秒の条件で構内にEFM変調ランダムパターンのオーバーライトを試みた。EFM変調方式では3Tから11Tまでの時間的長さをもつマークを使用するが、これらマーク時間長の異なるマークをランダムに発生させたパターンがEFM変調ランダムパターンである

【0179】これらパターンを、前述の分割方式例3 (n=3,4,5,6,7,8,9,10,11に対し tm=1,2,2,3,3,4,5,5,5のように分割する。)のパルス分割方式を用いて、記録パワーPw t=18 mW、消去パワーPe=t=18 mW、バイアスパワーPb=t=18 mWとしてオーバーライト記録を行った。本パルス分割方式は、図t=18 mWととで実現できた。

40 【0180】再生は2.4m/s (CDの2倍速)で行い、再生信号は2kHzの高周波通過フィルターを通した後、信号振幅の中心を関値としてDCスライスして読みとった。オーバーライトを行なうに当たり、まず、3 Tから11Tの各マーク時間長でのパルス分割方式の最適化をあらかじめ行った。具体的には先頭記録パルス区間α.T、最後尾オフパルス区間β.Tを最適化した。【0181】例として、11Tマーク(2倍速換算で1.27マイクロ秒)を5分割して、各記録パルス幅、オフパルス幅を決めた場合を示す。図6(a)に示すパ50 ルス分割方式を用い、α.のみを変化させて記録した。

(25)

47

【0182】同様に、図6(b)に示すパルス分割方式を用い、 β 。(m=5)依存性を測定した。CD線速の2倍速に対応する線速2. 4m/sにおける再生マーク時間長の β 。依存性を図8に示す。 β 。= β s=1. 0でマーク時間長1. 35マイクロ秒であった。このような実験を各マーク時間長のマークに対して行い、先頭記 10録パルス α 1と最後尾オフパルス β 5。を特に最適化した、図9に示すパルス分割方式を決定した。なお、8 T ~ 11 T ~ 1 ~ 1

【0183】最適化後、図9に示すパルス分割方式を用いて、結晶領域に非晶質マークをオーバーライト記録した。この時の、各nTマークの入力信号に対して、再生信号のマーク時間長を測定した結果を図10に示す。マーク長の変化が直線的であり、しかも、再生されたマーク長のずれは、3T~11Tの各マークを正確に区別して検出することができる範囲内にあった。そして、このときのジッタ値は低く、2倍速再生におけるCD規格のジッタ上限値17.5ナノ秒を十分下回り、また変調度も0.6以上となるなど好ましい記録信号を得ることができた。なお、図中、マーク長とあるのはマーク時間長、スペース長とあるのはスペース時間長のことである。

【0184】次に、図9に示すパルス分割方式を用いて、EFMランダム信号のオーバーライトを行なった。ランダム信号の生成には、ソニーテクトロニクス社製のAWG520を用いた。この際、マーク長毎にパルス分割の最適化を行なった。その結果、ランダム信号を発生させても所望のマーク長と、2倍速再生で17.5 ns以下の良好なマーク長ジッタ及びマーク間ジッタとが得られた。

【0185】なお、ランダムパターンを記録した場合、 nTマークは、複数の非晶質部分に分割されることな く、連続的な非晶質マークとして形成されていることを 透過電子顕微鏡で確認した。

実施例2

1. 2 mm厚でトラッキング用の溝(トラックピッチ 1. $6 \mu \text{ m}$ 、溝幅約0. $5 3 \mu \text{ m}$ 、溝深さ約3 7 nm)を形成したポリカーボネイト基板上に(Z n S) $_{50}$ (S i O₂) $_{20}$ 保護層を7 0 nm、 $G \text{ e}_{7}$ S b $_{70}$ T e $_{11}$ 記録層を1 7 nm、(Z n S) $_{55}$ (S i O₂) $_{15}$ 保護層を4 0 nm、A 1 sp.s T a $_{65}$ 合金を2 2 0 nm、それぞれ真空チャンバー内でスパッタにより成膜した。その上に紫外線硬化型保護コートを $4 \mu \text{ m}$ 塗布し硬化して光ディスクを作製した。

【0186】このディスクを、レーザー波長810 n

m、ビーム径約108 μ m×1.5 μ mのバルクイレーザで420 μ m×1.5 μ mのバルクイレーザで420 μ m×1.5 μ mのバルクイレーザで420 μ m×0.55 μ mのパワーで初期結晶化を行い、さらに、レーザー波長780 μ m、ピックアップの開口数NAが0.55 μ mがあればした。 1回ずつ9.5 μ mがのDC光で結晶化させ、結晶レベルのノイズを減らす作業を行った。

【0187】その後、このディスクに対して、レーザー 波長780 nm、ピックアップの開口数NAO. 55 の評価装置にて、線速19.2 m/s(CDの16倍速)、基本クロック周波数69.1 MHz、T=14.5ナノ秒の条件で図6 (c)に示すパルス分割方式を用いて溝内に時間的長さ11 Tの非晶質マークを記録した。記録パワーPw=18 mW、消去パワーPe=9 mW、バイアスパワーPb=再生パワーPr=0.8 mW としてオーバーライト記録を行った。

【0188】再生は2.4m/s(CD02倍速)で行い、再生信号は2kHzの高周波通過フィルターを通した後、信号振幅の中心を関値としてDCスライスして読みとった。その結果、マークジッタは13.1ナノ秒、スペースジッタは13.2ナノ秒であり、CD規格の上限値17.5ナノ秒を十分に下回った。

【0189】また、実施例1と同様にしてEFM変調ランダムパターンを記録し再生したが、これも良好な結果が得られた。

比較例1

実施例2で作製したディスクに対して、レーザー波長780nm、ピックアップの開口数NA0.55の評価装置にて、線速19.2m/s(CDの16倍速)、基本クロック周波数69.1MHz、T=14.5ナノ秒の30条件で図11に示す、現行CD-RWのn-k分割方式(m=n-k、k=1。n/mの最小値は1.1)を用いて時間的長さ11Tの非晶質マークと11Tのスペースを交互に記録した。

【0190】記録パワーPw=18mW、消去パワーPe=9mW、バイアスパワーPb=再生パワーPr=0.8mWとしてオーバーライト記録を行った。しかしながら、線速2.4m/sで信号を再生すると、再生信号のマーク中央部に相当する部分で反射率が落ちきらず、マークを観察したところマーク中央部がかなり再結40 晶化していた。ジッタは17.5ナノ秒を大幅に越え測定不能なレベルであった。再結晶化を抑制するために、n-1分割方式のまま各記録パルス幅をより細くしたが、記録レーザー光の変調が追いつかず、記録パワーPwの増大をもたらすだけで、冷却効果の改善は全く見られなかった。

実施例3

50

1. 2 mm厚でトラックピッチ1. 6 ミクロン、溝幅約 0. 5 3 μm、溝深さ約 3 7 n mのトラッキング用の溝 を形成したポリカーボネート樹脂基板上に (Z n S) so (S i O₂) 20 保護層を 7 0 n m、G e 7 S b 78 T e 15 記

録層を17nm、 (ZnS) so (SiO_z) 20 保護層を45nm、Al so so 10z co 10z

【0191】実施例1及び2と同様に、本ディスクをレーザー波長約810 n m、ビームの長軸約108 μ m×短軸約1.5 μ mの楕円形の集束光を長軸が半径方向にそろうように配置して、線速 $3\sim6$ m/s で操作し、 $400\sim600$ mWのパワーを照射して初期化を行った。さらに、780 n m、ピックアップの開口数NA=0.55の評価装置で、サーボをかけて溝と溝間部を1回ずつ9.5 mWのDC光で結晶化させ、結晶化レベルのノイズを減らす作業を行った。

【0192】記録再生評価には、パルステックDDU1000(波長780nm, NA=0.55)を用い、構内に記録再生を行った。記録時の線速度如何にかかわらず、再生は2倍速にて行った。この場合のCDフォーマットとしてのジッタの許容値は17.5ナノ秒である。ゲート信号発生用の信号源として任意波形信号源ソニーテクトロニクス社製AWG520を用いた。

【0193】まず、CD線速の16倍速(19.2m/s)で記録を行った。この際基準クロック周期Tは14.5ナノ秒である。

(1) まず、図14に示す分割記録パルスを用い中間 30パルス群の最適条件を検討した。記録パワーPwiは一定で20mW、バイアスパワーPbiも一定で0.8mWとし、マーク間の消去パワーPeは10mWとした。

【0194】まず、図14 (a) のように、 $\alpha_i = 1$ で一定とした分割記録パルスで、 β_i を β c (一定値) として、これを変化させて非晶質マーク形成へのオフパルス区間長依存性を調べた。オフパルス区間がおよそ1 Tより短い場合には、図3 (d) に示すようなマーク前端の再結晶化により、マーク前端での信号振幅が低下しており、後端でも、まだ振幅が低めであった。マーク長全40体での最大振幅を消去レベルの信号強度で除した値(×100%)を変調度と定義し、変調度のオフパルス区間依存性を図15 (a) に示した。オフパルス区間が短いと、前述の波形ひずみの影響(非晶質マーク形成不良)のため、変長度が低下していることが分かる。オフパルス区間が1 Tを超えたところでようやく変調度が飽和して、歪みのない方形波に近い波形が得られた。

【0195】次に、図14(b)に示すような分割記録パルスで、オフパルス区間を1.5Tで一定として、変調度の記録パルス区間依存性を検討した。図14(b)

において、 α : は α c (一定値) として一律に変化させた。図15 (b) に変調度の α c 依存性を示した。 α c = 1 \sim 1.5程度でほぼ飽和して変調度が得られていることが分かる。

【0196】(2) そこで、次に、中間パルス群は α =1、 β =1. 5で固定して、先頭周期、最後尾の周期の制御により、マーク長及びマーク端の特性を制御することを図16の分割記録パルスを使用して検討した。図16において最後尾に0.5 Tの記録パルス区間 10 を1個追加したのは、マーク長を正確に11 Tに近づけるためである。こうして、マーク長とマーク間長がともに11 Tになり、良好なジッタが得られる条件を探した。元になる波形は11 Tマークと11 Tマーク間の繰り返しパターンで、11 Tマークの前端に同期して、先頭記録パルスが立ち上がるものとした。ここで、2倍速再生しているので、ジッタの許容値の上限は17.5 ナノ秒(α s)に相当する。図17、18及び19には、これらの値が点線で表記されている。

【0197】図16(a)のような分割記録パルスを用いて、先頭の記録パルス α 、長依存性を調べた。図17(a)及び(b)はそれぞれマーク長とマーク間長の α 、依存性、マークとマーク間ジッタの α 、依存性である。図17(b)より、まず、ジッタを17. 5ナノ秒以下にできる α 、として0. $8\sim1$. 8が適当であることが分かる。

【0198】図17 (b) ではマーク長とマーク間長は所望の11 Tが得られていないので、次に α 1 = 1として、図16 (b) に示すような分割記録パルスを用いて、先頭オフパルス β 1 T長依存性を検討した。図18 (a) 及び (b) はそれぞれマーク長とマーク間長の β 1 依存性、マークとマーク間ジッタの β 1 依存性である。 β 1 = 1.3 で、ほぼ所望のマーク長及びマーク間長が得られ、 β 1 = 1~1.7 の範囲で良好なジッタが得られていることが分かる。ここでは、 β 1 = 1.5 を選択する。

【0199】さらに、図16 (c) に示すような分割記録パルスを用いて、 $\alpha_1 = 1$ 及び $\beta_1 = 1$. 5として、最後尾のオフパルス β_m 長依存性を検討した。図19 (a) 及び (b) はそれぞれマーク長とマーク間長の β_m 依存性、マークとマーク間ジッタの β_m 依存性である。 $\beta_m = 0$. 7近傍で所望のマーク長とマーク間長が得られ、 $\beta_m = 0 \sim 1$. 8の広い範囲で良好なジッタが得られていることが分かる。

【0200】以上より $\alpha_1 = 1$ 、 $\beta_1 = 1$. 5、 $\beta_m = 0$. 8とすれば、所望の11Tマーク長と最小のジッタが得られることになる。

(3) 上記 (1) 及び (2) の結果を元に、 $\alpha_!=1$ ± 0.5、 $\beta_!=1\pm0$.5の範囲で、前記(分割記録 50 パルス発生方法 2) に基づいて、周期 2 T をベースとし

51

たパルス分割方法を3T~11Tマーク長からなるEF M変調信号に対して試みた。具体的な各マーク長ごとの パルス分割方法は図20に示す通りである。

【0201】すなわち、nが偶数、つまりマーク長がnT=2LT、ただし、Lは2以上の整数、のマークの記録に際して、m=L個の区間に分割し、記録パワーPw; を照射すべき記録パルス区間 α ; 及びバイアスパワーPb; を照射すべき区間オフパルス区間 β ; を

[0202]

【数25】 $\alpha_1 + \beta_1 = 2$

 $\alpha_i + \beta_i = 2 \quad (2 \leq i \leq m-1)$

 $\alpha \cdot + \beta \cdot = 1.6$

なるように照射し、一方、nが奇数、つまりマーク長nT=(2L+1) Tのマーク長記録の場合は、m=L個に分割し、

[0203]

【数26】 α_1 '+ β_1 '=2.5

 α_i ' + β_i ' = 2 (2 \leq i \leq m-1)

 α , β , β , α ,

としている。つまり、2LTマークと (2L+1) Tマ 20 ークで分割数はm=Lで同じであるが、先頭と最後尾の 周期に0.5Tずつ差をつけることで区別している。

【0204】図20では、 α_1 Tのn Tマーク前端に対する遅延T α_1 = 0 としている。また、 $n \ge 4$ では、n によらず、中間記録パルス群は、 α_1 = 0.8、 β_1 = 1.2 ($2 \le i \le m-1$) で一定とした。さらに、n が偶数の場合には、 α_1 = 0.8、 β_1 = 1.2、 α_n = 0.7、 β_n = 0.9であり、奇数の場合には α_n ' = 1.0、 β_n ' = 1.5、 α_n ' = 1.0、 β_n ' = 1.1 とした。3 Tの場合のみ変則的で、 α_1 = 1.2、 α_1 = 1.5 でちょうど3 Tマーク長を得た。なお、図20では、記録パルス区間と、オフパルス区間を、それぞれ矩形波の上底及び下底として示している。具体的な区間長は、数字で記載されており、上底及び下底の長さ自体は、区間長に対応して表記されているわけではない。

【0205】記録パワーPwi、バイアスパワーPbiはiによらず一定で、Pw=20mW, Pb=0.8mWとした。消去パワーPeは10mWとした。9回オーバーライト後(初回記録を0回とみなす)の、各nTマーク及びnTマーク間のマーク長及びマーク間長、さらにジッタを測定した。マーク長及びマーク間長の結果を図21(a)に、マーク及びマーク間のジッタを図21(b)に示した。マーク長及びマーク間長はほぼ正確にnTになっており、ジッタもオーバーライトにより、初回記録に比べ2~3ナノ秒程度悪化するが、17.5ナノ秒以下に収まった。なお、オーバーライトではなく、一旦、消去パワーPeを直流的に照射して消去を行ったところ、さらに2ナノ秒程度ジッタが改善された。

【0206】(4) 同様の媒体に線速vとクロック周 50 的な非晶質マークとして形成されていることを透過電子

期下の積が一定となるように、クロック周期を変化させて、CD10倍速でのオーバーライトを試みた。すなわち、この場合の基準クロック周期Tは23.1ナノ秒である。 $n \ge 4$ においては、 α : T ($1 \le i \le m$) をほぼ一定となるように決めた。即ち、中間記録パルス群は、 α : = 0. 5、 β : = 1. 5 ($2 \le i \le m - 1$) で一定とした。

【0208】9回オーバーライト後(初回記録を0回とみなす)の、各nTマーク及びnTマーク間のマーク長及びマーク間長、さらにジッタを測定した。マーク長及びマーク間長の結果を図23(a)に、マーク及びマーク間のジッタを図23(b)に示す。マーク長及びマーク間長はほぼ正確にnTになっており、ジッタもオーバーライトにより、初回記録より2~3ナノ秒程度悪化するが、17.5ナノ秒以下に収まった。

【0210】線速と基準クロック周期との積を一定としたまま、線速を変化させて、それぞれで消去比を求めたところ、CD線速の10倍速、12倍速、16倍速及び18倍速で、オーバーライト消去比20dB以上が得られた。なお、ランダムパターンを記録した場合、nTマークは、複数の非晶質部分に分割されることなく、連続的な非晶質マークとして形成されていることを透過電子

顕微鏡で確認した。

【0211】なお、以上で使用したのと同様の記録層を初期化後の状態で剥離し、透過電子顕微鏡観察によって結晶性の確認を行ったところ、六方晶の単一相からなる多結晶であることがわかった。結晶相としては相分離は確認できず、単一相で、配向面が回転した多結晶構造であると推定される。さらにX線回折による検討も行ったところ、六方晶構造であることがわかった。

53

実施例4

0.6 mm厚でトラックピッチ0.74 μ m、溝幅約0.27 μ m、溝深さ約30 n mのトラッキング用の溝を形成したポリカーボネート樹脂基板上に(Z n S) so (S i O₂) $_{20}$ 保護層を68 n m、G e s S b $_{10}$ T e $_{10}$ 記録層を14 n m、(Z n S) so (S i O₂) $_{20}$ 保護層を25 n m、A l so s 合金反射層を200 n m (体積抵抗率約100 n Q · m、面積抵抗率0.5 Q 一)、真空チャンバー内でスパッタ法により成膜した。その上にスピンコートによって約4 μ m の紫外線硬化樹脂層を設けた。これに、もう一枚同じ層構成を有する厚さ0.6 m m の基板を貼り合わせて相変化型ディスクとした。

【0212】得られたディスクに対して、実施例3と同様に、レーザー波長約810nm、ビームの長軸約108 μ m×短軸約1.5 μ mの楕円形の集束光ビームを長軸が半径方向にそろうように配置して、線速3 \sim 6 m/s で走査し、 $400\sim600$ mWのパワーを照射して初期化を行った。さらに、波長約660nm、ピックアップの開口数NA=0. 65の評価装置で、トラッキング及びフォーカスサーボをかけて溝部に1回ずつ約6mWのDC光を4m/s で走査させて、結晶化レベルのノイズを減らす作業を行った。

【0214】まず、記録時の線速をDVD04. 8倍速 40に相当する16. 8m/s(DPD04. 8倍速 40に相当するDPD04. 8m/s(DPD04. 8倍速 40に相当するDPD04. 8m/s(DPD04. 8m/s0 (DPD04. 8m/s0 (DPD04. 8m/s0 (DPD04. 8m/s0 (DPD04. 8m/s0 (DPD04. 8m/s0 (DPD04) 25. 8m/s0 (DPD04) 25. 8m/s0 (DPD04) 25. 8m/s0 (DPD04) 26. 8m/s0 (DPD04) 27. 8m/s0 (DPD04) 26. 8m/s0 (DPD04) 27. 8m/s0 (DPD04) 26. 8m/s0 (DPD04) 26. 8m/s0 (DPD04) 26. 8m/s0 (DPD04) 26. 8m/s0 (DPD04) 27. 8m/s0 (DPD04) 26. 8m/s0 (DPD04) 27. 8m/s0 (DPD04) 28. 8m/s0 (DPD04) 28. 8m/s0 (DPD04) 29. 8m/s0 29. 8m/s0

5 (b)) の2つの場合につき、再生信号の記録マーク 部分の変調度のTwのTに対する比(Tw/T)依存性 を評価した。2T周期のTw/Tが1.0の場合で、ほ ぼ歪みのない方形波に近い信号が得られ、変調度も最大 となった。0. 5未満では歪んだ波形が得られており、 記録パワー照射区間が不十分なため、温度上昇が不足し ていると考えられる。逆に、Tw/Tが1.0以上の範 囲では、Twの増加に伴い、変調度が低下している。こ れは、冷却時間が不足して再結晶化により非晶質化が阻 10 害されたためと考えられる。さらに、Tw/Tが1.5 を越えると、変調度は5%よりも小さくなり、歪んだ波 形となった(図示せず)。一方、1 T 周期の場合は、す べての範囲で変調度は低く、歪んだ波形しか得られなか った。この場合、1 T 周期では、十分な記録パワー照射 時間と冷却時間とが両立する範囲が存在しないためと考 えられる。

【0215】以上の結果から、分割記録パルス発生方法 2または3で、少なくとも2≤i≤m-1の中間分割記 録パルス群において、 $\alpha_i = \alpha_i$ '=1、 $\beta_i = \beta_i$ '=1 と設定することが好ましいことがわかる。続いて、上記 ディスクが、14m/s及び17.5m/s(DVD線 速3.5m/sの4及び5倍速に相当)の高線速で高速 消去が可能であることを以下のようにして確認した。即 ち、8Tマーク用の分割記録パルスと8Tのマーク間長 とからなる繰り返しパターン (8 Tパターン)と、3 T マーク用の分割記録パルスと3Tのマーク間長とからな る繰り返しパターン(3Tパターン)とを用いて、オー バーライトを行なった。3 Tパターンを9回オーバーラ イト後、10回目に8Tパターンをオーバーライトし て、3 T信号のキャリアレベルの低下率をオーバーライ ト消去比として求めた。DVDと同じ記録密度となるよ う線速と基準クロック周期との積を一定として、それぞ れのオーバーライト消去比を求めたところ、14m/s 及び17.5m/sそれぞれで25dB以上の値が得ら れた。

【0216】さらに、前記分割記録パルス発生方法3に基づいて、周期2Tをベースとしたパルス分割方法を3T~11T及び14Tマーク長からなるEFM+変調信号記録を線速14m/s及び16.8m/s(DVD線速3.5m/sの4倍速及び4.8倍速)に対して行なった。4倍速におけるクロック周波数は104.9MHz、クロック周波数は104.9MHz、クロック周波数は125.9MHz、クロック周期は7.9nsecである。具体的なパルス分割方法は図26に示す通りである。nが偶数、つまりマーク長がnT=2LT(ただし、Lは2以上の整数)の場合、マークの記録に際して、マークをm=L個の区間に分割し、記録パルス区間 α 1T及びオフパルス区間 β 1Tにおける α 1及び β 1を、

[0217]

【数27】 $T_{ai} + \alpha_i = 2$ ($T_{ai} = 0$. 95) $\beta_{i=1} + \alpha_i = 2$ ($2 \le i \le m-1$)

とし、一方、nが奇数、つまりマーク長がn T=(2L+1) T の場合、マークの記録に際して、マークをm=L 個の区間に分割し、記録パルス区間 α_i T ΔU ΔU

55

[0218]

【数28】 T_{a1} ' $+\alpha_{1}$ ' =2.05 (T_{a1} ' =1) β_{1} ' $+\alpha_{2}$ ' =2.45

 β_{i-1} ' $+\alpha_i$ ' = 2 (3 \le i \le m-1)

 β_{-1} ' + α_{-} ' = 2. 45

とした。この場合、L=2では $\beta_1' + \alpha_2' = 2$. 9とし、 $\alpha_n = 1$ 、 $\alpha_n' = \alpha_n + 0$. 2=1. 2とした。

【0219】そして、L \geq 3の場合は、中間記録パルス群は、 α_i ' = α_i = 1、 β_i ' = β_i = 1($2 \leq i \leq m-1$)で一定とし、 α_i = α_i ' = 1で一定とした。また、L \geq 2では、 α_i = α_i ' = 1.05及び、 β_i = β_i ' = 0.4でnによらず一定とした。さらに3Tの場合は、 T_{4i} = 1.15、 α_i = 1.2、 β_i = 0.8でちょうど3Tマーク長を得た。なお、図25では、記録パルス区 20間と、オフパルス区間を、それぞれ矩形波の上底及び下底として示している。具体的な区間長は、数字で記載されており、上底及び下底の長さ自体は、区間長に対応して表記されているわけではない。

【0220】バイアスパワーPb_iはiによらず一定の値Pb=0.5mWとし、消去パワーPeは4.5mWとした。記録パワーPw_iもiによらず一定とし9回オーバーライト後のエッジ・ツー・クロックジッタと変調度の記録パワー依存性を測定した。再生は、再生光パワーPr=0.8mW、線速度3.5m/sで行った。い30ずれの記録線速においても図27の(a)及び(b)に示すように、記録パワー15.0mWにおいてエッジ・ツー・クロックジッタは10%未満、変調度は60%以上を実現している。またR_{io}は約18%であった。記録パワー15.0mWでオーバーライト依存性を測定したところ、図27の(c)に示すように10000回後でもエッジ・ツー・クロックジッタは11%以下であった。このときR_{io}及び変調度はオーバーライトによってほとんど変化しなかった。

【0221】さらに、同様のディスクに対して、前記分割記録パルス発生方法3に基づいた図28に示すパルス分割方法を用いてEFM+変調信号記録をDVD2倍速に相当する線速7m/s、クロック周波数52.5MHz(クロック周期19.1nsec)で記録を行なった。4倍速及び4.8倍速記録と同様にバイアスパワーを一定Pb=0.5mWとし、消去パワーPeを4.5mWとしたうえで、記録パワーPwiもiによらず一定とし9回オーバーライト後のエッジ・ツー・クロックジッタと変調度の記録パワー依存性を測定した。図27

(a) 及び(b) に示すように、記録パワー13.0 m²50

Wでエッジ・ツー・クロックジッタは8%未満、変調度は57%以上を実現している。 R_{top} は約18%であった。記録パワー13.0mWでオーバーライト依存性を測定したところ、図27(c)に示すように、10000回後でもエッジ・ツー・クロックジッタは11%以下であった。このとき R_{top} 及び変調度はオーバーライトによってほとんど変化しなかった。

56

【0222】以上より、分割記録パルス発生方法3に基づいたパルス分割方法を用いることによって、DVD線10 速の2倍速から4.8倍速という広い範囲での記録が可能であることが分かる。従って、この方法を用いることによって、例えば、DVDのデータエリアである半径約24mmから約58mmの半径範囲において、回転角速度を一定とした記録が可能となる。

[0223]

【発明の効果】本発明によれば、基準クロック周期が短い場合でも良好なマーク長変調記録が行え、光記録媒体の高密度化、高速記録化が可能となる。ひいては、記録可能な光ディスクの大容量化が可能となり、また光ディスクの記録速度及び転送レートを高めることができ、音楽・映像などの大量データ記録やコンピュータの外部記憶装置用としての用途を大きく広げることができる。例えば、CD線速の12倍速以上でEFM変調マークのオーバーライトを行なう書き換え型CDや、DVD線速で4倍速以上でEFM+変調マークのオーバーライトを行なう書き換え型DVDを実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係わる記録パルス分割方式とその発生 方法の一例の説明図

【図2】従来の記録パルス分割方式の説明図

【図3】相変化型光記録媒体の記録マーク形状及び反射 率変化を説明する模式図

【図4】相変化型光記録媒体の記録層に記録光を照射した際の温度履歴の例

【図 5 】E F M変調信号の再生波形(アイパターン)の 模式図

【図6】本発明実施例の11Tマークの記録パルス分割の例

【図7】本発明実施例1における、α₁ とマーク時間長の関係を示すグラフ

【図8】本発明実施例1における、β. とマーク時間長の関係を示すグラフ

【図9】本発明実施例1における、EFMランダムパタ ーンの記録パルス分割の一例

【図10】本発明実施例1におけるマーク時間長/スペース時間長の測定値の理論値との関係を示すグラフ

【図11】従来の11Tマーク/11Tスペースの記録 パルス分割の一例

【図12】本発明におけるパルス分割方法の一例を示す 説明図 【図13】図12のパルス分割方法におけるゲートの発生のタイミングを示す説明図

【図14】実施例3の(1)におけるパルス分割方法を示すを示す説明図

【図15】実施例3の(1)における変調度の依存性を 示すグラフ

【図16】実施例3の(2)におけるパルス分割方法を示すを示す説明図

【図17】実施例3の(2)におけるマーク長及びマーク間長の α 、依存性を示すグラフ

【図18】実施例3の(2)におけるマーク長及びマーク間長のβ,依存性を示すグラフ

【図19】実施例3の(2)におけるマーク長及びマーク間長の β ・依存性を示すグラフ

【図20】実施例3の(3)におけるパルス分割方法を示すを示す説明図

【図21】実施例3の(3)におけるマーク長及びマー*

* ク間長、並びにそれらのジッタを示すグラフ

【図22】実施例3の(4)におけるパルス分割方法を示すを示す説明図

【図23】実施例3の(4)におけるマーク長及びマーク間長、並びにそれらのジッタを示すグラフ

【図24】本発明のパルス分割方法の具体例を示す説明 図

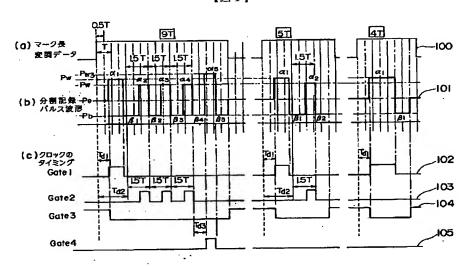
【図25】実施例4におけるパルス分割方法及び得られた変調度のTw/T依存性を示す説明図

10 【図 2 6 】実施例 4 におけるパルス分割方法の具体例を 示す説明図

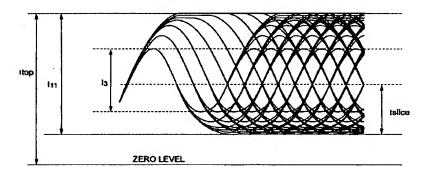
【図27】実施例4における変調度及びジッターのパワー依存性及びジッターのオーバーライト回数依存性を示す図

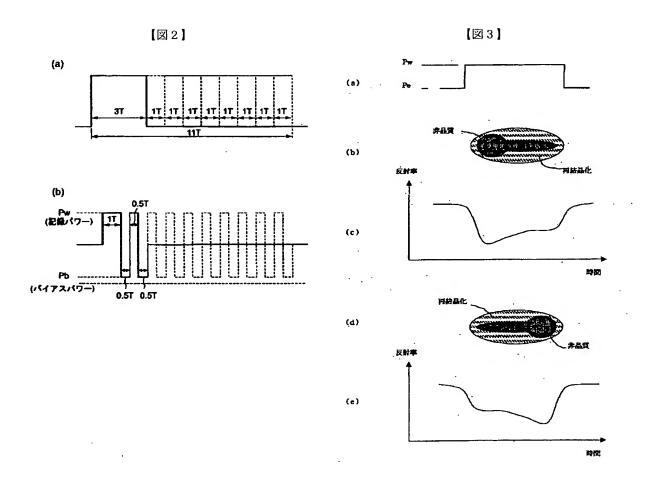
【図28】実施例4におけるパルス分割方法の他の具体 例を示す説明図

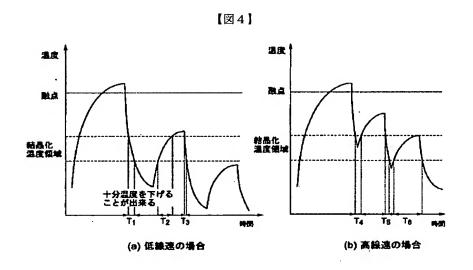
【図1】

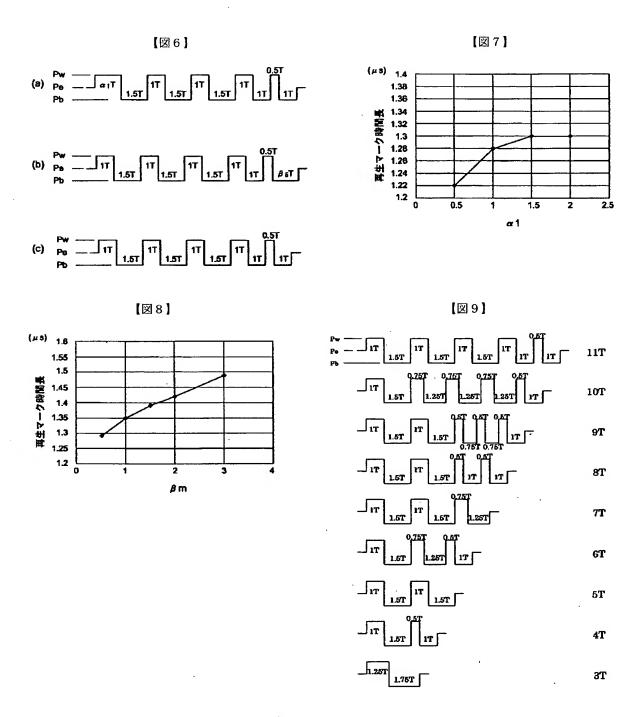


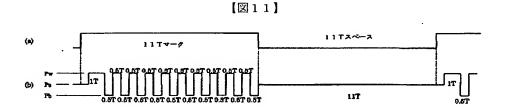
[図5]

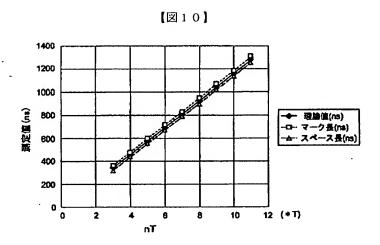




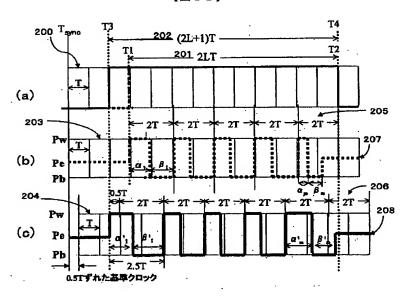




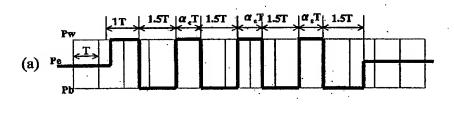


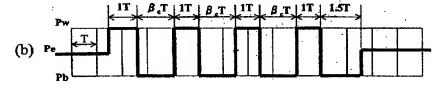


【図12】

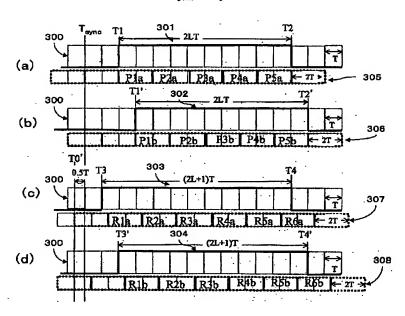


【図14】

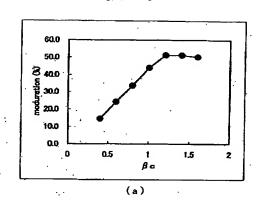




【図13】

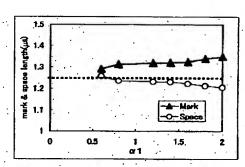


【図15】

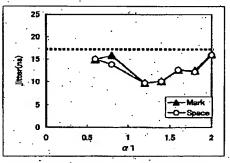


60.0 50.0 8 40.0 9 30.0 10.0 0.0 0.5 1 1.5 2 αc

【図17】

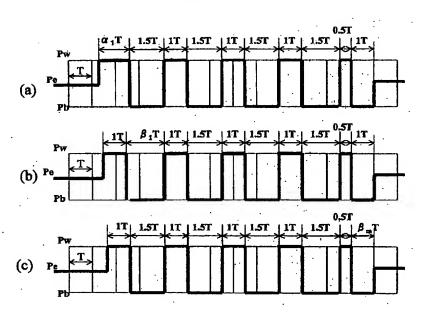


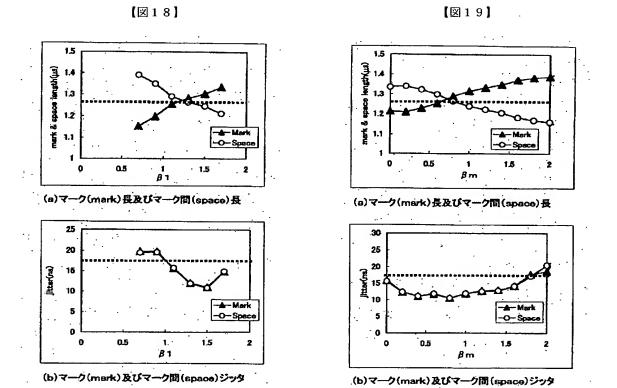
(a)マーク(mark) 長及びマーク間(space) 長



(b)マーク(mark)及びマーク間(space)ジッタ

[図16]

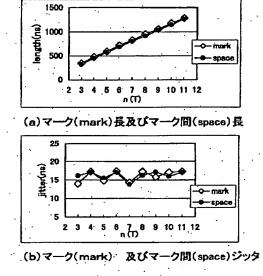




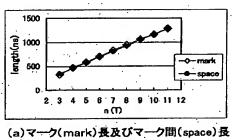
【図20】

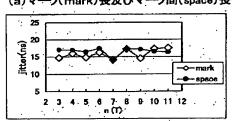
								-	٠		
٠.		. a 1	B 1	α2	. β2	α3_	β3	α4	β4	α5	85
31		1.2T	1.5Т			•					,
4T		T8.0	1.2T	0.71	0.9T			·		٠.	
5 Т		1.01	1.51	1.0T	_1JT_		·		٠,		
вт		T8.0	1.2T	T8.0	1.2T	0.7Ť	0.97			٠	
, <u>t</u> t		1.07	1.5T	TB.0	1.21	- 1.0T	1.1T				
81		0.8T	1.2T	0,8T	1.2T	0.8T	1.27	0.7T	0.9T		
9T	ľ	1.01	1.5T	T8.0	1.2T	0.8T	1.2T	1.01	1.17		
10T		T8.0	1.2T	0.8T	1.2T	. 0.81	1.2T	78.0	1.21	0.7T	0.9T
11 T		1.0T	1,51	0.8T	1.2T	Q.BT	1.2T_	0.8T	1.2T	1.0T	1.1T

【図21】



【図23】



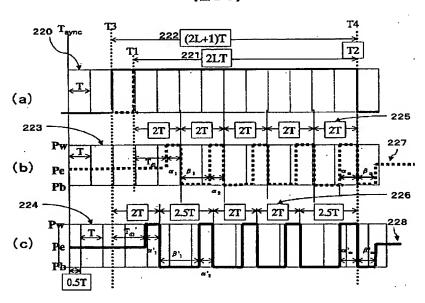


(b)マーク(mark) 及びマーク間(space)ジッタ

[図22]

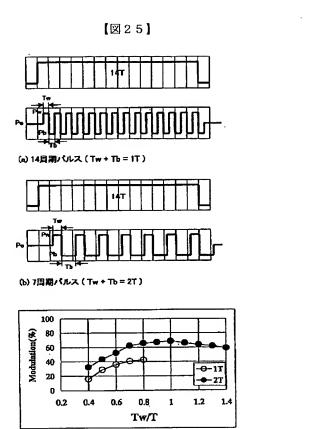
	1 0	1	β1	· a2	β2	α9	βЗ	a 4	β4	a 5	β5	ĺ
3T ·	0.	вт	2,4T				. 49.	experience			in our	٠.
47	0.	eT.	1.47	0.57	1.4T			٠.		٠.		
5T	0.	6T .	1.97	0.87	1,8T					٠.		
8T	0.	6T	1.4T	0.51	1.5T	0.5T	1.4T	Ċ		-	·	·
'n	a	вт	1.97	78.0	1.5T	0.6T	1.8T					
81	0	вт	1.4T	0.57	1.51	0.5T	. (.5Т	0.51	1.4T			
9T	0.	6T	1.91	0.51	1,57	0,57	1,5T	0,67	1,8T			
iót	0	6T .	1.4T	0.51	1.51	0.51	1.51	0.5T	1,57	0.51	1.4T	
117	Q.	6T	1.97	0.51	1.57	0.5T	1.5T	0.57	1.51	0.87	LAT	ļ

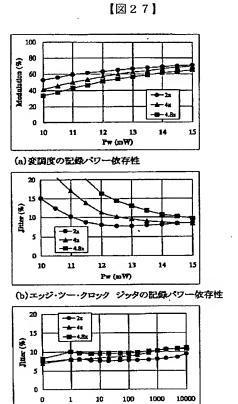
【図24】



【図26】

		Tat	m1	ا دم ا	a 2	82	σß	28	a 4	84	a 5	#6	-6	88	α7	87
27		1,157	1.27	0.67_												
47		0.957	1.05T	3.01	1.OT	257										
61		1.07	1.06T	_12T_	1.2T	0.47	:									
eT		QBST	1.057	1.07	1,01	1.0T	1.0T	0AT								
17	•	1.07	1.0ST	1,457	1,0T	1457_	1.01	CAT								
87		788.0	1.0ST	_15	1.0T	1.01	10.1	ூர	1.0T	247						
97		1.07	1.067	1,457	1.0T	LPT	1.07	1.45T	1.0T	Q4T						
101	ŀ	782.0	1.05T	1.07	1.0T	I,DT	1,07	JOT	1.UT	LOT	1.0T	9.41				
117		IAT	1,061	1451	1.0T	1.01	1.07	J.OT	1.07	1/51	1.0T	941				
									•							
14T	1	0.95T	1.057	1,91	1.01	1.01	1.01	1.07	1.0T	1.01	TQI	1.01	1.07	1.01	1.0T	941





(c)エッジ・ツー・クロックジッタのオーバーライト回数依存性

DO₩

0,71 41 1,07 ST 1.067 OFT QTT 1.41 Ė 1.07 1,07 1,37 0.77 QZT 975 1.87 1.0T 1,37 0.71 1.DT 1.05T 1,0T 1.701 121 977 0,77 OT 0.7T 0.71 1.01 1.0T 0.71 977 ۵ЛТ 117 1.051

【図28】

フロントページの続き

Fターム(参考) 2H111 EA04 EA12 EA23 EA32 FB04

FB05 FB09 FB10 FB12 FB16

FB17 FB19 FB21 FB22 FB23

FB25 FB27 FB30

5D029 JA01

5D090 AA01 BB05 CC02 DD03 EE06

FF17 GG03 KK05

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第4区分

【発行日】平成14年5月24日(2002.5.24)

【公開番号】特開2001-331936 (P2001-331936A)

【公開日】平成13年11月30日(2001.11.30)

【年通号数】公開特許公報13-3320

【出願番号】特願2000-139953 (P2000-139953)

【国際特許分類第7版】

G11B 7/0045

B41M 5/26

G11B 7/24 511

[FI]

G11B 7/0045 A

7/24 511

B41M 5/26

【手続補正書】

【提出日】平成14年2月25日(2002.2.2.5)

X

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 記録媒体に光を照射することによってマーク長変調された情報を複数の記録マーク長により記録するにあたり、一つの記録マークの時間的な長さをnTとしたとき(Tは基準クロック周期であって25ns以下である。nは2以上の自然数である。)、

記録マークの時間的長さnTを、

 α_i T、 β_i T、 \cdots 、 α_n T、 β_n T、 η_2 T (mはパルス分割数である。 Σ_i (α_i + β_i) + η_1 + η_2 = n である。

 α : $(1 \le i \le m)$ は0より大きい実数であり、 β : $(1 \le i \le m-1)$ は0より大きい実数であり、 β : は0以上の実数である。 η : 及び η : はそれぞれ-2以上2以下の実数である。)

の順に分割し、

 α : T ($1 \le i \le m$) の時間内においては記録パワー P w: の記録光を照射し、

少なくとも一つの記録マークの時間的長さについては上記パルス分割数mを2以上とし、かつ、全ての記録マークの時間的長さについてn/m≥1.25を満たすこと

を特徴とする光記録方法。

【請求項2】 β_i ($1 \le i \le m-1$) は $0.5 \sim 2.5$ である請求項1に記載の光記録方法。

【請求項3】 全ての記録マークの時間的長さについて、 α_i T $(1 \le i \le m)$ の平均値が3ナノ秒以上で、かつ β_i T $(1 \le i \le m-1)$ の平均値が3ナノ秒以上である請求項1または2に記載の光記録方法。

【請求項4】 全ての記録マークの時間的長さについて、それぞれのiに対して α , $T \ge 3$ ナノ秒($1 \le i \le m$)で、かつ β , $T \ge 3$ ナノ秒($1 \le i \le m-1$)である請求項1乃至3のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項5】 全ての記録マークの時間的長さについて、n/m≥1.5を満たす請求項1乃至4のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項6】 $\alpha_i + \beta_i$ (2 \leq i \leq m = 1) あるいは、 $\beta_{i-1} + \alpha_i$ (2 \leq i \leq m = 1) が、1.5、2、あるいは2.5のいずれかの値をとる請求項1乃至5のいずれか1つに記載の光記録方法。

【請求項7】 nの異なる少なくとも2つの記録マークにおいて、同一のパルス分割数mを用い、前記少なくとも2つの記録マークにおいて、 α_i ($1 \le i \le m$)、 β_i ($1 \le i \le m$)、 η_1 、 η_2 、 Pw_i ($1 \le i \le m$) 及び Pw_i ($1 \le i \le m$) の少なくとも1つが相互に異なる請求項1乃至6のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項8】 マーク長がnT=2LT(ただし、Lは 2以上の整数)で表される場合、マークを分割数m=L 個の区間に分割し、記録パルス区間 α ; T及びオフパルス区間 β ; Tにおける α ; Dび β ; (これらはD0値に応じて変化し得る)を下記のように定め、

【数2】 $\alpha_1 + \beta_1 = 2 + \delta_1$

 $\alpha_i + \beta_i = 2$ $(2 \le i \le m-1)$

 $\alpha_{\bullet} + \beta_{\bullet} = 2 + \delta_{2}$

(ただし、 δ_1 及び δ_2 は、それぞれ順に、 $-0.5 \leq \delta$ $_1 \leq 0$. 5、及び $-1 \leq \delta_2 \leq 1$ を満足する実数である。 また、L=2の場合には、 α_1 、 β_1 、 α_n 及び β_n のみが 存在するものとする。)

マーク長が n T = (2 L + 1) Tで表される場合、マー クを分割数m=L個の区間に分割し、記録パルス区間α i T及びオフパルス区間 β i Tにおける α i 及び β_i '(これらはLの値に応じて変化し得る)を下記の ように定め、

【数3】 $\alpha_1' + \beta_1' = 2.5 + \delta_1'$ $\alpha_{i}' + \beta_{i}' = 2 \quad (2 \le i \le m-1)$ α , ' + β , ' = 2. 5 + δ ₂'

(ただし、 δ_1) 及び δ_2) は、それぞれ順に、-0.5 $\leq \delta_1$ ' ≤ 0 . 5、及び $-1 \leq \delta_2$ ' ≤ 1 を満足する実数 である。また、L=2の場合には、 α_1 '、 β_1 '、 α 。'及び β 。'のみが存在するものとする。) 且つ、 α_1 、 β_1 、 α_n 、 β_n 、 α_1 '、 β_1 '、 α_n '、及 びβ_•'が下記式を満足することを特徴とする請求項7 に記載の光記録方法。

【数4】

 $\alpha_1 + \beta_1 + \alpha_2 + \beta_2 + \Delta = \alpha_1' + \beta_1' + \alpha_2' + \beta_2'$ $(220, \Delta = 0.8 \sim 1.20)$

【請求項9】 α_1 、 β_1 、 α_1 及び β_1 が下記式を満 足する請求項8に記載の光記録方法。

【数5】 $\alpha_1 + \beta_1 + \Delta_1 = \alpha_1' + \beta_1'$

 $\beta_1 + \alpha_2 + \beta_{-1} + \alpha_1 + \Delta_2 = \beta_1' + \alpha_2' + \beta_{-1}' + \alpha_1'$

(ただし、 $\Delta_1 = 0.4 \sim 0.6$)

 $(22^{\circ}, \Delta_2 = 0.8 \sim 1.2^{\circ}$

【請求項11】 3以上のLに対して、 $\beta_1' = \beta_1 +$ 約 $0.5 \, , \, \beta_{r1} \, ' = \beta_{r1} \, + 約0.5 \, , \,$ であり、 $\alpha_1 =$ 0. $8\alpha_1' \sim 1$. $2\alpha_1'$, $\alpha_n = 0$. $8\alpha_n' \sim 1$. 2 α .'、 β .=0.8 β .'~1.2 β .'とする請求項1 0に記載の光記録方法。

【請求項12】 マーク長nT=2T又は3Tのマーク の記録に際して、m=1個の区間に分割する請求項8乃 至11のいずれか1つに記載の光記録方法。

【請求項13】 Lが3以上の場合に、 $2 \le i \le m-1$ なる i に対して、 $\alpha_i = \alpha$ c で一定とし、かつ、 α_i = α.'で一定とする請求項8乃至11のいずれか1つに 記載の光記録方法。

【請求項14】 Lが3以上の場合に、αc及びαc' がLによらず一定である請求項13に記載の光記録方

【請求項15】 Lが3以上の場合に、 $\alpha c = \alpha c$ 'と する請求項13又は14に記載の光記録方法。

【請求項16】 Lが3以上の場合に、Tal, Tal, α_1 、 α_1 '、 β_1 、及び β_1 'がそれぞれ一定の値をとる 請求項8乃至15のいずれか1つに記載の光記録方法。

【請求項17】 Lが3以上の場合に、 α 、 α 。、 β **ω、及びβω** がそれぞれ一定の値をとる請求項8乃至は *【請求項10】 マーク長がnT=2LT (ただし、L は2以上の整数)で表される場合、マークを分割数m= L個の区間に分割し、記録パルス区間α: T及びオフパ ルス区間 β : Tにおける α : 及び β : (これらはしの値に 応じて変化し得る)を下記のように定め、

【数6】 $T_{ai} + \alpha_i = 2 + \epsilon_i$

 $\beta_{i-1} + \alpha_i = 2 \qquad (2 \le i \le m)$

一方、マーク長がnT = (2L+1) Tで表される場 合、マークを分割数m=L個に分割し、記録パルス区間 α ', T及びオフパルス区間 β ', Tにおける α ', 及び β '。(これらはLの値に応じて変化し得る)を下記の ように定め、

【数7】 T_{a1} ' $+\alpha_1$ ' $=2+\epsilon_1$ ' $\beta_1' + \alpha_2' = 2. 5 + \epsilon_2'$ β_{i-t} ' $+\alpha_{i}$ ' = 2 ($3 \le i \le m-1$) $\beta = 1$ ' $+\alpha = 2$. $5 + \epsilon = 3$ '

(ただし、L=2の場合には、 β_1 '+ α_2 '=2.5+ ϵ_2 ', ϵ_2 ', ϵ_2 ' ϵ_3 ', ϵ_2 ' ϵ_3 ', ϵ_2 ', ϵ_3 ', ϵ_4 ', ϵ_2 ', ϵ_3 ', ϵ_4 ', ϵ_2 ', ϵ_3 ', ϵ_4 ', ϵ_4 ', ϵ_4 ', ϵ_4 ', ϵ_4 ', ϵ_4 ', ϵ_5 ', ϵ_5 ', ϵ_5 ', ϵ_6 ', ϵ_6 ', ϵ_8 ', た、Tar、Tar'は-2以上2以下なるLによらないほ ぼ一定の実数値とする。さらに、 ε1、 ε1'、 ε2'、 ε3'は-1以上1以下の実数とする。)

 $\beta > 0$, β_1 , α_2 , β_{m-1} , α_m , β_1' , α_2' , β 、 、 及び α 、 が下式を満足することを特徴とする 請求項7に記載の光記録方法。

15のいずれか一つに記載の光記録方法。

【数8】

【請求項18】 周期Tの第1の基準クロック1と周期 Tで第1の基準クロックに対して0.5 Tだけずれた周 期丁の第2の基準クロック2とを用いて、基準クロック 1を分周して得られる周期2Tの基準クロック3に同期 させて、 α : $(1 \le i \le m)$ を発生させ、基準クロック 2を分周して得られる周期2Tの基準クロック4に同期 させて、 α_i ' (2 \leq i \leq m - 1) を発生させる請求項 8乃至17のいずれか1つに記載の光記録方法。

【請求項19】 すべてのLに対して、記録パルス a.T 及びα1、Tの立ち上がりに、記録すべきマーク長の前端 に対する遅延時間Talを設け、

記録トラック上に所定の位置に形成されたクロックマー クに対応した基準時間 Tone を発生させ、

基準時間Tsync を起点として、各マーク長及びマーク間 に対応した変調信号を発生させ、

基準時間T_{smc} を起点として遅延時間T_a をもって発生 された、周期2Tの基準クロック1aと、該基準クロッ ク1aに対して0.5T先行した周期2Tの基準クロッ ク2aと、該基準クロック1aに対して1T先行した周 期2Tの基準クロック1bと該基準クロック1aに対し て1.5 T先行した周期2 Tの基準クロック2 b との4 種の基準クロックを発生し、

n が奇数である場合には、n Tマークの前端を基準として遅延時間 T_a の経過後、 Σ (α_i ' + β_i ') T なるゲートG 4 を発生させ、

基準時間T_{smc} を起点としてnTマークの前端までの経過時間を、基準クロックTの個数として計数し、

該経過時間が基準クロックTの偶数倍であれば、nが偶数であるか奇数であるかに応じてゲート信号群Gla又はGlbを選択し、

該経過時間が基準クロックTの奇数倍であれば、nが偶数であるか奇数であるかに応じてゲート信号群G1b又はG2aを選択し、

G3及びG4のいずれもがオフである場合、消去パワー Peの記録光を照射し、

G3及びG4のいずれかがオンである場合、バイアスパワーPbの記録光を照射し、

G3とG1aとが同時にオンである場合、G1aオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、

G3とG1bとが同時にオンである場合、G1bオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、

G4とG2aとが同時にオンである場合、G2aオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、且つG4とG2bとが同時にオンである場合、G2bオン区間に対応して記録パワーPwの記録光が照射される請求項8に記載の光記録方法。

【請求項20】 すべてのLに対して、記録パルス α_1 T 及び α_1 , Tの立ち上がりに、記録すべきマーク長の前端に対する遅延時間 α_1 T 以は α_2 を設け、

記録トラック上に所定の位置に形成されたクロックマークに対応した基準時間 T_{snc} を発生させ、

基準時間T_{sme} を起点として、各マーク長及びマーク間に対応した変調信号を発生させ、

基準時間 T_{sree} を起点として発生された、周期2 Tの基準クロック1 a と該基準クロック1 a に対して0.5 T 先行した周期2 Tの基準クロック2 a と、該基準クロック1 a に対して1 T 先行した周期2 T の基準クロック1 b と該基準クロック1 a に対して1.5 T 先行した周期2 T の基準クロック2 b との4種の基準クロックを発生し

nT=2LTなるマークの記録に際して、基準クロック

基準時間T_{smc} を起点としてnTマークの前端までの経 過時間を、基準クロックTの個数として計数し、

該経過時間が基準クロックTの偶数倍であれば、nが偶数であるか奇数であるかに応じてゲート信号群G1a又はG2bを選択し、

該経過時間が基準クロックTの奇数倍であれば、nが偶数であるか奇数であるかに応じてゲート信号群G1b又はG2aを選択し、

G3及びG4のいずれもがオフである場合、消去パワー Peの記録光を照射し、

G3及びG4のいずれかがオンである場合、バイアスパワーPbの記録光を照射し、

G3とG1aが同時にオンである場合、G1aオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、

G3とG1bが同時にオンである場合、G1bオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、

G4とG2aが同時にオンである場合、G2aオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、

G4とG2bが同時にオンである場合、G2bオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射する請求項10に記載の光記録方法。

【請求項21】 同一の記録媒体に対して、v×Tが一定の複数の線速度vでマーク長変調方式による記録を行うに際し、

2以上のLにおいて、 $2 \le i \le m-1$ における($\alpha_i + \beta_i$) T、及び(α_i '+ β_i ') Tの周期を線速によらず一定に保ち、さらに各iにおける Pw_i , Pb_i 、及びPeも線速度によらずほぼ一定に保ち、且つ低線速度ほど α_i 及び α_i '($2 \le i \le m$)を減少させる請求項8に記載の光記録方法。

【請求項22】 同一の記録媒体に対して、v×Tが一定の複数の線速度vでマーク長変調方式による記録を行うに際し、

2以上のLにおいて、 $2 \le i \le m$ における(β_{i-1} + α_i) T、及び(β_{i-1} ' + α_i ') Tの周期を線速によらず一定に保ち、さらに各 i におけるP w_i , P b_i 、及びP e も線速度によらずほぼ一定に保ち、且つ低線速度

ほど α ,及び α ,' (2 \leq i \leq m)を減少させる請求項10に記載の光記録方法。

【請求項23】 α_i T、及び α_i ' T($2 \le i \le m-1$)を線速度によらずほぼ一定とする請求項21 又は2 2に記載の光記録方法。

【請求項24】 マーク間の時間において、 $Pb_i \le Pe \le Pw_i$ ($1 \le i \le m$) なる消去パワーPeを照射する請求項1乃至は23のいずれか一つに記載の光記録方法。

【請求項25】 記録媒体が、結晶状態を未記録・消去 状態とし、非晶質状態を記録マークとする相変化型の光 記録媒体である請求項1乃至24のいずれか一つに記載 の光記録方法。

【請求項26】 全ての記録マークの時間的長さについて、 $4 \ge n/m \ge 1$. 5、 Σ_i (α_i) < 0. 6 n、かつ、P b_i/P $e \le 0$. 2 を満たす請求項1乃至25のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項27】 記録時の線速度が10m/s以上であって、最短マーク長が0.8μm未満である請求項1乃 至26のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項28】 記録光の波長が500nm未満であり、記録光を集束させるためのレンズの開口数が0.6以上であり、かつ、最短マーク長が0.3 μm未満である請求項1乃至27のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項29】 マーク長変調方式が、8-16変調方式もしくは(1,7)-RLL-NRZI変調方式である請求項1乃至28のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項30】 マーク長変調方式がEFM変調方式であり、記録時の線速度をCDの基準線速度1.2m/s~1.4m/sの10倍速以上として、記録線密度を一定としながら記録を行う請求項1乃至29のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項31】 マーク長変調方式がEFM変調方式であり、記録時の線速度をDVDの基準線速度3.49m/sの2倍速以上として、記録線密度を一定としながら記録を行う請求項1乃至30のいずれかに記載の光記録

方法。

【請求項32】 請求項1乃至31のいずれかに記載の 光記録方法により記録を行うための相変化型光記録媒体 であって、M. Ge, (Sb. Tein) in a 合金 (た だし、0 \leq z \leq 0 . 1 \lesssim 0 < y \leq 0 . 3 \lesssim 0 . 8 \leq x \lesssim Mは、In、Ga、Si、Sn、Pb、Pd、Pt、Zn、Au、Ag、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Co、Mo、Mn、Bi、O、N、Sから選ばれる少な くとも一種)からなる記録層を有することを特徴とする 光記録媒体。

【請求項33】 $\alpha_i + \beta_i$ (2 \leq i \leq m - 1) あるいは、 $\beta_{i-1} + \alpha_i$ (2 \leq i \leq m - 1) が、iによらず一定である請求項6に記載の光記録方法。

【請求項34】 $\alpha_i + \beta_i$ (2 \leq i \leq m - 1) あるいは、 $\beta_{i-1} + \alpha_i$ (2 \leq i \leq m - 1) が、iによらず2であり、かつ、2 \leq i \leq m - 1 の全てのiに対して、 α_i = α c (一定値) である請求項33に記載の光記録方法。

【請求項35】 分割数mが3以上である全ての時間的 長さの記録マークにおいて、 α_i (2 \leq i \leq m-1) が 一定である請求項33又は34に記載の</u>光記録方法。

【請求項36】 前記nの異なる少なくとも2つの記録マークが、隣合う時間的長さをもつ記録マークである請求項7に記載の光記録方法。

【請求項37】 前記nの異なる少なくとも2つの記録 マークにおいて、 $(\alpha_1 + \beta_1)$ T及び $(\alpha_2 + \beta_2)$ Tの 少なくとも一つが相互に異なる請求項36に記載の光記 録方法。

【請求項38】 前記nの異なる少なくとも2つの記録マークにおいて、($\beta_1 + \alpha_2$) T及び($\beta_{-1} + \alpha_{-1}$) Tの少なくとも一つが相互に異なる請求項36に記載の光記録方法。

【請求項39】 $\alpha_i + \beta_i$ (2 \leq i \leq m-1) あるいは、 $\beta_{i-1} + \alpha_i$ (2 \leq i \leq m-1) が、iによらず2である請求項7に記載の光記録方法。

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第4区分

【発行日】平成14年11月15日(2002.11.15)

【公開番号】特開2001-331936 (P2001-331936A)

【公開日】平成13年11月30日(2001.11.30)

【年通号数】公開特許公報13-3320

【出願番号】特願2000-139953 (P2000-139953)

【国際特許分類第7版】

G11B 7/0045

B41M 5/26

G11B 7/24 511

[FI]

G11B 7/0045 A

7/24 511

B41M 5/26 X

【手続補正書】

【提出日】平成14年8月20日(2002.8.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 記録媒体に光を照射することによってマーク長変調された情報を複数の記録マーク長により記録するにあたり、一つの記録マークの時間的な長さをn T としたとき(T は基準クロック周期であって25n S 以下である。n は2 以上の自然数である。)、

記録マークの時間的長さnTを、

【数1】

 η : T、 α : T、 β : T、 α : T、 β : T、···、 α : T、 β : T、···、 α : T、 β : T、 η : T (mはパルス分割数である。 Σ : $(\alpha_i + \beta_i) + \eta_1 + \eta_2 = n$ である。 α : $(1 \le i \le m)$ は 0 より大きい 実数であり、 β : $(1 \le i \le m-1)$ は 0 より大きい実数であり、 β : は 0 以上の実数である。 η : D び η : は それぞれ -2 以上 2 以下の実数である。)

 α : T ($1 \le i \le m$) の時間内においては記録パワーP w: の記録光を照射し、

 β ; T ($1 \le i \le m-1$) の時間内においては、P b; < P w; かつP b; < P w; の記録光を照射し、

少なくとも一つの記録マークの時間的長さについては上記パルス分割数mを2以上とし、かつ、全ての記録マークの時間的長さについてn/m≥1.25を満たすことを特徴とする光記録方法。

【請求項2】 β : $(1 \le i \le m-1)$ は0. $5 \sim 2$. 5 である請求項1 に記載の光記録方法。

【請求項3】 全ての記録マークの時間的長さについて、 α : T ($1 \le i \le m$) の平均値が3ナノ秒以上で、かつ β : T ($1 \le i \le m-1$) の平均値が3ナノ秒以上である請求項1または2に記載の光記録方法。

【請求項4】 全ての記録マークの時間的長さについて、それぞれのiに対して α , $T \ge 3$ ナノ秒($1 \le i \le m$)で、かつ β , $T \ge 3$ ナノ秒($1 \le i \le m-1$)である請求項1 乃至3 のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項5】 全ての記録マークの時間的長さについて、 $n/m \ge 1$. 5を満たす請求項1乃至4のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項 6 】 $\alpha_i + \beta_i$ (2 \leq i \leq m - 1) あるいは、 $\beta_{i-1} + \alpha_i$ (2 \leq i \leq m - 1) が、1.5、2、あるいは2.5のいずれかの値をとる請求項1乃至5のいずれか1つに記載の光記録方法。

【請求項7】 nの異なる少なくとも2つの記録マークにおいて、同一のパルス分割数mを用い、前記少なくとも2つの記録マークにおいて、 α_i ($1 \le i \le m$)、 β_i ($1 \le i \le m$)、 η_i 、 η_z 、 Pw_i ($1 \le i \le m$) 及び Pw_i ($1 \le i \le m$) の少なくとも1つが相互に異なる請求項1乃至6のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項8】 マーク長がnT=2LT(ただし、Lは 2以上の整数)で表される場合、マークを分割数m=L 個の区間に分割し、記録パルス区間 α_i T及びオフパルス区間 β_i Tにおける α_i 及び β_i (これらはLの値に応じて変化し得る)を下記のように定め、

【数2】 $\alpha_1 + \beta_1 = 2 + \delta_1$

 $\alpha_i + \beta_i = 2 \qquad (2 \le i \le m - 1)$

 $\alpha_* + \beta_* = 2 + \delta_2$

(ただし、 δ , 及び δ 2は、それぞれ順に、-0. $5 \leq \delta$

 $1 \le 0$. 5、及び $-1 \le \delta_2 \le 1$ を満足する実数である。 また、L=2の場合には、 α_1 、 β_1 、 α_n 及び β_n のみが 存在するものとする。)

マーク長 \dot{m} T = (2L+1) Tで表される場合、マー クを分割数m=L個の区間に分割し、記録パルス区間α $_{i}$ T及びオフパルス区間 β_{i} Tにおける α_{i} 及び β_i '(これらはLの値に応じて変化し得る)を下記の ように定め、

【数3】 $\alpha_1' + \beta_1' = 2.5 + \delta_1'$ $\alpha_{i}' + \beta_{i}' = 2 \quad (2 \le i \le m-1)$ α , $+\beta$, =2. $5+\delta_2$,

(ただし、 δ_1) 及び δ_2) は、それぞれ順に、-0.5 $\leq \delta_1$ ' ≤ 0 . 5、及び $-1 \leq \delta_2$ ' ≤ 1 を満足する実数 である。また、L=2の場合には、 α_1 '、 β_1 '、 α , 及び β , のみが存在するものとする。) 且つ、 α_1 、 β_1 、 α_n 、 β_n 、 α_1 '、 β_1 '、 α_n '、及 びβ. 'が下記式を満足することを特徴とする請求項7 に記載の光記録方法。

【数4】

 $\alpha_1 + \beta_1 + \alpha_2 + \beta_2 + \Delta = \alpha_1' + \beta_1' + \alpha_2' + \beta_2'$

【請求項9】 α_1 、 β_1 、 α_1 及び β_1 が下記式を満 足する請求項8に記載の光記録方法。

【数5】 $\alpha_1 + \beta_1 + \Delta_1 = \alpha_1' + \beta_1'$

 $(\hbar k l) \Delta_1 = 0.4 \sim 0.6$

 $\beta_1 + \alpha_2 + \beta_{-1} + \alpha_1 + \Delta_2 = \beta_1' + \alpha_2' + \beta_{-1}' + \alpha_n'$

 $(220, \Delta_2 = 0.8 \sim 1.20$

【請求項11】 3以上のLに対して、 $\beta_1'=\beta_1+$ 約 $0.5 \cdot \beta_{-1} = \beta_{-1} + 約0.5 \cdot \tau$ あり、 $\alpha_1 =$ 0. $8 \alpha_1' \sim 1$. $2 \alpha_1'$, $\alpha_n = 0$. $8 \alpha_n' \sim 1$. 2 α 、 β = 0. 8 β 、 \sim 1. 2 β 、 とする請求項1 0に記載の光記録方法。

【請求項12】 マーク長 n T = 2 T 又は 3 T のマーク の記録に際して、m=1個の区間に分割する請求項8乃 至11のいずれか1つに記載の光記録方法。

【請求項13】 Lが3以上の場合に、2≤i≤m-1 なる i に対して、 $\alpha_i = \alpha$ c で一定とし、かつ、 α_i ' = α、'で一定とする請求項8乃至11のいずれか1つに 記載の光記録方法。

【請求項14】 Lが3以上の場合に、αc及びαc' がしによらず一定である請求項13に記載の光記録方

【請求項15】 Lが3以上の場合に、 $\alpha c = \alpha c$ ' と する請求項13又は14に記載の光記録方法。

【請求項16】 Lが3以上の場合に、Ta, Ta', α_1 、 α_1 '、 β_1 、及び β_1 'がそれぞれ一定の値をとる 請求項8乃至15のいずれか1つに記載の光記録方法。

■、及びβ、'がそれぞれ一定の値をとる請求項8乃至は 15のいずれか一つに記載の光記録方法。

*【請求項10】 マーク長がnT=2LT (ただし、L は2以上の整数)で表される場合、マークを分割数m= L個の区間に分割し、記録パルス区間αιT及びオフパ ルス区間 B_i Tにおける α_i 及び β_i (これらは Lの値に 応じて変化し得る)を下記のように定め、

【数6】 $T_{ai} + \alpha_i = 2 + \epsilon_i$

 $\beta_{i-1} + \alpha_i = 2 \qquad (2 \le i \le m)$

一方、マーク長がnT= (2L+1) Tで表される場 合、マークを分割数m=L個に分割し、記録パルス区間 α' , T及びオフパルス区間 β' , Tにおける α' , 及び β'; (これらはLの値に応じて変化し得る)を下記の ように定め、

【数7】 $T_{d1}' + \alpha_1' = 2 + \epsilon_1'$ $\beta_1' + \alpha_2' = 2. 5 + \epsilon_2'$ β_{i-1} ' $+\alpha_i$ ' = 2 (3 \leq i \leq m-1) $\beta_{\bullet\bullet}$, $+\alpha_{\bullet}$, $=2.5+\epsilon_3$,

(ただし、L=2の場合には、 β_1 '+ α_2 '=2.5+ ϵ_2 ', ϵ_2 ', ϵ_3 ', ϵ_4 ', ϵ_4 ', ϵ_5 ', ϵ_6 ', ϵ_7 ', ϵ_8 た、Tai、Tai,は-2以上2以下なるLによらないほ ぽ一定の実数値とする。さらに、 ε1、 ε1'、 ε2'、 ε3'は-1以上1以下の実数とする。)

かつ、 β_1 、 α_2 、 β_{-1} 、 α_{-1} 、 β_1 , α_2 , β 、 '、及びα 'が下式を満足することを特徴とする 請求項7に記載の光記録方法。

【数8】

【請求項18】 周期Tの第1の基準クロック1と周期 Tで第1の基準クロックに対して0.5 Tだけずれた周 期Tの第2の基準クロック2とを用いて、基準クロック 1を分周して得られる周期2Tの基準クロック3に同期 させて、α: (1≦i≦m)を発生させ、基準クロック 2を分周して得られる周期2丁の基準クロック4に同期 させて、 α_i ' (2 \leq i \leq m - 1) を発生させる請求項 8乃至17のいずれか1つに記載の光記録方法。

【請求項19】 すべてのLに対して、記録パルスaiT 及びα」、Tの立ち上がりに、記録すべきマーク長の前端 に対する遅延時間Talを設け、

記録トラック上に所定の位置に形成されたクロックマー クに対応した基準時間Tspec を発生させ、

基準時間Tsmc を起点として、各マーク長及びマーク間 に対応した変調信号を発生させ、

基準時間Tṣṇc を起点として遅延時間Ta をもって発生 された、周期2Tの基準クロック1aと、該基準クロッ ク1aに対して0.5T先行した周期2Tの基準クロッ ク 2 a と、該基準クロック 1 a に対して 1 T 先行した周 期2Tの基準クロック1bと該基準クロック1aに対し て1. 5 T 先行した周期 2 T の基準クロック 2 b との 4 種の基準クロックを発生し、

nT=2LTなるマークの記録に際して、基準クロック 1a及び1bのいずれかに同期させて、 α , T、 α , T

($2 \le i \le m-1$)、 α . Tの発生区間に対応したタイミングのゲートの一群G1a及びG1bを発生させ、nT=(2L+1) Tなるマークの記録に際して、基準クロック2a及び2bのいずれかに同期させて α . α . Tに対応したタイミングのゲートの一群G2a及びG2bを発生させ、 α が偶数である場合には、 α Tマークの前端を基準として遅延時間 α の経過後、 α (α) TなるゲートG3を発生させ、

n が奇数である場合には、n T マークの前端を基準として遅延時間 T_{ai} の経過後、 Σ (α_{i} ' + β_{i} ') T なるゲート G 4 を発生させ、

基準時間 T_{sym} を起点としてn Tマークの前端までの経過時間を、基準クロックTの個数として計数し、

該経過時間が基準クロックTの偶数倍であれば、nが偶数であるか奇数であるかに応じてゲート信号群G1a又はG2bを選択し、

該経過時間が基準クロックTの奇数倍であれば、nが偶数であるか奇数であるかに応じてゲート信号群G1b又はG2aを選択し、

G3及びG4のいずれもがオフである場合、消去パワー Peの記録光を照射し、

G3及びG4のいずれかがオンである場合、バイアスパワーPbの記録光を照射し、

G3とG1aとが同時にオンである場合、G1aオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、

G3とG1bとが同時にオンである場合、G1bオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、

G4とG2aとが同時にオンである場合、G2aオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、且つG4とG2bとが同時にオンである場合、G2bオン区間に対応して記録パワーPwの記録光が照射される請求項8に記載の光記録方法。

【請求項20】 すべてのLに対して、記録パルス α_1 及び α_1 ' Tの立ち上がりに、記録すべきマーク長の前端に対する遅延時間 T_a 又は T_a 'を設け、

記録トラック上に所定の位置に形成されたクロックマークに対応した基準時間 T_{smc} を発生させ、

基準時間T_{smc} を起点として、各マーク長及びマーク間 に対応した変調信号を発生させ、

基準時間 T_{smc} を起点として発生された、周期2 Tの基準クロック1 a と該基準クロック1 a に対して0.5 T 先行した周期2 Tの基準クロック2 a と、該基準クロック1 a に対して1 T 先行した周期2 T の基準クロック1 b と該基準クロック1 a に対して1.5 T 先行した周期2 T の基準クロック2 b との4種の基準

クロックを発生し、nT=2LTなるマークの記録に際して、基準クロック 1 a 及び 1 b のいずれかに同期させて、 α_i T、 α_i T ($2 \le i \le m-1$)、 α_i T の発生区間に対応したタイミングのゲートの一群G 1 a 及びG 1

bを発生させ、

基準時間T_{sync} を起点としてnTマークの前端までの経過時間を、基準クロックTの個数として計数し、

該経過時間が基準クロックTの偶数倍であれば、nが偶数であるか奇数であるかに応じてゲート信号群G1a又はG2bを選択し、

該経過時間が基準クロックTの奇数倍であれば、nが偶数であるか奇数であるかに応じてゲート信号群G1b又はG2aを選択し、

G3及びG4のいずれもがオフである場合、消去パワー Peの記録光を照射し、

G3及びG4のいずれかがオンである場合、バイアスパワーPbの記録光を照射し、

G3とG1aが同時にオンである場合、G1aオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、

G3とG1bが同時にオンである場合、G1bオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、

G4とG2aが同時にオンである場合、G2aオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射し、

G4とG2bが同時にオンである場合、G2bオン区間に対応して記録パワーPwの記録光を照射する請求項10に記載の光記録方法。

【請求項21】 同一の記録媒体に対して、v×Tが一定の複数の線速度vでマーク長変調方式による記録を行うに際し、

2以上のLにおいて、 $2 \le i \le m-1$ における(α_i + β_i) T、及び(α_i ' + β_i ') Tの周期を線速によらず一定に保ち、さらに各 i におけるP w_i , P b_i 、及び P e も線速度によらずほぼ一定に保ち、且つ低線速度ほど α_i 及び α_i '($2 \le i \le m$)を減少させる請求項 8 に記載の光記録方法。

【請求項22】 同一の記録媒体に対して、v×Tが一定の複数の線速度vでマーク長変調方式による記録を行うに際し、

2以上のLにおいて、 $2 \le i \le m$ における(β_{i-1} + α_i) T、及び(β_{i-1} ' + α_i ') Tの周期を線速によらず一定に保ち、さらに各 i におけるPw $_i$,Pb $_i$ 、及びPe も線速度によらずほぼ一定に保ち、且つ低線速度ほど α_i 及び α_i '($2 \le i \le m$)を減少させる請求項 10 に記載の光記録方法。

【請求項23】 α_i T、及び α_i ' T ($2 \le i \le m-1$) を線速度によらずほぼ一定とする請求項21 又は22に記載の光記録方法。

【請求項24】 マーク間の時間において、 $Pb_i \le Pe \le Pw_i$ ($1 \le i \le m$)なる消去パワーPeを照射する請求項1乃至は23のいずれか一つに記載の光記録方法。

【請求項25】 記録媒体が、結晶状態を未記録・消去 状態とし、非晶質状態を記録マークとする相変化型の光 記録媒体である請求項1乃至24のいずれか一つに記載 の光記録方法。

【請求項26】 全ての記録マークの時間的長さについて、 $4 \ge n/m \ge 1$. 5、 Σ_i (α_i) < 0. 6 n、かつ、P b_i /P e \le 0. 2 を満たす請求項1乃至25のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項27】 記録時の線速度が10m/s以上であって、最短マーク長が0.8μm未満である請求項1乃至26のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項28】 記録光の波長が500nm未満であり、記録光を集束させるためのレンズの開口数が0.6以上であり、かつ、最短マーク長が0.3μm未満である請求項1乃至27のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項29】 マーク長変調方式が、8-16変調方式もしくは(1,7)-RLL-NRZI変調方式である請求項1乃至28のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項30】 マーク長変調方式がEFM変調方式であり、記録時の線速度をCDの基準線速度1.2m/s~1.4m/sの10倍速以上として、記録線密度を一定としながら記録を行う請求項1乃至29のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項31】 マーク長変調方式がEFM変調方式であり、記録時の線速度をDVDの基準線速度3.49m/sの2倍速以上として、記録線密度を一定としながら記録を行う請求項1乃至30のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項32】 請求項1乃至31のいずれかに記載の 光記録方法により記録を行うための相変化型光記録媒体 であって、M. Ge, (Sb. Tein) $_{i,j}$ 合金(た だし、 $0 \le z \le 0$. 1、 $0 < y \le 0$. 3、0. $8 \le x$ 。 Mは、In、Ga、Si、Sn、Pb、Pd、Pt、Zn、Au、Ag、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Co、Mo、Mn、Bi、O、N、Sから選ばれる少な くとも一種)からなる記録層を有することを特徴とする 光記録媒体。

【請求項33】 $\alpha_i + \beta_i$ ($2 \le i \le m-1$) あるいは、 $\beta_{i-1} + \alpha_i$ ($2 \le i \le m-1$) が、i によらず一定である請求項6 に記載の光記録方法。

【請求項34】 $\alpha_i + \beta_i$ ($2 \le i \le m-1$) あるいは、 $\beta_{i-1} + \alpha_i$ ($2 \le i \le m-1$) が、iによらず2であり、かつ、

 $2 \le i \le m-1$ の全ての i に対して、 $\alpha_i = \alpha$ c (一定値) である請求項 3 に記載の光記録方法。

【請求項35】 分割数mが3以上である全ての時間的 長さの記録マークにおいて、 α 、(2 \leq i \leq m-1)が 一定である請求項33又は34に記載の光記録方法。

【請求項36】 前記nの異なる少なくとも2つの記録マークが、隣合う時間的長さをもつ記録マークである請求項7に記載の光記録方法。

【請求項37】 前記nの異なる少なくとも2つの記録マークにおいて、 $(\alpha_1 + \beta_1)$ T及び $(\alpha_2 + \beta_3)$ Tの少なくとも一つが相互に異なる請求項36に記載の光記録方法。

【請求項38】 前記nの異なる少なくとも2つの記録マークにおいて、 $(\beta_1 + \alpha_2)$ T及び $(\beta_{-1} + \alpha_{-})$ Tの少なくとも一つが相互に異なる請求項36に記載の光記録方法。

【請求項39】 $\alpha_i + \beta_i$ (2 \le i \le m-1) あるいは、 $\beta_{i-1} + \alpha_i$ (2 \le i \le m-1) が、iによらず2である請求項7に記載の光記録方法。

【請求項40】 $\alpha_i + \beta_i$ ($2 \le i \le m-1$) あるいは、 $\beta_{i-1} + \alpha_i$ ($2 \le i \le m-1$) が、i によらず一定である請求項1に記載の光記録方法。

【請求項41】 $\alpha_i + \beta_i$ (2 \leq i \leq m-1) あるいは、 $\beta_{i-1} + \alpha_i$ (2 \leq i \leq m-1) が、iによらず2である請求項40に記載の光記録方法。

【請求項42】 $2 \le i \le m-1$ の全ての i に対して、 $\alpha_i = \alpha$ c (一定値) である請求項40又は41に記載の光記録方法。

【請求項43】 分割数mが3以上である全ての時間的長さの記録マークにおいて、 α ; ($2 \le i \le m-1$)が一定である請求項40乃至42のいずれかに記載の光記録方法。

【請求項44】 同一の記録媒体に対して、v×Tが一定の複数の線速度vでマーク長変調方式による記録を行うに際し、

2以上のmにおいて、 $2 \le i \le m-1$ における $\alpha_i + \beta_i$ を線速によらず一定に保ち、さらに各 i におけるP w_i , P b_i 、及v P e t も線速度によらずほぼ一定に保ち、且つ低線速度ほど α_i ($2 \le i \le m$)を減少させる請求項1に記載の光記録方法。

【請求項45】 同一の記録媒体に対して、v×Tが一 定の複数の線速度vでマーク長変調方式による記録を行 うに際し、

2以上のmにおいて、 $2 \le i \le m$ における $B_{i:1} + \alpha_i \epsilon$ 線速によらず一定に保ち、さらに各iにおける Pw_i 、 Pb_i 、及びPeも線速度によらずほぼ一定に保ち、且つ低線速度ほど α_i ($2 \le i \le m$)を減少させる請求項1に記載の光記録方法。

【請求項46】 $\alpha_i T$ (2 $\leq i \leq m-1$) を線速度に よらずほぼ一定とする請求項44又は45に記載の光記

録方法。

【請求項47】 該記録媒体は、M. Ge, (Sb. Ten) から金 (ただし、0≤z≤0.1、0 < y≤0.3、0.8≤x。Mは、In、Ga、Si、Sn、Pb、Pd、Pt、Zn、Au、Ag、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Co、Mo、Mn、Bi、O、N、Sから選ばれる少なくとも一種)からなる記録層を有する記録媒体である、請求項1に記載の光記録方法。【請求項48】 Sbn Ten 共晶点近傍よりも過剰のSbを含有し、光ビームの照射により、互いに光学的性質の異なる結晶状態と非晶質状態との間で可逆的に相変化する記録層を有してなる光学的情報記録用媒体であって、

<u>該結晶状態が、六方晶の実質的に単一相からなる多結晶であることを特徴とする光学的情報記録用媒体。</u>

【請求項49】 該記録層が、M.Ger (Sb.T e₁₋₁) ₁₋₇ (ただし、0≤z≤0.1、0<y≤0. 3、0.8≤x。Mは、In、Ga、Si、Sn、P b、Pd、Pt、Zn、Au、Ag、Zr、Hf、V、 Nb、Ta、Cr、Co、Mo、Mn、Bi、O、N、 <u>Sから選ばれる少なくとも一種)からなる記録層を有する請求項48に記載の光学的情報記録用媒体。</u>

【請求項50】 請求項48又は49のいずれかに記載の光学的情報記録用媒体に、該記録層の結晶状態を未記録状態及び消去状態とし、非晶質状態を記録状態として記録及び/又は消去を行うことを特徴とする記録消去方法。

【請求項51】 Sbn Ten 共晶点近傍よりも過剰の Sbを含有し、光ビームの照射により、互いに光学的性 質の異なる結晶状態と非晶質状態との間で可逆的に相変 化する記録層を有してなる光学的情報記録用媒体の製造 方法であって、

基板上に少なくとも該記録層を形成した後、該記録層に、短軸の長さが 0. 1 μ m ~ 1 0 μ m である楕円状光ビームを短軸方向に走査しながら照射して結晶化し初期化するにあたり、

該光ビームを、該記録層のオーバーライト可能な最高線 速度の50%~80%のいずれかの速度で走査すること を特徴とする光学的情報記録用媒体の製造方法。